

制御爆破に関する基礎的研究

1973. 1.

勝山邦久



制御爆破に関する基礎的研究

1973. 1.

勝 山 邦 久

第1章 籍 論	1
1.1 卷 言 —————	1
1.2 本研究に関連した従来の研究	2
1.3 本研究の目的と内容	6
第2章 応力波の伝統にともなりき裂の生成機構 ———	10
2.1 考 言	1 û
2.2 無限裝置と考えられる材料内に生ずる応力技形	10
2.8 応力物の伝播にともなりを裏の生成機構に関する一考察	14
2.4 走査型電子顕微鏡をよび光学期は遺によるき裂面の実際	16
2.4.1 静的府力代報と考えられる場合に生成するき姿面の	
大学顕微鏡による観察	16
2.4.2 応力波の伝承にときなって生成したき製団の領域境	
による観察	18
2.5 故芍ੇੇ 被获 0 作図	- 52
2.6 故治線代程禄の形式	26
2.7 羟妄填口場合Oσr,σθ O時間的変化状態	2 8
2.8 核口分布密度	
29 結 言	
	9.1
第3章 一自由面爆破におけるき裂およびクレータの生成機構	9.9
3.1 着 言	

3.2 動的応力の解析方法 3.4
3.2.1 解析方法の概略 3.4
3.2.2 破壊を計算に導入する方法 3.6
3.23 プログラムのフローチャート 38
3.3 破壊を考慮しない場合の応力状態 4.1
3.3.1 数値解析に用いた条件 4.1
3.3.2 応力解析結果 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
3.4 き裂の成長過程のシミュレーション
3.5 破断面上に現われるリップルマークについて
3.6 結 言
第4章 空孔の存在による動的応力のじょう乱に関する数値解析 —— 59
4.1 緒言59
4.2 円柱状空孔の存在する媒質内を応力波が伝播する場合に
発生する応力状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.2.1 数値解析に用いた条件 60
4.2.2 波長 A と空孔の直径 d の比 A / d が 2 の場合の解析
結果 61
4.2.3 波長 λ と空孔の直径 d の比 λ / d の値が応力状態に
およぼす影響 65
4.2.4 理論解との対比72
4.3 断面が正方形の角柱状空孔の存在する媒質内を応力波が
伝播する場合に発生する応力状態73
4.3.1 数値解析に用いた条件 73

4. 3. 2		7 4
4.4 疎7	水トンネルの周囲における爆破振動 ――	7 7
4. 4. 1	爆 破振動の測定の方法	7 7
4. 4. 2	振動測定結果と数値解析結果との対比	8 0
4.5 結	言 in the second of the second of the second	8 3
弟5章 ス・	ムース・プラスティングの場合の破壊機構と最適	
爆る	破条件の検討	8.5
5 1 緒	=	3 5
5. 2 英切	信解析に用いた条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 5
5. 3 一才	孔のみが爆轟した場合の応力状態とき裂のシミュ	
レ-	- ション **** **** **** * * * * * * * * * * *	8 9
5. 3. 1	破壊を考慮しない場合	- 8 9
5. 3. 2	破壊を考慮する場合	9 4
	, n+2 ,・ ・ ・の爆薬が完全に斉発した場	
	カシミュレーション	99
	べての爆薬が完全に斉発した場合のシミュレー	
	接薬の効果について	
5.7 結		106
htt a +		
	ムース・プラスティングにおけるガイドホール	
	効果	108
6.1 緒		108

	6.	2		き裂	とから	の応	力解力	汝波					* * * ****			222 200		1	10
		6.	2.	1	单軸	引張	試験	で材料	力が	破断	した	際に	発生	する					
					応力	解放	波に:	ついて	3	*****			2007 - 51	en 1110 W	g. 11454 4 0		, y	1	10
		6.	2.	2	hoo	рa.	tres	s の解	7放	波に	つい	て		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,		0	1	1 4
	6.	3		ガイ	ドホ	- ル	による	5 き 裂	fΦ	抑制剂	効果	1000	nii kan-			me o		1	18
		6.	3.	1	ガイ	ドホ	- ルュ	丘傍の	応	力計算	算の	一方	法	148 a 19	ent i sus	1		1	18
		6.	3.	2	応力	解析	結果	10.00.00	T. P. (177)	US 2 2 10			* 0		ų.		7044 - 10	1	20
		6.	3.	3	ガイ	ドホ	- n (てよる	き	裂の打	印制	効果	******	oune of a	0 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	-10,4411*	***	1	2 1
	6.	4		スム	- ス	・ブ	ラスラ	ティン	グ	に関う	する	現場	実験	X/9 =/		HI KAR		1	26
		6.	4.	1	実験	現場	附近@	2見取	図	と岩る	日の	物理	的性	質 -		mir -es		1	26
		6.	4.	2	実験	方法	ie i	MUD NOT	M.O. 1513	7 2 202.07					2 7-2	970		1	2 7
		6.	4.	3	実験	結果	50000 (0.1	040 00 00 00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	or a ass	erana na ara		-140	par sa		(40000000000000000000000000000000000000	- 1	29
	6.	5		結	言	3 E		198		44 4	3032 B	40 Top	edica :		40.40	34	\$ (\delta \delt	1	3 4
鴻	7	草		特殊	形状	薬包	にょん	るき裂	と方	向の作	制御	S#41 %		weite	()	W. a	2-77-1111	1	3 5
	7.	1		緒	言	No. 140		************		**********	Source	- 1875 - 41	0 - 4	ROF (A)	+	+1 +4	an anna a	1	3 5
	7.	2		特殊	形状	薬包	N: ******	7 2 100	**					- 2 × 6	1.0E-00-0	4 4341	** * *****	· 1	3 5
	7.	3		応力	解析	条件	およう	び解析	f 結	·果	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	iir mil	mer non	017/107/2122	0100			1	3 7
	7.	4		特殊	未形状	薬包	を用り	ハて t	ュメ	ント	モル	タル	プロ	ック					
				を切	の断す	る実	験	i) kuosmaseo						eu - 24442)	www.			1	4 5
		7.	4.	. 1	実験	方法	10.116114			x								1	4 5
		7.	4	. 2	実験	結果		······································			**********			2.32.79	1 200 11			1	4 7
	7	5		結	营				55555	###C#O ##O	1000000		193- 1		6.7.5	o a char	1.100 (B) (100)	. 1	5.3

第8章	プリスプリッティングにおけるプリスプリット	
	の効果	4
8. 1	緒 言	4
8, 2	プリスプリットが本爆破にともなり波動を軽減	
	させる効果について 15	4
8. 2	1 き裂が存在する岩盤を弾性定数を変化させ	
	ることにより, き裂を表現する方法 15	5
8. 2	2 き裂が存在する岩盤には空孔があるものと	
	してき裂を表現する方法 15	8
8.2	3 Air gap として、き裂を表現する方法 16	1
8. 4	結言17	1
第9章	結論 : *** : *** : *** : **** : ***** 17	2
	謝辞17	8

第 1 章

緒 論

1.1 緒言

爆破作業は鉱山、土木などの分野では欠くことのできない作業の一つであり、建築の分野でも必要な作業となりつつある。爆破は、熱力学的に非常に不安定な物質である爆薬を用いて岩盤などの材料を目的に応じた大きさに破壊することを主な目的として実施されることは過去、現在ともに変わっていない。また、爆破作業の良否が操業能率に大きな影響を与えることは周知のとおりであるし、爆薬が爆轟を開始すると途中で爆轟を止めることはできないために、従来より保安の面からも合理的な爆破設計が望まれている。

最近では、爆破により破壊させたくない部分には損傷を与えず、こわしたい部分のみを破壊したいという要望が高まってきており、そのために種々の制御爆破工法が開発されてきている。そして、このような制御爆破についても良好な施工例が報告されつつあるが、爆破による破壊現象が非常に短時間に終了してしまうことと、動的な要素と静的な要素とが複雑にからみ合った現象であるために、制御爆破については、その破壊機構を理論的に検討しているものは少ないようである。

以上のような事情を考慮して、本研究は、制御爆破に際しての材料の破壊機構を明らかにし、制御爆破の合理的な設計に対して有用な資料を提供することを目的として行なったものである。すなわち、合理的な制御爆破の設計を行なうためには、まず、基本的な爆破条件のもとでの爆破による材料の破壊機構を明らかにする必要があるため、本研究は、まず基本的な爆破条件のもとにおける材料の破壊機構を理論的、実験的に究明し、その結果をふまえて制御爆破工法における材料の破壊機構について、理論的、実験的に究明したものである。

1.2 本研究に関連した従来の研究

爆破に関する基礎的な研究は、その重要性のために古くから多くの研究者によって行なわれてきており、制御爆破工法に関してもいくつかの報告がなされているので、本節では爆破に関連した従来の研究の概要を示すことにする。

爆薬の爆轟にともなって装薬孔内壁に作用する圧力は、衝撃的に作用する 圧力と、静的に作用する圧力とが相連続しているため、材料内に生ずる応力 状態も、爆轟衝撃によって材料内に投射された強力な応力波による動的な応 力状態と、ガス圧の作用にもとづいて生ずる準静的な応力状態とに分けて考 えることができる。したがって、従来より発表されている爆破に関する研究 においても、主として動的な応力状態と破壊について論じているものと、主 として静的な応力状態と破壊について論じているものとに分けることができ る。

基本的な爆破条件である一自由面爆破を対象にして論じている理論についてみてみると、動的な爆破理論として、自由面におけるホブキンソン効果による引張応力の発生をとくに重視して、爆破による破壊は主としてとの作用のもとに行なわれるというものがあり、日野により提唱されている。この理論は、爆薬の爆轟にともなって岩盤内に投射され、自由面方向に伝播していく圧縮衝撃波が自由面で反射すれば、引張衝撃波としてふたたび岩盤中を引き返していくが、その際との引張衝撃波の作用によってクレータが生成するという考え方にもとづくものである。これによれば、まず反射引張衝撃波によって自由面近傍にSlabbingと呼ばれている平板状の引張破壊が生じ、ついでこの破断面を新しい自由面として衝撃液が反射し、同様の平板状の破壊を生成し、順次このような破断と反射とが繰り返えされてクレータが生成するというものである。したがって、この理論ではクレータは自由面から爆源に向って生成することになる。

一自由面爆波の際に応力波の伝播にともなって岩盤内に生ずる応力状態は、

伊藤、佐々によって理論的に解析されている。これは、爆源から周囲の岩盤 内へ投射された縦波が自由面へ入射した場合には、自由面から新たに反射縦波と反射横波とが岩盤内へ投射されるために、自由面近傍の任意の点に発生する応力は、爆源から直接その点に入射する縦波による応力と、反射縦波による応力および反射横波による応力との三つの応力の合成値となるという考えにもとづくものである。

また、一自由面爆破における破壊現象と岩盤内に生じている応力状態との関係を静的な問題としてとらえた最近の研究では、Jeffryによって求められた応力関数を用いた解析結果が花崎、伊藤とD.D.Porter, C.Fairhurstとによって別個に報告されている。さらに、水中に存在している岩盤が水圧を受けている場合の一自由面爆破の際の岩盤内の応力状態を有限要素法を用いて解析した結果が花崎、伊藤によって報告されている。

以上に示したように、もっとも基本的な爆破である一自由面爆破の際の岩盤の破壊機構に関して埋論的に研究された結果はかなり多く報告されている。 つぎに、制御爆破工法に関連した従来の研究の概要を示すととにする。

制御爆破工法と呼ばれる工法にはいくつかの工法が含まれており、たとえば Line Drilling, Cushion Blasting, Smooth Blasting, Pre—shearing, Pre—splitting, Sculpture Blasting, Perimeter Blasting, Coutour Blasting などの名称で呼ばれている。これらを整理すれば、(1)ラインドリリング法、(2)プリスプリッティング法、(3)スムース

プラスティング法の三つに分類できるであろう。

第1のラインドリリング法は、切断予定線に沿って多数のボアホールを狭い一定の孔間隔で穿孔し、ボアホールには爆薬は装填せず、爆破に起因する振動やき裂は切断予定線上に設けたこれらのボアホールによって遮断し、それらより奥にはあまり伝わらないようにする方法である。この方法はボアホール間隔を小さくする必要があり、穿孔時間を多く必要とすることからあまり実施されていないようであるが、ラインドリリング法をテネシー川のウィルソンダムに大規模に適用した例が J.E. Mc Clintonによって報告されている。

第2のプリスプリッティンク法も切断予定線に沿って多くの装薬孔を穿孔 するが、これらの孔には爆薬は軽装塡され、切断予定線上にあるこれらの装 薬は他の装薬よりも時間的に早く起爆される。したがって,切断予定線に沿 って装薬孔を結ぶき裂が生じ、ラインドリリング法と同様に岩盤内に不連続 面ができることになる。燥破によりこのような不連続面をつくるため、切断 予定線上の穿孔間隔は,ラインドリリング法に比較して大きくすることがで き,経済的となる。この工法の大規模な実施例は、1960年頃に実施された ナイアガラ発電所建設計画におけるプリスプリッティングが有名であって, R.S.Paine, D.K. Holmes, H.E. Clarkによって報告されている。また. と の報告で Paine らは、切断予定線上に存在する装薬孔間にのみ、どうして 大きなき裂が生成するかについて述べており、主な原因として、装薬孔の接 線方向に主として引張応力として作用する応力波が、互いに干渉することに よって切断予定線上に大きな引張応力が生ずることをあげている。J.J. Ludwig.A.K.Smith は, Plexiglass を用いたプリスプリッティングの 実験で高速度写真を撮影した結果,一つの装薬が爆轟した場合には, この装 薬孔壁面からき裂が生成すると同時に、隣接した装薬孔壁面からも切断予定 線に沿ってき裂が生成することを指摘し、隣接した装薬孔周辺に生ずる応力 集中の効果をあげている。また、同様に、U.Langefors,B.Kihlström

は、装薬孔に隣接して穿孔したガイドホールの効果について検討し、ガイドホールの影響が大きいことを指摘している。さらに、H、K・Kutter、C・Fairhurstは、 隣り合った装薬が同時に爆轟した場合、少しの時間差を持って爆轟した場合、それぞれが別個に爆轟した場合などについて実験的に検討し、またガス圧の役割についても言及している。

第3のスムース・プラスティング法も,切断予定線に沿って多くのポアホ ールを設け、これらのボアホールにはプリスプリッティング法と同様に爆薬 が軽装塡される。しかし、プリスプリッティング法と異なるところは、これ ちの軽装塡された装薬が最後に起爆されることである。プリスプリッティン ダ法,スムーヌ・プラスティング法は,いずれも元来スウェーデンで開発さ れたものであって、スムース・プラスティング法の大規模な実施例はスウェ ーデンのEtronorrfors Power Stationの建設工事においてみられる。 スムース・プラスティング法の場合の岩盤の破壊機構は,プリスプリッティ ング法の場合とほぼ同じと考えられるが、スムース・プラスティング法を実 施する場合は、切断予定縛に平行な自由面がすぐ近くに存在することがブリ スプリッティング法の場合とは異なる。スムース・プラスティング法におけ る破壊機構については、伊藤、佐々によって動的な応力解析の結果より考察 した研究が発表されている。この研究では、装薬孔壁面から材料内に投射さ れる応力波の波長が、隣接して設けられた装薬孔の直径に比較して長い場合 K, この隣接した装薬孔壁面と切断予定線との交点K生ずる応力集中を重視 して応力解析を行なっている。また、静的な応力解析結果からスムース・プ ラスティングにおける破壊機構を論じたものに下村、山口の研究がある。 この研究では、切断予定線上にある二つの装薬孔の中心を原点とする双曲座 標を用いて、切断予定線上に生ずる応力を解析し、隣接した装薬孔の存在に よる応力集中を重視して, スムース・プラスティングの際の破壊機構につい て検討している。

1.3 本研究の目的と内容

前節に示したように、一自由面爆破については、理論的なものに限っても従来から多くの研究者によって研究されてきており、かなりの成果があげられている。とくに、難解な爆破現象は伊藤らによって系統的に解明されつつあるが、しかし一つ一つの現象をとってみるとまだ明らかでない点が多く、このことが爆破による破壊機構についても種々の考え方が存在する理由でもある。また、前節において制御爆破工法についてはその実施例を多くあげていることからわかるように、制御爆破工法についての理論的研究はようやくその緒についたものといえる段階であって、現場における実施にあたっても今のところ試行錯誤の段階といえるであろう。制御爆破工法に関する理論的研究が遅れている最大の理由は、なんといってもこの工法を対象にした応力解析が困難であったことをあげることができる。しかし、近年、電子計算機の発達により、複雑な境界条件を含む問題に対しても、動的あるいは静的な応力解析ができるようになってきたため、条件が複雑な制御爆破工法における破壊機構について、理論的な研究を行なりことができるようになってきた。

以上のような事情を考慮して、本研究は、基礎的な爆破現象のうちでまだ明らかにされていない事柄を究明しつつ、その成果をふまえて、制御爆破工法による材料の破壊機構について研究し、それを明らかにするとともに、装薬孔周辺に放射状に生成するき裂をいかにして制御して希望する方向にのみき裂を生成させるかについて検討し、合理的な制御爆破の設計を行なうための資料を得ることを目的として行なったものである。

さて、制御爆破工法による破壊現象を考察するためには、まず、なんらの 制御を行なわないで爆破を実施した際に生ずるき裂の生成機構、およびき裂 が生成する方向性などについて検討しておかなければならない。そこで本研 究においては、まず第2章において、無限媒質と考えられる媒質内で一つの 装薬が爆躁した場合に装薬孔から材料内に投射される応力波の伝播にともな って放射状に生成するき裂の生成機構について検討し、準静的な応力状態の もとで生成したき裂の生成機構との差について述べた。また、第3章においては、爆破の基礎の一つである一自由面爆破について、電子計算機を用いて引張破壊を考慮に入れた応力解析を行ない、き裂の成長過程をシミュレートした結果と実験結果とを対比することにより、一自由面爆破の際の破壊機構について考察を行なった。

制御爆破を実施する場合には、多くの装薬孔を穿孔するが、とくに相隣り合う装薬孔同士はたがいに空孔として作用するため、それがき裂制御に大きな影響をおよぼすものと思われる。しかしながら、空孔周辺の過渡的応力状態はまだ充分解析されていないように思われるため、第4章においては、動的応力が空孔の存在によってどのように乱されるかについて理論的に検討するとともに、一実験例を引用して実験的に検討した結果と理論的な研究で得られた結果とを比較検討した。

以上の研究により、なんちの制御をも行なわない爆破によって生ずるき裂の生成機構およびき裂が生成する方向など、制御爆破を検討する際に必要となる基礎的な点が明らかとなったので、つぎに、制御爆破を実施した場合の材料の破壊機構などについて検討した。勇 5章では、スムース・プラスティングを実施した場合の材料の破壊機構について、引張破壊を考慮に入れて応力解析を行なった結果から考察を行ない、さらに最適爆破条件を得るために一、二の検討を行なった。

第6章では、スムース・プラスティングにおけるガイドホールの効果について、ガイドホールの方向に生成したき裂面から材料内に投射される応力解放波の影響を重視して理論的、実験的に検討し、さらに、実操業規模の現場実験を行ない、有効と考えられるスムース・プラスティングの工法を提示した。

制御爆破工法の進歩は,爆薬そのものにも変化を与えてきており,最近ではガス圧の作用を重視し,爆破による振動を少なくして市街地でも使用できる爆薬,すなわちコンクリート破砕薬が開発されてきている。そこで,第7

章では、コンクリート破砕薬を特殊な形状をした薬包に入れ、この薬包を装填して爆破を実施した場合の材料内に生ずる応力状態を有限要素法を用いて解析し、その結果と大きなコンクリートブロックをこの特殊形状薬包を用いて切断した実験結果とから、き裂の方向を制御する特殊形状薬包の効果について述べた。

第8章は、制御爆破工法の一つであるブリスブリッティング法について検討したものであって、ブリスブリットが本爆破によって生ずるき裂を制御し、ブリスブリットよりも奥に生長しようとするき裂を抑制する効果について理論的、実険的に考察し、合理的なプリスブリッティング法を実施するために有用と考えられる一、二の資料を提示した。

なお、第1章は緒論で、制御爆破工法に関する従来の研究の概要および本 研究の目的と内容とについて簡単に述べ、第9章は結論で、本研究の結果を 総括して示したものである。

参 考 文 献

- 1) 日野熊雄:工業火薬協会誌, 15-4(1954), 233
- 2) 伊藤一郎, 佐々宏一: 日本鉱業会誌, 79-898 (昭38), 261
- 3) 村田 勉,田中一三:工業火薬協会誌,15-4(昭29),294 村田 勉,田中一三:工業火薬協会誌,16-1(昭30),32 村田 勉,田中一三:工業火薬協会誌,17-1(昭31),19
- 4) 花崎紘一, 伊藤一郎: 水曜会誌. 17-2(昭45), 61
- 5) D.D. Forter, C. Fairhurst: Dynamic Rock Mechanics, Twelfth Symposium on Rock Mechanics. (1971)497
- 6) 花崎紘一, 伊藤一郎: 工業火薬協会誌, 33-144(昭47)
- 7) J.E.Mcclinton: The Explosives Engineer, 1959 January -February P.5
- 8) R.S. Paine, D.K. Holmes, H.E. Clark: The Explosives 1961, May-June P.71
- 9) J.J.Ludiwg, A.K. Smith: Mining Congress Journal, 1965 October, P.66
- 10) U, Langefors, B. Kihlström: The Modern Technique of Rock Blasting John Wiley & Sons, 1963, P. 296
- 11) H.K.Kutter, C.Fairhurst: Proceedings of the Ninth Rock Mechanics Symposium, Chap. 14, Colorado School of Mines, Golden AIME, New York (1968) P. 265
- 12) 文献 10)
- 13) 伊藤一郎, 佐々宏一:日本鉱業会誌,84-964(1968),1059
- 14) 下村弥太郎, 山口梅太郎: 工業火薬協会誌, 30-2(1969)71

第 2 章

応力波の伝播にともなうき裂の生成機構

2.1 緒言

合理的な爆破設計を行なりためには、爆破にともなり媒質の破壊現象を的確にとらえておく必要があるが、爆破による破壊現象は動的な要素と静的な要素とが互いに影響しあうことなどで、大変複雑である。また、この現象が非常に短時間に終了してしまりために、簡単にその過程を観察することはできない。しかしながら、爆薬の爆器にともなって、媒質内にはまず最初は動的な応力状態が生ずるであろうし、また、爆破の主な対象物である岩石は引張りに弱いことを考慮すれば、装薬孔周辺の破壊圏の外周は引張破壊によって生じたき裂によって定まるものと思われる。したがって、装薬孔内壁から投射された応力波の伝播にともなって放射状に生ずるき裂の生成機構について検討することは重要である。

また、ある材料が爆薬の爆爆による衝撃を受けた場合には、材料内へ投射 された球面状応力波により、応力波の伝播方向に沿うき裂が生成すること はよく知られているが、このようなき裂の生成機構についてはなお明らかで ない点が多い。

そこで本章では、爆薬が無限媒質と考えられる材料内で爆轟した場合に材料内に生じた破断面を、光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて観察した結果をもとにして、き裂の生成機構について検討した。なお、今回の研究の対象に選んだ材料は、光学顕微鏡により容易に破断面を観察することのできるメタアクリル酸樹脂板である。

2.2 無限媒質と考えられる材料内に生ずる応力波形

無限媒質内で爆薬が爆器した場合に、弾性体とみなされる媒質内に投射さ

$$\sigma_{\gamma}(\tau) = (\lambda + 2 \mu) \left\{ -\frac{n \text{ A o U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1} - \frac{\text{B o V}(\tau)}{\gamma \text{ m C}_{L}} \right\} + \lambda \frac{\text{A o U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1}$$

$$\sigma_{\theta}(\tau) = (\lambda + 2 \mu) \frac{\text{A o U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1} + \lambda \left\{ -\frac{n \text{ A c U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1} - \frac{\text{B o V}(\tau)}{\gamma \text{ m C}_{L}} \right\} \dots (2.1)$$

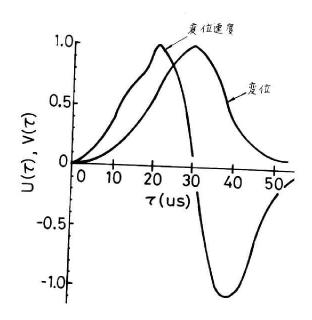
$$\sigma_{z}(\tau) = \lambda \left\{ -\frac{n \text{ A o U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1} - \frac{\text{B o V}(\tau)}{\gamma \text{ m C}_{L}} + \frac{\Lambda \text{ o U}(\tau)}{\gamma \text{ n} + 1} \right\}$$

ただし、 $\tau=t-r/C_L$ 、 λ 、 μ はラメの定数、 C_L は縦波の伝播速度、n、m はそれぞれ媒質粒子の変位および変位速度の距離による減衰指数、 A_G Bo はそれぞれ r=1 での変位および変位速度の値、U(r)、V(r) はそれぞれ 爆源



第2.1図 メタアクリル酸樹脂板を1号電気雷管で衝撃した場合に粒子の変位, 変位速度を測定する方法

・らての点における変位および変位速度の時間的変化を表わす。計算に必要これらの諸数値は第2.1 図にその方法を示す実験により求めることができっすなわち、厚さ1.8 cmのメタアクリル酸樹脂板に設けた直径0.7 cmの装孔内で1号電気雷管を爆轟させ、樹脂板内に投射された応力波の伝播にとなって、板の端面に生ずる変位の時間的変化状態を、岩崎通信機製の容量微小変位計MD-12型またはプリモ社製FM振動計FV-805 型を用い御定し、その信号を増幅器で増幅し、変位に対応して生ずる信号電圧の時的変化状態、およびその信号を微分回路を通すことにより端面の変位速度対応する電圧の時間的変化状態をそれぞれ2要素シンクロスコープにより録する。ただし、この測定は、媒質の端面で測定するために、媒質内に生



第2.2図 メタアクリル酸樹脂板を1号電気雷管で 衝撃した際に材料内に生ずる粒子の変 位および変位速度の時間的変化状態

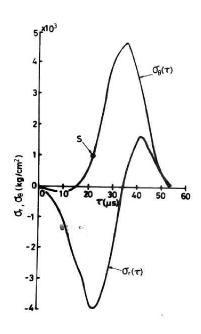
ずる値の2倍の大きさの値を記録していることになる。このようにして得られた変位および変位速度の時間的変化状態の一例を示したのが第22図であって、変位および変位速度のいずれも、それらの最高値を1として表わしてある。第22図より、波動の主な部分が媒質端面に作用している時間はほぼ50μS であることがわかる。このような測定を数個所の測点について実施して求めたその他の数値はつぎのとおりである。

 $\text{C}_{\,\text{L}}\!=\!3\!\times\!1\,\,0^{\,3}\,\text{ m/s}$, $\text{n}\!=\!0.9$, $\text{m}\!=\!0.9$, $\text{Ac}\!=\!0.0\,876\,\text{cm}$

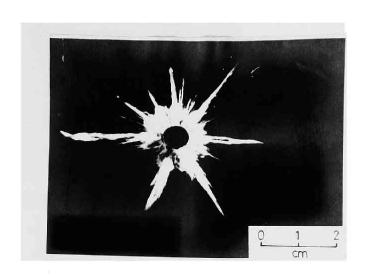
 $B_o=6 imes10^3$ cm/s , $\lambda=7.38 imes10^7$ g/cm , $\mu=1.83 imes10^7$ g/cm これらの値を(2.1)式に適用して,材料内に生ずる応力を計算した。その

2.3 図は材料が破壊しないと仮定した 場合に、装薬孔の中心より1cmの点に 生ずる応力 σ_{Υ} , σ_{θ} の時間的変化状 態を示したものである。この図より明 らかなように、爆源から材料内に投射 される応力波の伝播方向, すなわち, 波面に直角な方向の応力σγは主とし て圧縮応力として作用し,接線方向の 応力 σ_{θ} は主として引張応力として作 用する。ただし、との点では、波動が 到達してから 15μ s程度の間は σ_{t} が 圧縮応力 として作用するので、波動が との点に到達してから15μs以内の 時間では, あらゆる方向に圧縮応力が 作用していることになる。また, 応力 の生じている時間は約50μsである。 このようにσμの大きな引張応力によ

一例を示したのが第2.3図である。第



第2.3図 爆源から1cmの点に 生ずる主応力 σ_{Υ} , σ_{θ} の時間的変化状態



第2.4図 **0**0 の引張応力によって生成する 放射状のき裂

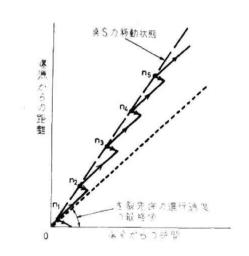
って、装薬孔周辺には第2.4図に示すような爆源を中心とする放射状のき裂が生成する。

2.3 応力波の伝播にともなりき裂の生成機構に関する一考察

いま、応力波の伝播により生ずる接線方向の応力 $\sigma\theta$ の値がその材料の動的な引張強度に達したとき、すなわち、第23図に示した $\sigma\theta$ の時間的変化状態を表わす曲線上に示した S点においてその材料にき裂が生成すると仮定する。一方、爆薬の爆轟によって材料内へ投射される応力波は、応力最高値の減衰および波形の変化をともないながら縦波の伝播速度で材料内を伝播してゆくので、S点に対応する応力値も爆源近傍では縦波の伝播速度に近い速度で材料内を進行することになる。したがって、爆源近傍の材料内を破壊が進行する速さも縦波の伝播速度に近い値をとるものと考えることができる。ところが他方では、従来から行なわれてきた理論的および実験的検討の結果によれば、材料内に生成するき裂の先端が進行する最終速度は、ほぼレーリ

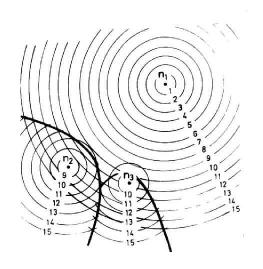
-波の伝播速度に近い速度であることが示されている。^{2),3),4)}

以上の2点を合わせて考えれば、爆薬の爆轟によって材料内へ投射された 応力波に起因して生ずる放射状のき裂は、燥源から連続的に生成するのでは ないことがわかる。そこでいま、応力波の伝播にともなって材料内にはまず 多くのき裂の核が生成し、それらの個々の核から生成する別個のき裂がつな がり合って一つの大きなき裂を形成するものと考えてみる。このような考え



第2.5図 応力波によるき裂の核の生成を核を中心とするき裂の 結合によって完成するき裂 の生成機構

のように、応力波の伝播にともなって作用する引張応力によってき裂の核が 生成すると、核の周辺部には応力集中が発生するので、応力波による引張応 力の作用方向に直交する面内にそれぞれの核を中心とし、その先端が同心円 状に発達していくき裂が生成するものと考えられる。これらの核を中心とす る別個のき裂は発達するにつれて互いに結合することになるので、これらの 別個のき裂の結合によって一つの長いき裂が生成することになる。このよう な核を中心とし、その先端が同心円状に発達するき裂の進行速度の最終値は、 レーリー波の伝播速度に近い値であろうと推定されるから、第2.5 図に示す 実線の傾斜は、点線の傾斜と一致することになる。

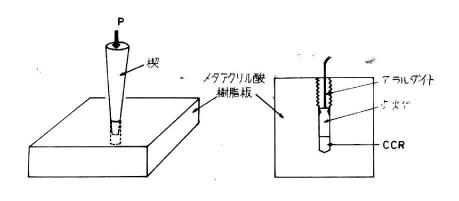


第2.6図 応力波によるき裂の生成機 権に関する説明図

平面内にあるとは考えられないので、核n、からのき裂と核n。からのき裂とが結合して生成したき裂面においては、両者の結合点に段がつき不連続的となるものと思われる。したがって、それぞれの核から発達してきたき裂の結合点の軌跡は、発生した長いき裂の面上に一種の模様となって現われ、かつ、その模様は第2.6図の太い実線で示したような放物線状の曲線となるものと推論することができる。

- 2.4 走査型電子顕微鏡および光学顕微鏡によるき裂面の観察
 - 2.4.1 静的応力状態と考えられる場合に生成するき裂面の光学顕微鏡に よる観察

まず、応力波の伝播にともなって生成するき裂の生成機構と静的応力によ って生成するき裂のそれとの差違を明瞭に理解するために、応力波の伝播に ともなって生成したき裂面の観察結果を示す前に、荷重が静的と考えられる 場合に生成したき裂面を観察した結果を示すことにする。今回は、強力な波 動は発生しないような荷重速度で,しかも時間とともに増大する外力によっ て材料を破壊する方法として、第2.7図(a)、(b)に示す2種類の方法を用いて

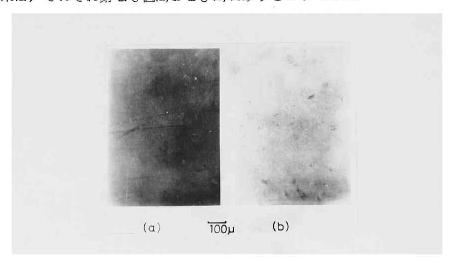


を楔で割る方法

(a)メタアクリル酸樹脂板 (b)メタアクリル酸樹脂板 を CCR で割る方法

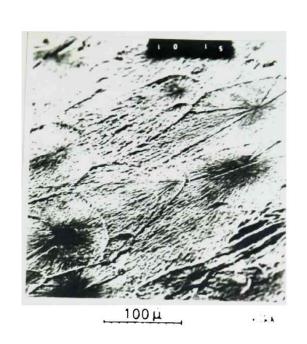
第2.7図 準静的に加えた荷重により材料 を破壊させる実験方法

材料を破壊し、その場合に生成したき裂について検討した。すなわち、 第2.7回(a)に示す方法は、厚さ1.8cmのメタアクリル酸樹脂板に直径0.7cm の穴を設け、その穴に楔を押し込んで板を二つに割る方法であり(1)に示す方 法は、圧力の立ち上り時間が比較的遅いために,爆発しても材料内には波動 が発生せず、ガス圧のみで材料を破壊するようにつくられているコンクリー ト破砕薬の一種であるCCRをメタアクリル酸樹脂板内に装塡し、アラルダ イトで密閉して爆発させ、板を割る方法である。このような2種類の方法で メタアクリル酸樹脂板を割った場合に生成したき裂面を光学顕微鏡で観察し た結果は、それぞれ第2.8図(a) および(b) に示すとおりである。



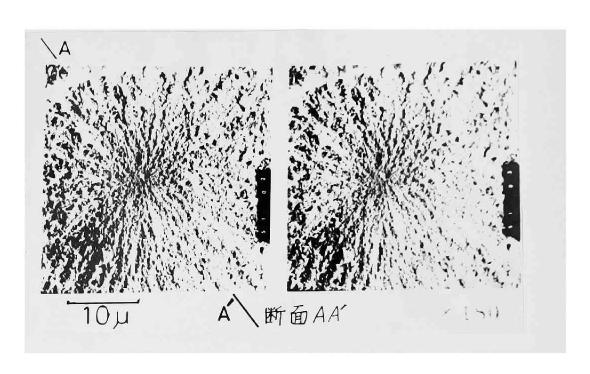
第28図(a)は、楔を押し込んで得たき裂面の観察結果であるが、破断後に傷つけた傷以外には、不連続的な模様は何も見つけられない。また、第28図(b)に示したCCRの爆発により得たき裂面の場合も、本章の23節で推定したような放物線状の模様はみとめられない。このように、強力な波動が発生しないような準静的な荷重によってメタアクリル酸樹脂板を破壊させた場合には、そのき裂面上に放物線状の模様が発生しないということを明らかにすることができた。

2.4.2 応力波の伝播にともなって生成したき裂面の顕微鏡による観察 つぎに、応力波の伝播にともなって生成したき裂面の顕微鏡による観察結 果を示すことにする。今回観察したき裂面は、厚さ1.8 cmのメタアクリル酸 樹脂板に直角に設けた孔内で1号電気雷管を爆調させた場合に生成した放 状き裂(第24図参照)の面である。まず、第二9図は、応力改の伝播に もなって生成した上記の放射状き裂の表面を、走査型電子顕微鏡で観察し 場合に得られた顕微鏡写真の一例であるが、この写真よりき裂面上に存在 る放物線状の模様を明瞭に認めることができる。また、この放物線状の模



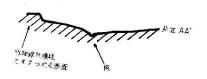
第2.9図 応力波の伝播にともなって生成 したき裂面の走査型電子顕微鏡 写真

の焦点の位置を中心として放射状に伸びる細いすじが数多く認められ,さにその中心に小さなくほみを認めることができる。このくぼみの中心がきの核である。第2.10図は,第2.9図と同じ試料の他の部分を拡大して写た写真であって,爆源からほぼ1.5cmの位置の立体写真である。左右の写



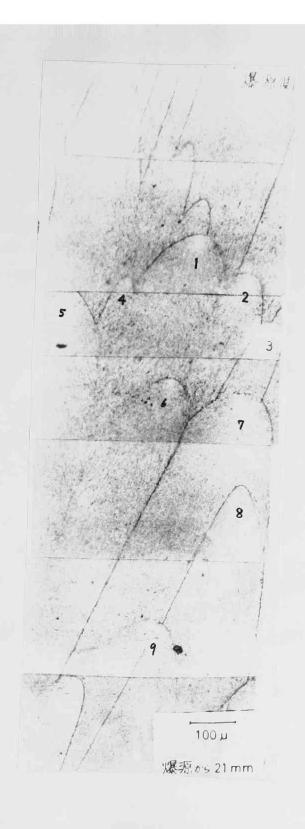
第2.10図 核の近傍の立体写真

の相対的な傾斜角は約5°である。 第210図を立体写真用眼鏡で観察 すると,第210図の線分AA′の断 面は第211図のようになっている ことがわかる。すなわち,き裂の核 のところはへこみ,き裂の核から離 れるにしたがって感り上り,放物線



第2.11図 第2.10図に示した 断面AA¹の観察図

状模様として認められるところは不連続的にとび出しているのが観察できる。 これは、放物線状模様が、それぞれの核から同心円状に発達するき裂の結合 点の軌跡であるという前節で示した推定を裏づけている。



勇 2.1 2 図 き裂面の光学顕微鏡写真

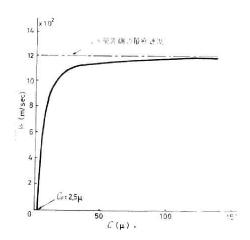
2.5 放物線状模様の作図

第2.12図は、爆源から放射状に生成したき裂の一つをとり出し、爆源から2.1cmの点の附近でのき裂の表面を光学顕微鏡で観察した結果を示したものであって、走査型電子顕微鏡による観察で得られた第2.9図の写真と同様に、放物線状模様を明瞭に認めることができる。このような放物線状模様は、2.3節で推定したように、核を中心とするき裂の結合点の軌跡であると考えることができるので、核を中心として同心円状に拡がるき裂の進行速度がつぎの(2.2)式を満足するものと仮定して、計算によってき裂の結合点の軌跡を求め、その形と実際に生成した放物線状模様とを対比してみた。

$$V c = \sqrt{\frac{2\pi}{K} \cdot \frac{E}{\rho}} \left(1 - \frac{Co}{C}\right)^{1/2} \left\{1 - (n-1)\frac{Co}{C}\right\} \frac{1}{2}$$

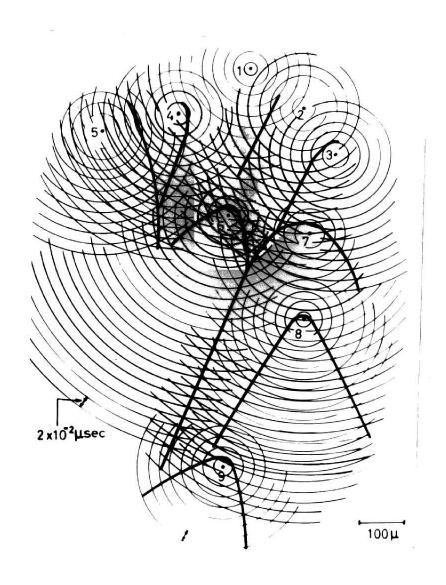
$$= Vm (1-\frac{Co}{C})^{\frac{1}{2}} \left\{ 1-(n-1)\frac{Co}{C} \right\}^{\frac{1}{2}} \cdots (2.2)$$

ただし、Vc :核から拡がるき裂先端の進行速度,K :定数,E :ヤング率, ρ :密度,Co :核の半径,C :核を中心とするき裂の長さ, $n=\frac{4\gamma E}{\pi C_0\sigma_0^2}$, γ :比表面エネルギー, σ_0 :場の応力, V_m :き裂先端の進行速度の最終値である。今回は, $V_m=1.2\times10^{3\,m}/_{\rm S}$, $C_0=2.5\,\mu$,n=1.6 として計算を行なったが,これらの値はメタアクリル酸樹脂板の物性および顕微鏡観察の結果を考慮して定めた妥当な値である。まず, 2.13 図は,(2.2)式より求めたき裂先端の進行速度とき裂の長さとの関係を示したものであって,図より明らかなように,場の応力が一定の場合には,き裂の先端の進行速度は,核からのき裂の長さが長くなるにしたがって速くなり,最終速度に漸近的に近づくことがわかる。なお,最終速度の9.0%の速さになるのに必要な時間は $2.5\times10^{-3}\mu_{\rm S}$ である。第2.1.4 図は,第2.1.2 図に示した写真に現われているき裂の核の直径を 5μ とし,その核から

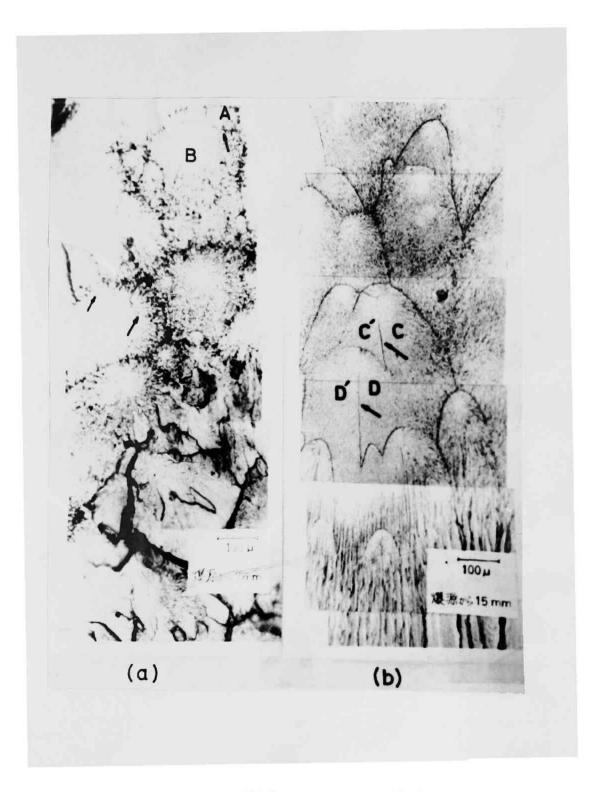


第 2.1 3 図 き 製先端の進行速度とき 裂 の長さとの関係

第2.13図に示した関係をもつ進行速度でき裂が進行するものとして、それぞれの核から進行してきたき裂の結合点の軌跡を求めて示したものである。第2.14図に示した1、2、・・・・・・9の数字は、第2.12図の写真に示した1、~9の数字に対応している。第2.12図と第2.14図に示した6、7、8、9の数字の周囲の放物線状模様を比較すれば明らかなように、両者は比較的よく一致している。数字8で示した両者の放物線状模様は少し異なっているが、これは実際には理論的に核が生成すると思われる時間よりも遅れて核が生成したためと思われる。また、数字9で示した放物線状模様において、第2.12図では核から生ずる明瞭な一本の筋が観察されるが、第2.14図では作図されていない。これは、この筋の成因が、放物線状模様の成因とは異なるためと思われる。このように、実際に顕微鏡観察で得られた放物線状模様と作図によって求めたそれらとが比較的よく一致していることは、2.3節



第2.14図 作図により求めたき裂の結合点の軌跡



第2.15図 第2.12図と同じき裂面の顕微鏡写真

2.6 放物線状模様の形状

第2.15図(a), (b)は、それぞれ第2.12図で示したものと同じき裂面で爆源から0.7cm および1.5cm の附近の光学顕微鏡写真である。これらから、放物線状模様の曲率は爆源から離れるにしたがって大きくなり、模様は細長くなる傾向が認められる。また、核の近傍では核から離れたところより白っぽいが、これは第2.13図に示したように、核の近傍ではき裂先端の進行速度が小さいために滑らかな面、いわゆる鏡面が生成したためと思われる。

今回用いたメタアクリル酸樹脂板は均質であると考えられるから、多くの 部分で,第25図に示したよりに,爆源からの距離に応じた時間に対応して 核が生成するという関係が成立すると思われるが、応力状態がなんらかの原 因で乱れたり、また材料の強度にばらつきがあるところでは、爆源からの距 離が近い点でも,それより遠くにある点より遅れてき裂の核が生成すること もあると思われる。したがって、その場合には放物線状模様は逆の方向に向 って形成されるであろう。そのようにして形成されたとみなされる放物線状 模様を,第215図@)に矢印で示した。そのうちのもっとも爆源側に近い放 物線状模様を一例としてみてみると、一般的には面Bを含む放物線状模様よ り面Aを含む放物線状模様の方の核が早く生成するが,ここではBの方の核 が早く生成したために、面 A を含む放物線状模様は下に凸になったものと思 われる。また, 第 2.1 4 図(b) に示した面 C, C' を含む放物線状模様や面 D, D'を含む放物線状模様には,矢印で示したように,それぞれの核から生成 している一本の筋が明瞭に観察される。これらの筋は、面Cと面C'が、ま た面 Dと面 D'とが異なった平面上に存在するために生ずることが,他の立 体写真から明らかとなっている。そして,面Cと面Dが同一平面上に存在す るために、その境界となるべき放物線状模様は明瞭な線としては現われてい ない。このような数個の核が同一平面上に存在するという傾向は, 爆源から 離れるにしたがって顕著となる。したがって、放射状に生じたき裂の先端に 近くなるほどき裂の幅は細くなることになる。つぎに、爆源至近点に生ずる

き裂面を観察した結果を示したのが 第216図であって,第216図回) は細長い楕円形をした核,第216 図向は一般であるとの様がとのである。 をのであって、これらの例はであって、これらの例はであって、これらの例はでいませる。 数した点のき裂面上に生ずるのようされた。 場際近傍ではなが観察されるは、 がらしい多い。これは、場際近傍を縮により材料の温度が上昇し、場際が生成する時 が比較してき裂の核が生成する時 が生成する時



(a)



(b)

第 2.1 6 爆源至近点で観察され ためずらしい形の核

に多くの抵抗を受けやすいために、種々の形をしたき裂の核が生成するので はないかと思われる。

なお、装薬孔壁面のごく近傍のき裂面には、第2.17図の写真に示すように、メタアクリル酸樹脂が一度溶けた後に再び凝固したと思われる部分が認

められ,材料内の温度が上昇し たことを裏づけている。

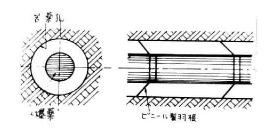


第2.17図 爆源至近点で観察され る破断面の一例

2.7 爆薬を軽装塡した場合の σ_{γ} , σ_{θ} の時間的変化状態

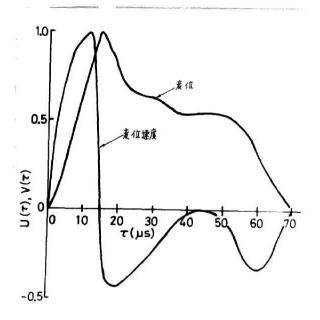
以上は、現在普通に使用されている破壊工法の場合について述べたが、ことでは制御爆破工法を実施する際に使用されている爆薬を軽装填した場合について述べる。

爆薬を軽装填する方法の一つは,第2.18図に示すように,第2.18図に示すように,装薬孔の直径より小さい直径の爆薬を,ビニール製の羽根などを用いて,装薬孔の動とが一致するように装填する方法である。こで表生を用いれば,爆薬の爆発にとずるために,爆薬の爆発にとするために,爆薬の爆発にと

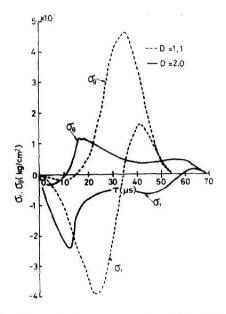


第 2.1 8 図 爆薬を軽装塡する 一方法

もなり尖頭圧が消滅し、装薬孔壁面に作用する圧力は準静的な圧力により近くなり、装薬孔壁面近くに生ずる粉砕圏を小さくすることができると考えられている。装薬孔の直径を爆薬の直径で除した値 De は、デカップリング係数と呼ばれており、De の値が1のときは密装填の場合であり、De の値が1より大きくなると軽装填したことになる。

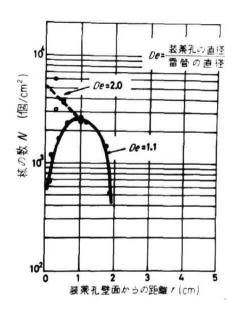


第2.19図 De = 2.0 の場合に爆源から4cmの 点に生ずる変位および変位速度の 時間的変化状態



第 2.20 図 De=2.01.1 の場合に爆源から1cm の点に生ずる主応力 σ_{7} , σ_{θ} の時間的変化状態 -29-

線で示した。図より明らかなように、 $D_0=2.0$ の場合は、 $D_0=1.1$ の場合に比べて、 σ_T のピークの値は約1/2 、 σ_g のピークの値は約1/5 にそれぞれ減少している。また、この σ_T の値から、 $D_0=2.0$ の場合の装薬孔内壁に作用する圧力の最大値は $D_0=1.1$ の場合のそれに比べて約1/4.5に減少しているものと推定できる。さらに、 $D_0=2.0$ の場合に、応力が作用している時間は $D_0=1.1$ の場合に比べて1.5 倍と長くなっている。このように、デカップリング係数を大きくした場合に媒質内に生ずる応力については、応力の値が小さくなり、作用する時間が長くなる、ということがいえる。つぎに、 $D_0=2.0$ の場合でも、 $\sigma_0=3.0$ の引張応力の大きさのいかんによっては、 娯源から放射状に発達するき裂が生成し、このき裂面上にも放物線状模様が現われるが、 $D_0=2.0$ と $D_0=1.1$ のそれぞれの場合に示す応力状態の差違が、き裂生成時にどのような影響を与えるかを検討することにする。



第2.21図 核の数と装薬孔壁面からの距離 との関係

2.8 核の分布密度

第2.21図は、き裂中に単位面積当りに存在している核の数№を縦軸にと り,装薬孔壁面からの距離γを横軸にとって、核の分布密度が距離とともに どのように変化するかを示した図である。図より明らかなように, De=1.1 の場合には、装薬孔壁面近傍では $N \doteq 6.6 \times 1.0^2$ 個 $/ cm^2$ であるが、 $\gamma \leqslant 10$ cmの範囲では、 γ の増加とともcN は順次増加し、 $\gamma \rightleftharpoons 1.0 cm$ 近傍では $\mathbb{N} \div 2.5 \times 10^{3}$ 個 $/ c_n^2$ の最大値となり, $r > 1.0 c_m$ の範囲ではrの増加とと もにNは減少している。しかるに、D_a = 2.0の場合には、装薬孔壁面近傍で は N ÷ 5 × 10³個/cmという大きな値を示し、 アが大きくなるにしたがって Nは順次減少している。一方,装薬孔内壁では, $D_{\alpha}=1.1$ の場合の圧力は D_e = 2.0 の場合の圧力に比較して約 4.5 倍であるにもかかわらず,装薬孔 壁面近傍の核の数は, $D_{\rm e}=1.1$ の場合の方が, $D_{\rm e}=2.0$ の場合よりも少な くなっている。これは,すでに述べたように,応力波の伝播にともなう断熱 圧縮により材料内の温度が上昇し、延性が増したことなどに起因しているも のと思われる。また,r>1㎝の範囲では,rが大きくなるにしたがってN の値が小さくなるという現象については,応力波の伝播とともに波頭応力が 滅衰するために,材料内に生ずる応力が小さくなり,核になりにくい材料内 の欠陥は,核にまで成長せず,核になりやすい欠陥だけが核になるために, rの増加とともにNの値が減少すると解釈すれば説明することができる。

2.9 結言

本章においては、無限媒質と考えられる媒質内で爆薬を爆題させた場合に、 爆薬の爆轟により媒質内に投射される応力波の伝播にともなって、装薬孔を 中心として放射状に生ずるき裂の生成機構を、雷管衝撃によってメタアクリ ル酸樹脂板に生じたき裂面を、走査型電子顕微鏡および光学顕微鏡で観察し た結果を用いて考察した。 その結果、第24図に示した写真のように、爆破後、き裂が完成した時には一つの大きなき裂であっても、このき裂は爆源側から連続的に生成するのではなく、応力波の伝播にともない、まず多くのき裂の核が生成し、このようなき裂の核から同心円状にそれぞれ別個に生成する小さなき裂が結合し合って一つの大きなき裂になることを示した。また、き裂上におけるき裂の核の分布状態を調べた結果、今回の実験で得られたき裂の場合には、核の分布密度は最大約6×10³個/c㎡であった。また、この核の分布状態は、爆源からの距離に応じて種々の変化を示し、核の生成には材料内に発生する応力状態が大きな要素として考えられることを示した。さらにまた、核の分布状態かよび放物線状模様の大小などの関係から、材料内に潜在的に存在する欠陥には、小さな応力状態のもとで核からき裂へと成長する欠陥、および小さな応力状態のもとでは核になり得ない欠陥などがあるであろうということも推論できた。最後に、本章で提示した走査型電子顕微鏡写真は日本電子株式会社の御協力を得て撮影したものである。ことに記して感謝の意を表する。

参 考 文 献

- 1) 伊藤一郎, 佐々宏一:日本鉱業会誌, 84巻, 964号(昭43)8月 1059
- 2) E.M. Pugh: J. Appled Phys. 22,487,(1951)
- 3) 桜井武尚:工業火薬協会誌, 19, 181, (昭33)
- 4) Sh.A.Manbetov, V.N.Mosinets: Soviet Mining science 3. 232, (1965)
- 5) J.C.Jager and N.G.W.Cook: Foundamental of Rook Mechanics, Methuen and CO.L. T.D.London, 1969

第 3 章

一自由面爆破におけるき裂および クレータの生成機構についての一考察

3.1 緒言

合理的な爆破設計を行なりためには、爆破にともなり媒質の破壊現象を的確にとらえる必要がある。そこで前章では、もっとも基本的な爆破条件の場合、すなわち、無限媒質内で爆薬を爆轟させた場合に、応力波の伝播にともなって爆源から放射状に生ずるき裂の生成機構について検討した。

しかし,実操業では,無限媒質内で爆破を実施することはなく,少なくと も一自由面を有する媒質内で爆破を行なう。したがって,一自由面爆破の際 の破壊現象を的確にとらえておくことが必要である。

近年,電子計算機の発達によって,破壞現象を逐次破壞現象としてとらえ破壞の進展にともなり材料内の応力状態の変化が解析されるようになってきた。波動の伝播にともなり材料の破壞に関しても,ラグランジュ座標で表示した運動方程式を差分近似を用いて解くという手法を用いて,黨源近傍の破壞の様相や一自由面爆破の場合の破壞劑の大きさを, 破壞を考慮した応力解析結果から推定しようとする研究が行なわれている^{2),3)}。

そこで本章では、この手法を用いて、まず材料の破壊を考慮しない場合について、一自由面爆破の際に媒質内に生ずる応力状態を求め、その結果と、材料内の応力状態が、爆源から媒質内に投射された縦波による応力、すなわち(21)式で表わされる応力と、その縦波が自由面で反射することによって生成する反射縦波と反射横波とによる応力の三つの応力の合成値となるという

4).5)

考え方に基づいて解析された結果 , とを対比して検討し、ついで破壊を考慮した応力解析を行なって.き裂の成長過程を推定し、その推定したき裂の進展状態と実際に実施した小規模の爆破試験によって生成したき裂の様相とを対比するとともに、さらに破断面上に生成するリップルマークの生成機構をシミュレーションの結果を用いて検討した。

3.2 動的応力の解析方法 6)

3.2.1 解析方法の概略

今回採用した動的応力の解析方法は、本章における研究のみならず、第 4章、第5章および第8章に述べる研究においても用いるために、本節でと の方法について述べておく。

この解析方法,G. Muschen と S. Sack によって示されている Tensor Code を少し修正したものである。実操業においては,装薬孔はその直径に比較して長い円筒状であることが多いこと,および電子計算機の容量および計算時間の節約などの理由により,平面ひずみ問題として応力解析を行なった。

直交座標(x, y, z) において、x, y, z 方向の応力をそれぞれ σ_x , σ_y , σ_z とし、x, y, z 方向の偏差応力を S_x , S_y , S_z とすると・

$$P = (\sigma_{x} + \sigma_{y} + \sigma_{z}) / 3$$

$$S_{x} = \sigma_{x} + P$$

$$S_{y} = \sigma_{y} + P$$

$$S_{z} = \sigma_{z} + P$$

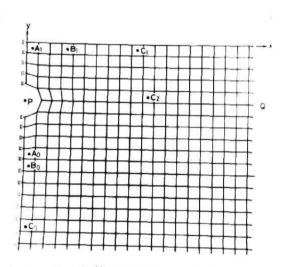
$$(3.1)$$

となる。ただし、Pは圧縮を正とし、 σ_X 、 σ_Y 、 σ_Z は引張りを正とする。 いま、変位加速度のX、Y方向の成分を a_X a_Y とすると、オイラー座 標系における運動方程式はつぎのようになる。

$$ax = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial (P-S_X)}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}$$

$$ay = -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial (P-S_Y)}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}$$

とこに ρ は密度、 τ_{xy} はせん 断応力である。つぎに、たとえ ば第 3.1 図に示すように、ラグ ランジュ座標(k, ℓ)を考える と、(3.2)式はラグランジュ 座標系で表示でき、つぎのよう になる。



第3.1図 数値解析のための模型

$$a_{x} = -\frac{1}{\rho_{J}} \left\{ \frac{\partial (P-S_{x})}{\partial k} \cdot \frac{\partial y}{\partial \ell} - \frac{\partial (P-\sigma_{x})}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial y}{\partial k} \right\} - \frac{1}{\rho_{J}}$$

$$\left\{ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial k} \cdot \frac{\partial x}{\partial \ell} - \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial x}{\partial k} \right\}$$

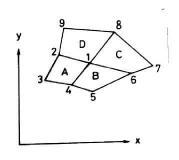
$$a_{y} = -\frac{1}{\rho_{J}} \left\{ \frac{\partial (P-S_{y})}{\partial k} \cdot \frac{\partial x}{\partial \ell} - \frac{\partial (P-S_{y})}{\partial k} \cdot \frac{\partial x}{\partial k} \right\} + \frac{1}{\rho_{J}}$$

$$\left\{ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial k} \cdot \frac{\partial y}{\partial \ell} - \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial y}{\partial k} \right\}$$

$$\left\{ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial k} \cdot \frac{\partial y}{\partial \ell} - \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial y}{\partial k} \right\}$$

とこで、Jは座標変換のヤコピアンである。 第 3.2 図に示したラグランジュ座標で区切られた 四辺形要素 A , B , C , D 内では,応力一定である と考える。また,点1 のx 方向の加速度 ax は, それぞれ線分 81 , 21 , 41 , 61 の中央の点にお ける加速度 ax_{81} , ax_{21} , ax_{41} , ax_{61} から線分 の長さの長短を考慮して求めることができる。

ただし、偏微分項は要素の境界線の中央で定義 されるために、ax*,は



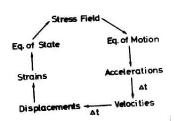
第3.2 図 計算方法の概念図

$$a_{x_{81}} = -\frac{1}{\rho_{J}} \left\{ \frac{\partial (P-S_{x})}{\partial k} \cdot \frac{\partial y}{\partial \ell} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial k} \right\}$$
 (3.4)

となり、 $a_{x_{81}}$ を求めるときは、 $\frac{\partial (P-S_{x})}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial y}{\partial k}$ 、 $\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial \ell} \cdot \frac{\partial x}{\partial k}$ の項はなくたる。

ある時間(t=t。)に媒質内に応力場が存在していると,(33)式などを用いてラグランジュ座標の節点の加速度を,その節点を囲む四つの四辺形要素の応力から求め,△ t なる微小な時間間隔で2回積分することにより, t=t。+△t 時間における各節点の変位を求め,ついでラグランジュ座標で囲まれている要素内のひずみを,それを取り囲んでいる四つの節点の変位より求め,そのひずみに材料の状態方程式を適用して,t=t。+△t時間に対応する材料内の応力状態を算出するという

ように、第33図で示したループを材料内の各点について△tなる時間間隔でまわすことによって、応力波の伝播にともなう動的応力を計算できる。



3.2.2 破壊を計算に導入する方法 爆轟衝撃に起因する応力波の伝播にとも

第 3.3 図 動的応力解析方法説明図

なう材料の破壊の形態としては、降伏またはせん断破壊、および引張破壊が存在し、降伏またはせん断破壊圏は爆源のごく近傍に発生し、その外側に引張破壊圏が発生する⁷⁾。しかし、破壊圏の外周は引張破壊によって規定されるとと、および引張破壊によって生ずるき裂を制御することが本研究の大きな課題の一つであるととを考慮して、本研究においては、引張破壊に注目して応力解析を行ない、降伏、せん断破壊は考慮しなかった。

材料の引張破壊を応力解析に導入する方法としては種々の方法が考えられ るが、今回は、とりあえず四辺形要素内の最大主応力の、が引張強度 Stに達 した瞬間(t=tc)にその要素内の最大主応力の作用する面内の一点にき 裂が生成し,それが有限の速さで進展するとみなすことにした。すなわち, 引張き裂が生成すればその瞬間に,き裂面に作用していた引張応力は零とな るであろう。しかし、き裂先端の進行速度の大きさは有限であるために、四 辺形要素をき裂が横切るためには数 µS の時間が必要となる。さらに, ぉ 婴の影響が四辺形要素全体に現われるためにもわずかの時間が必要であると 考えることができる。そこで、この応力解析では、これらのことを考慮して、 t = tc に最大主応力が作用していた面に生じていた引張の直応力がその後 直線的に減少し, $t=t_c+5~\mu S$ で零となるようにした。すなわち,t= t_c で σ , \geq S_t と なった要素の応力値を、まず σ /= $0.9~\mathsf{S}_\mathsf{t}$ とし、最小 主応力 $\sigma_{\!\!2}$ の値を、改めて $\sigma_{\!\!2}'=\sigma_{\!\!2}+\left\{\,-\,\lambda\left(\,\sigma_{\,\!1}-\,0.9\,\mathrm{S}_{\,\!\mathrm{t}}\right)\,\diagup\left(\,\lambda+\,2\,\mu\right)\,\right\}$ として次の時間サイクルの応力計算を実施し、t=tc+△tでは、 t= t_c で最大主応力が作用していた面に生ずる直応力 σ_{\ln} を、改めて σ_{\ln} = $0.8~S_{t}$ とし、これと直交する直応力 $\sigma_{\rm en}$ を、改めて $\sigma_{\rm en}$ = $\sigma_{\rm en}$ + $\{-\lambda$ ($\sigma_{\rm in}$ -0.88t) $/ (\lambda + 2\mu)$ }とするといりよりに、徐々に σ_{in} の値を低下さ せ、 $\mathsf{t}=\mathsf{t_c}+\mathsf{9}$ \triangle t ではその面に生ずる σ_{in} の値は零となるようにした。そ して $\mathbf{t} \geq \mathbf{t}_{\mathrm{c}} + 10$ Δ \mathbf{t} の時間で σ_{In} の値が正の場合には、改めて $\sigma_{\mathrm{In}} = 0$ とし、 $\sigma_{\rm en}$ 値を改めて $\sigma_{\rm en}$ = $\sigma_{\rm en}$ +{ $-\lambda\,\sigma_{\rm in}$ /(λ +2 μ)}とし、 $\sigma_{\rm in}$ の値が負の場合には,そのままの値にしておくこととした。ここで, σ_1 '

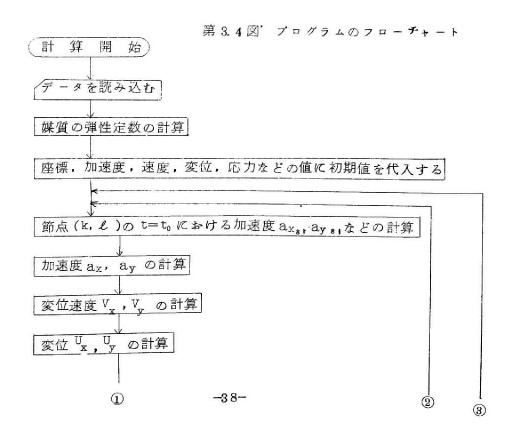
 σ_2 ', σ_1 n', σ_3 n' は補正された応力である。したがって、 $t \ge t_c + 10 \triangle t$ すなわち,破壊を考慮した場合は $\triangle t = 0.5~\mu S$ であるため, $t \ge t_c + 5~\mu S$ の時間では, $t = t_c$ で最大主応力が作用していた面には引張りの直応力は生じないことになる。以上のようにして,破壊現象を計算に導入することによって破壊を考慮した応力計算を行なった。なお、破壊した要素の弾性定数は,破壊しない場合の定数と同じ値を用いた。

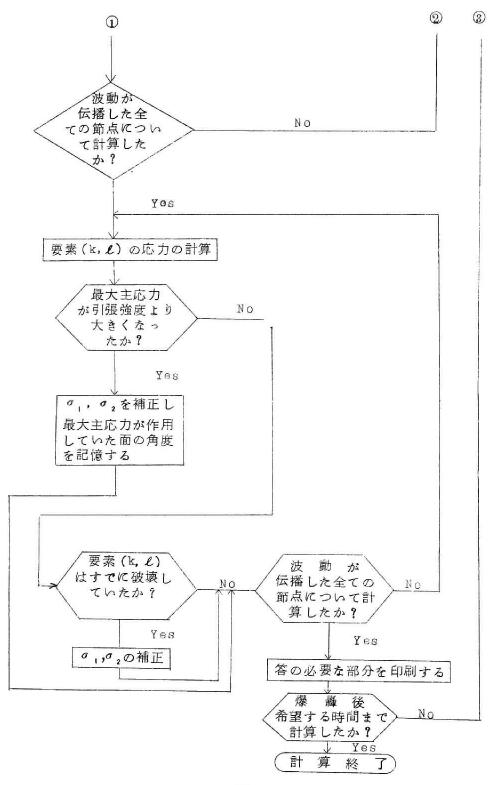
3.2.3. プログラムのフローチャート

この解析方法で媒質内の動的応力状態を解析するために用いた電子計算機は、京都大学大型計算機センターのFACOM280-60である。

FORTRAN 言語による今回のプログラムは、ほぼ500語の命令語からなるものであるが、以下にその概要を簡単に示す。

このプログラムは、第34図にも示したように、まず、時間もに関する一





つの大きなループと,その中に変位加速度,変位速度。変位と応力とを計算 するラグランジュ座標(k, l) に関する二つの小さなループとから成り立 っている。まず、装薬孔内壁に圧力が作用するまでは、媒質が運動もせず、 また媒質内には応力も生じていないとするならば,変位加速度,変位速度, 変位および応力などの値はすべて零とたる。爆薬の爆轟後 t=△t の時間で は,装薬孔とみなした要素に隣接した要素と,これらの要素の境界となる節 点とに変化が生ずる。爆源から離れた他の要素や節点の部分には、波動はま だ到達していないから,計算をしても変位加速度などの値はすべて零となる ので、実際に計算をする節点や要素は、波動が到達した範囲内にある節点や 要素が対象になる。したがって,t = △t の時間に波動が到達している部分 にある節点の変位加速度を求め、つぎに、これらの節点の変位状態から要素 内の応力を求め、最大主応力が媒質の引張強度より大きくなったかどうかを 調べ,もし破壊していなかったなら,得られた結果をそのまま印刷し,つぎ の $t=2. \triangle t$ の時間における変位加速度などを求めるために、時間に関する 大きなループをまわる。したがって、一度時間に関する大きなループをまわ ると,すべての要素の応力の値が求まることになる。そして,爆薬の爆轟後 の時間なが希望する時間になるまでループはまわり続ける。

なお、カードリーダで読み込んだ人間に理解できるFORTRAN 言語を、電子計算機が理解できるような機械語に変換するのに必要な、いわゆるコンパイルタイムは約172秒であり、計算機の中で印刷形式などを指定したりするところの編集に必要な、いわゆるエディットタイムは約63秒である。

また、実際に計算を実行して最終的な解を得るまでの計算時間は、当然解析しようとする模型の大きさと、△tの大きさによって大きく異なるが、時間に関する大きなループを一回まわって一つの要素内の応力を求めるのに必要な計算時間の平均値は、約4.4 ms である。

3.3 破壊を考慮しない場合の応力状態

3.3.1 数値解析に用いた条件

前節で述べた方法を用いて、一自由面爆破の際に媒質内に生ずる応力状 態を解析するために,媒質をラグランジュ座標(k.ℓ)で第31図に示すよ うに分割した。問題の対称性を利用して、媒質の 1/2 の部分のみべついて 平面ひずみ問題として解析を行なった。したがって、応力解析は、円柱状の 長装薬を用いたペンチカット爆破の場合とほぼ同じ条件で行なったことにな る。想定した模型は、アクリル酸樹脂板を1号電気電管を用いて衝撃した場 合に生成するき裂の様相と計算結果とを対比して検討するために、第31図 に示した点Pを中心とする内圧が作用する円柱孔の半径を 0.60cm,点Pか ら自由面までの距離,すなわち、最小抵抗線の長さ(M)を2cm.正方形の部分 の四辺形要素の一辺の長さを0.42cmとした。模型の大きさはよと \times たてが 約40cm×25cmであるので,今回の場合は,爆破によってクレータが牛成 してしまうまでに、自由面以外の端面からの反射波によって媒質内の応力状 態が影響されるととはない。四辺形要素数は約6000,破壊を考慮しない 場合の時間間隔△t は1 μS であって,80回繰り返してt= 80 μS まで 計算するのに必要な計算時間は約770秒である。上記のように,き裂の成 長過程をシミュレートするために,模型の弾性定数はメタアクリル酸樹脂板 の値を用いた。前章でも述べたように,縦波の伝播速度は 3.0 × 1 0 ° m/s. 横波の伝播速度は 1.22×10 m/s, 密度は 1.2 g/cm である。また,引 張強度は 7.5 × 1 0²~1.0×10³ 粒であるので,今回は 9.0 × 10° cm とい う値を採用した。

円柱孔 P の内壁には、(3.5)式で示されるパルス的な変化をする圧力を作用させた。

ただし、 P_o 。は圧力最高値、Nは定数、 α 、 β は圧力波形を定める定数、

tは時間である。なお、Po , α, βの値は爆源から4cmの位置における応力状態が、1号電気雷管を用いて試料を衝撃した場合に発生した粒子の変位速度などの実測結果を(2.1)式に適用して算出した応力状態とほぼ同一となるように定めた。

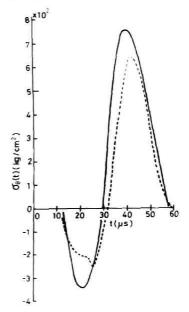
3.3.2 応力解析結果

まず、自由面が存在しないと仮定した場合に、爆源から4cmの距離の点に生ずる接線方向の主応力のもの時間的変化状態を示したのが第3.5図である。第3.5図には、比較のために、厚さ1.8cmのアクリル酸樹脂板に設けられた直径0.7cmの装薬孔内で1号電気雷管を爆盪させた場合に材料内に生ずる応力状態を、材料粒子の変位速度などの実測結果を(2.1)式に適用することにより算出した結果を点線で示しておいた。第3.5図に示したのもの時間的変化状態は、両者ともほぼ同一である。ただし、今回の解析では、媒質

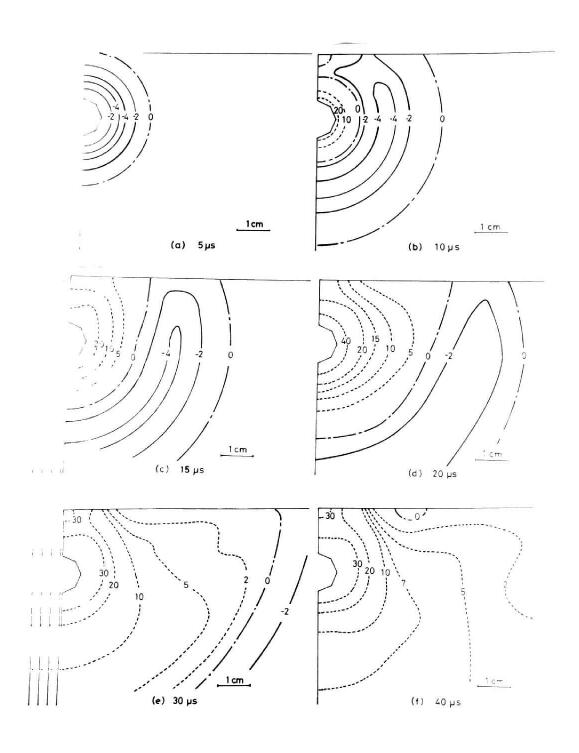
を完全弾性体として解析を行なったために、応力波の伝播にともなり $\sigma_{ heta}$ の最高値の減衰指数が 0.98 であり、

(2.1)式より算出した現実に近い σθの減衰指数が 1.4 2 であって, 両者は少し異なる。

つぎに、このような応力波が爆源から投射された場合に、自由面が存在する媒質内ではどのような応力状態になるかを、等最大主応力線を用いて各時間ごとに示したのが第36図であって、引張応力は点線で、圧縮応力は実線で示してある。第36図(a)に示すように、t=5 μs では、応力波の波頭がちょ



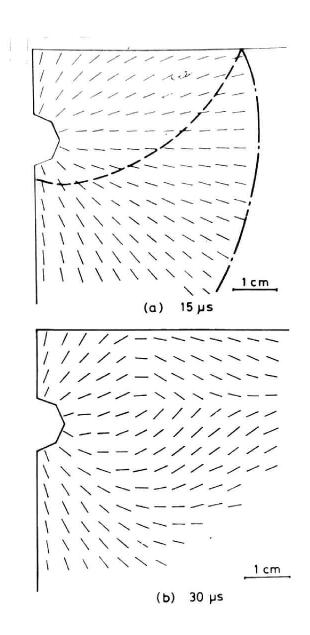
第3.5図 爆源から4cmの点に 生ずるσηの時間的 変化状態



第3.6 図 等最大主応力線図(数字:×10²%)

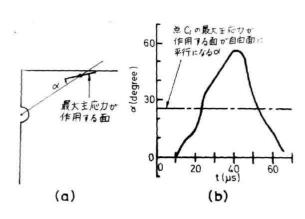
りど自由面に達したところであって、応力分布にはまだ自由面の影響は現わ れておらず、等最大主応力線は同心円状で、かつ波動の影響を受けているす べての部分で圧縮応力である。したがって、との部分のすべての点では、三 つの主応力とも圧縮応力であることになる。 t = 1 0 μs になると,装薬孔 周辺に引張応力が生じ始め、最小抵抗線近傍の応力状態は、自由面からの反 射波によって大きく乱れ始める。その結果,最小抵抗線と自由面との交点近 傍にも,小さな値ではあるが引張応力が生じ始める。t=15με では,装 **薬孔周辺および自由面近傍で応力が引張応力となる範囲が急速に拡がってい** る。いま、引張応力として1×10° 紅あるいは2×10° 紅を示す等最大 主応力線についてみてみると、最小抵抗線から少し離れた点ではこの等最大 主応力線が自由面により近くまでのびている。このことは興味あることであ って、自由面で反射した応力波と装薬孔から投射された応力波との干渉によ って、このような状態が生じたものと考えられる。なお、このような傾向は さきに実施された応力解析結果 8)でも認められている。 $t=20~\mu s$ では, 最小抵抗線と自由面との交点近傍に引張応力の集中がみられ,また,自由面 上では×<2wの広い範囲で引張応力となっているが,w<×<2wでは引 張応力の値は小さく、自由面から応力が解放されやすいことを示している。 したがって、x>wの範囲では、自由面上よりはむしろ自由面から離れた第 3.1 図に示した P Q 線上の近傍で引張応力が大きくなっている。 $t=3.0~\mu s$ では、 $t=20 \mu s$ で認められた傾向がさらに強まっている。 $t=40 \mu s$ となると,自由面上のx;15w近傍で小さな絶対値ではあるが圧縮応力が 現われてくる。これ以後は,波動のピークは爆源から離れて行き,媒質内の 応力の絶対値は小さくなっていく。

第 3.7 図(a), (b)は,それぞれ t=1.5 μ s および t=3.0 μ s における最大主応力が作用する面の方向を示した図であって,もし引張破壊によるき裂が生ずるとすれば,この面に沿って生ずるものと考えることができる。 第 3.7 図(a)において,一点鎖線で示した曲線は,この時点での波頭の位置を



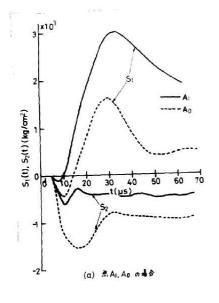
第37図 最大主応力が作用する面の方向

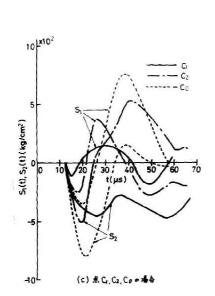
示したものであって、自由面と破線で囲まれた部分は自由面からの反射液の影響を受けている部分、破線と一点鎖線で囲まれた部分は、まだ反射液の影響を受けていない部分である。したがって、破線と一点鎖線で囲まれた部分では、最大主応力の作用する面の方向は装薬孔の半径方向と一致している。第3.7図(b)に示した t = 3.0 μs となると、図に示した部分はすべて反射波の影響を受けており、この時点になれば、最小抵抗線よりかなり離れた自由面近傍の各点での最大主応力の作用する面の方向に特異性がみられるようになる。第3.8 図は、第3.1 図に示した点で、に生ずる最大主応力について、それが作用する面の方向が時間とともにどのように変化するかを示した図である。すなわち、第3.8 図(a)に示したように、一自由面燥破の際に生ずる最大主応力が作用する面が、自由面が存在しないと仮定した場合に最大主応力が作用する面から変化する角度をα度とし、第3.8 図(b)では、このαの値を

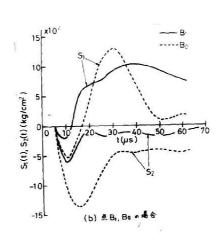


第3.8図 第3.1図の点 C, に生ずる最大主 応力が作用する面の方向の時間的 変化状態

縦軸にとり、時間を横軸にとって図示した。したがって、反射波の影響が現われるまでは $\alpha=0$ の値となるはずであるが、点C、は自由面に一番近い要素の一つであるため、波頭が到達する時間($t \div 12~\mu s$)と同時に反射波







第3.9 図 主応力 S₁, S₂の時間的変化状態

の影響が現われている。波動がこの点に到達すると、同時に α は正の値をとるようになり、 $t=23\mu$ Sで $\alpha=25.4$ °となる。これは、この時間で、最大主応力が作用する面が自由面と平行になることを意味している。これ以後、 α の値はさらに大きくなり、波動がさらに伝播すると、再びこの面は自由面と平行となり、波動が点 C! を通過してしまうころには、 α の値は再び零となる。

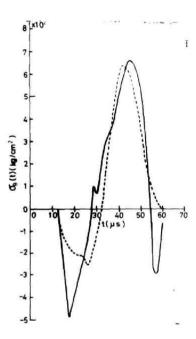
第 3.9 図(a), (b), (c)は,それぞれ自由面の影響を著しく受けると考えられる 第3.1 図に示した点A1. 点 B1および点 C1. C2に おける主応力の時間的変化状 態を示した図であるが、さらにこれらの図には比較のために、自由面の影響が 少ないと考えられる点 Ao, Bo, Co における主応力の時間的変化状態をも示し ておいた。たお,点Aoと点 A , ,点 B。と点 B , ,点 Co と点 C ,, C2 はいずれも爆 源から等距離に選んだ点である。とれらの図において,主として引張応力とし て作用する主応力をSI,主として圧縮応力として作用する主応力をS2とする。 第39図回より,点A」に生ずるS」の最大値は点A。に生ずるS」の最大値の約2 倍となっていることがわかる。また.第 3.9 図(b)より,点 B)に生ずる Siの最大 値は.点 Boに生ずるそれより小さいが.引張応力として作用する時間は点 Biの 方が点 Bo よりも長いことがわかる。第39図(C)より,点 C)に生ずる Siは, 点CMに生ずるSMに比べて早い時間で引張応力となるが、SIの引張応力の最大 値は小さく、またすぐ圧縮応力となり、振動性を帯びてくる。とのことは、 点 Ci近傍では引張破壊が発生しにくい傾向を示すものと考えられる。また、全 体として,自由面近傍の点に生ずる Szの最大値は,自由面から離れた点に生 ずる Soの最大値よりも小さい。以上の結果と第36図および第37図に示し た結果とを合わせ考えれば、自由面近傍において、最小抵抗線の近くでは引 張主応力は大きな値を示すが、 ※> ₩ の範囲では引張主応力は小さくなり. 引張破壊は発生しにくくなるものと思われる。以上に,一自由面爆破の場合 に材料内に発生する動的応力状態を差分近似を用いて解析した結果を示した が、これらの結果はすべて、材料内の動的応力状態は爆源から投射された縦

波に(2.1)式を適用して求まる応力状態と、その縦波が自由面で反射して生成する反射縦波および反射横波による応力状態との合成値であると考えて 9) 求められた応力解析結果とよく一致している。そこで、つぎに材料の破壊を 考慮した応力解析を実施して、き裂の成長状況について検討することにした。

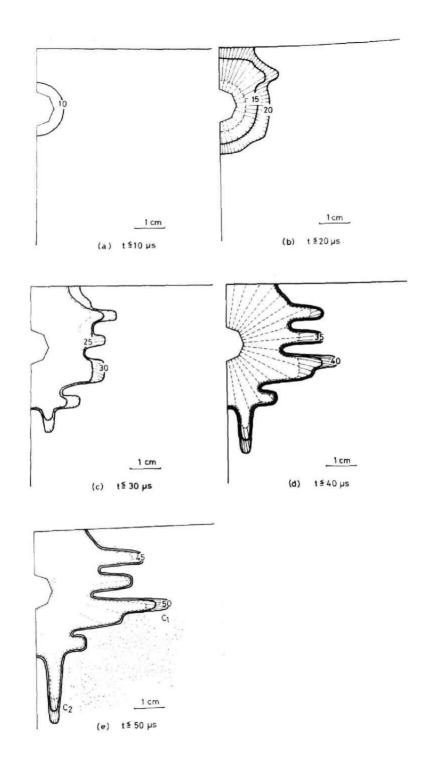
3.4 き裂の成長過程のシミュレーション

まず、第3.10 図に実線で示した曲線は、引張破壊を発生させつつ伝播してきた応力波によって、第3.1 図に $_0$ で示した爆源から4 cm離れた点において接線方向に作用する主応力の時間的な変化状態を示したものであり、比較のために、試料を1 号雷管で衝撃した場合に得られた変位速度などの実測結果を、(2.1)式に適用して求めた結果を点線で示しておいた。このように、

試料を1号雷管で衝撃した場合に得られた変位速度などの実測結果を用いて算出した応力状態と,実測結果を用いずに,上記の解析方法を用いて算出した応力状態とがほぼ一致するということは,今回実施した応力状態のでよって,実際に爆破を行なった場合に材料内に発生する応力状態が的確に解析されているということを示しており,以後に説明する破壊のシミュレーションの結果についる。と考れられる。



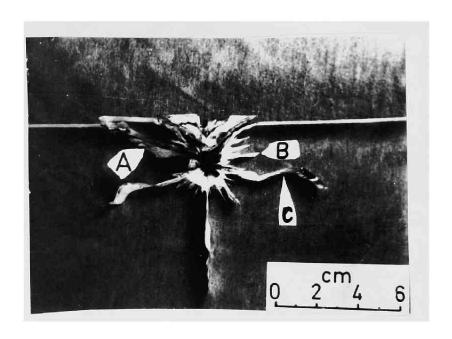
第310図 爆源から4cmの点に生 ずるのもの時間的変化 状態(引張破壊圏を通 過してきた場合)



第311図 き裂の成長過程のシミュレーション

第311図は,装薬孔壁面から成長する半径方向のき裂の先端(要素内の 主応力が仮定した引張強度に達したとき、その要素にき裂の先端が到達した と考える)が、爆鞴後ある時間でどこまで進展するかを示した図であって、 たとえば,第 3.1 1 図(b)には, t=1 5 μs および t=2 0 μs の場合のき 裂の先端の位置が実線で示してあって,破線はધ)におけるt=10#sの場 合のそれである。図より明らかなように、t=10μsでは、爆源から放射 状に生成するき裂の先端は、爆源からの距離 γが1 cmのところまで成長して いる。 t=15μs では、自由面の影響によって自由面に近い方のき裂の進 展は他の方向のそれよりも卓越し、t=20 μs では、自由面方向に進行し たき裂は自由面に達しているが、他の方向へのき裂の先端はまだ $\gamma=1.6~cm$ の位置にしか達していない。 t = 2 5 μs で注目すべき点は、自由面近傍の x<♥の範囲の破壊がほぼ終了してしまっていると同時に、き裂の先端を結 **ぶ曲線がこの時間までは比較的滑らかな曲線であったのが,凹凸のある曲線** になってきたことである。すたわち、 七く25 48 では、自由面近傍を除い たすべての方向でほとんど同じ程度にき裂が成長してきたが、 t=25 μs 頃から,そのまま成長するき裂と,成長の程度が遅くなるき裂とに分れるよ りになる。なお. t = 2 5 μs でのき裂先端は γ ⇌ 2 cmの位置にある。 t = 30μS ではき裂先端を結ぶ曲線の凹凸の傾向はさらに強くなり,これ以後に き裂が成長する方向が暗示されるようになる。そしてt≥30 μs では。 第 3.1 図に示した P Q 方向および最小抵抗線と逆の P C 方向の三つの方向へき 裂は成長するようになるが、第3.11図(Θ)に点点で示した部分にはき裂は生 成しない。今回は,き裂内へのガスの進入を考慮しなかったが,このガス圧 の作用を考慮すれば、PQ方向およびPC方向に生成したき裂はさらに成長 するであろうし,ガスの進入する程度やガスがどのき裂に進入するかにょっ ては、PQ方向に成長したき裂はさらに自由面方向に向って成長する場合も 生じ,大きなクレータを形成することもあるであろう。なお,PC方向に成 長したき裂は、本来ならば対称軸上に生成するべきものと考えられるが、今 回の計算に用いた要素分割が粗いためと、装薬孔が八角形をしているために, すこし対称軸から離れて生成したものと思われる。

第312図は、数値解析を行なった条件とほぼ同じと考えられる条件で、 アクリル酸樹脂板を用いて行なった実験により得られたき裂の様相を示した 写真である。第311図および第312図を比較することによって、数値解



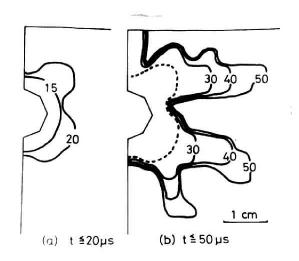
第3.12図 一自由面爆破によって生成したき裂の様相

析によるシミュレーションで推定したき裂の様相と、実験によって生成した き裂の様相とは、第312図にAで示した自由面に達しているき裂を除けば、 かなりよく一致していることがわかる。

いま、装薬孔壁面から幾何学的にはほぼ同じ位置から生成したAで示したき裂とBで示したき裂とを比較してみると、Aで示したき裂のみが、最小抵抗線を対称軸とした場合に、Bで示したき裂とは非対称に大きく成長しているのがわかる。Aで示したき裂は、第311図のシミュレーションの結果と

比べてみても、応力波の伝播だけでは生成しないものと思われる。さらに、第312図に示したき裂の破断面をよくみてみると、Bで示したき裂の破断面にないては、装薬孔壁面から12cmの位置まで黒く着色していて、この位置までガスが進入していることがわかる。一方、Aで示したき裂の破断面にないては、装薬孔壁面から32cmの位置まで黒く着色していて、Bで示したき裂に比較して燥源から非常に離れた位置にまでガスが進入しているのが観察される。また、PQ方向およびPC。方向に大きく成長したき裂の破断面は、いずれも1.5cmの位置まで黒く着色されている。このように、Aで示したき裂は、他のき裂より、より多くのガスがき裂先端まで進入したために自由面にまで達したものと思われる。また逆に、Aで示したき裂の方に多くのガスが流れ込んだため、他のき裂が生成した部分にはガス圧の作用が少なく、応力波の伝播によって生じたき裂のみが顕著となり、シミュレーションの結果とよく一致することになったとも考えられる。いずれにしても、巨視的にみれば、実験の結果とシミュレーションの結果とはかなりよく一致しているということができる。

第312図より明らかなよりに、爆源近くでは放射状に生成したき裂の数は多く、爆源から離れるにしたがってき裂の数は少なくなっていくことがわかる。このことは、第311図に示した解析結果でも明瞭に示されており、き裂の数が少なくなっていく程度は、 r ÷ 2 cm 頃から顕著となっている。爆源から離れるにしたがってき裂の数が少なくなる大きな要因の一つに、破壊をともなって伝播する波動の伝播距離が長くなるにつれて波長が順次長くなることがあげられる。波長が長いと、き裂の数が少なくなる理由については第6章で述べるので、ここでは、圧力波形を変化させて、第31図にC。で示した点に生ずる応力波の波長が、第310図で示した波長の約2倍になるよりにして、破壊を考慮して応力解析を行なった結果を示しておく。その結果を示したのが第313図であるが、第313図(a)より明らかなよりに、圧力の立ち上り時間が遅いため、壁面近傍に生ずる接線方向の主応力の立ち上り

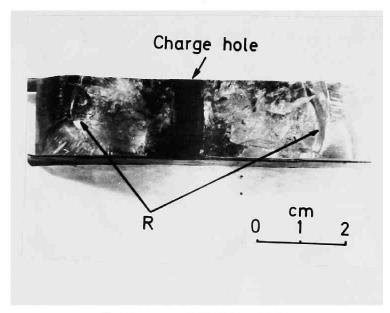


第3.13図 応力波長が実際の場合の2倍の長さと仮定した場合のき裂の シミュレーション

時間も遅くなり、き裂の先端が $\gamma \div 1$ cmまで進行するのは $t=15\mu$ 8 の時でもって、第3:1図にその結果を示した場合に比べて 5μ 8 も遅くなっている。それにもかかわらず、 $t=20\mu$ 6 では、き裂の先端を結ぶ曲線にはすでに凹凸が現われ始めており、き裂先端の進行に方向性が生じている。そして、第3:13図(b)に示した $t \le 50\mu$ 6 では、その方向性がさらに顕著になるととがわかる。このように、圧力の立ち上り時間が遅く、材料内に生ずる応力波の波長が長くなると、燥源近傍でも放射状に生ずるき裂の数は少なくなるととがわかる。

3.5 破断面上に現われるリップルマークについて

第312図に示した破壊の様相の写真より、爆源近傍に生ずる数多くのき 裂は巨視的にみればほぼ直線的に成長しているが、爆源から離れた部分にま で大きく成長した数本のき裂は、曲りながら成長しているのがわかる。さら に、き裂の先端に近くなるほど曲がる回数が多くなるようであるが、大きな 数本のき裂のいずれにしても、爆源から γ ⇒ 2.5 cm程度まではほぼ直線的に 成長しており、 T = 2.5 cmの近傍で第1回目の曲折があるのがわかる。そとで,例として第312図にひで示したき裂をとり出し,その破断面を観察してみると,第314図にRで示したように T = 2.5 cmの近傍に波打ったようを模様がみられる。この模様がリップルマークと呼ばれていることはよく知 10)11) られており,その生成機構についても一,二の考察がすでに発表されている。



第3.14図 破断面 C の写真

ここでは、前節に述べたき裂の成長過程のシミュレーションの結果から、リップルマークの生成機構を検討してみよう。第311図(e)に C_1 , C_2 で示したき裂において、 C_1 では $t \le 30$ μ s の範囲、 C_2 では $t \le 20$ μ s の範囲では、き裂は同じ程度の速度で成長し、その時のき裂の先端は C_1 では T = 2.4 cm、 C_2 では T = 1.6 cm まで達している。ところが、 C_1 では T = 2.4 cm、 C_2 では T = 1.6 cm まで達している。ところが、 C_1 では T = 2.4 cm、T = 2.4 cm T = 2.4 cm T

~3 cmの附近でき裂が成長する速度は速くなっているが、この位置は第313 図にRで示したリップルマークの位置と一致している。このことから、き裂 の先端が成長する速度が急散に大きくなると、その点にリップルマークが生 成するのではないかと思われる。また、成長が停止していたき裂に再び外力 を加え、そのき裂を成長させた時、古いき裂と新しく生成したき裂の境界に リップルマークが生成することは、実験的にも容易に証明できることである。 以上のことから、き裂の先端が成長する速度が停止しているか、またはある 速度で成長している状態から、さらに大きな速度でき裂が成長する状態に移 行するとその点にリップルマークが生成するものと思われる。

3.6 結言

本章においては、一自由面を有する媒質内で爆薬を爆選させた場合に、媒 質内に生ずる応力状態と破壊との関係について検討した。

まず、ラグランジュ座標系で表示した運動方程式を差分近似を用いて解く ことにより、波動による動的応力を解析するという方法を用いて、一自由面 を有するアクリル酸樹脂を爆破した際の応力状態を解析した。その結果、こ こで取り扱ったような波長の長い応力波の場合には、自由面近傍における応力状態の特徴の一つとして、最小抵抗線近傍に生ずる引張応力の値は、自由 面がないと仮定した場合に比べて約2倍の値を示すこと、また、最小抵抗線 から少し離れた×<wの範囲内に生ずる引張応力の値は、自由面がないと仮 定した場合に応べて小さくなるが、引張りとして作用する時間は長くなり、 さらに×>wの範囲では引張応力の値も小さくなるとともに引張りとして作 用する時間も短くなり、振動性を帯びてくること、などを明らかにした。

つぎに、引張破壊を考慮に入れた解析を行なってき裂の成長過程をシミュレートし、実験によって得られたき裂の様相およびクレータの形と比較検討した。その結果、実験によって得られたき裂の様相とクレータの形を数値計 質によりよくシミュレートすることができたが、それによれば、まず爆源近 傍では数多くのき裂が生成し、爆源から離れるにしたがって放射状に生成したき裂の数は減少することが明らかとなった。そして、メタアクリル酸樹脂を用いた一自由面爆破によって生ずる引張破壊は、まず、最小抵抗線近傍に生じ、すべての方向に T ÷ w の範囲内で引張破壊が生成するころには、自由面近傍の x < w の範囲での破壊はすでに終了している。それ以後は、主として P Q 方向および P C 方向にき裂が大きく成長し、ガス圧の作用の仕方、あるいは、どのき裂にガスが進入するかによって、 P Q 方向に伸展したき裂は自由面に達し、大きなクレータを形成する場合も起こりうることになる。

さらに、破断面上に生ずるリップルマークの生成機構についてシミュ**シ**ーションの結果から検討し、リップルマークは、き裂の成長する速度が停止しているか、またはある速度で成長している状態からさらに大きな速度で成長する状態に移行する点において生成するものと思われることを示した。

.

参 考 文 献

- 1) G. Maechen , S.Sack : Methods in Computational Physics vol.3.P.121
- 2) 佐々宏一, 伊藤一郎:材料, 21巻, 221号(昭47)123
- 3) J.T.Cherry : Int.Rock Mech. Min. Sin. Vol. 4, No.1, P. 1
- 4) 伊藤一郎, 佐々宏一:日本鉱業会誌, 79-898(昭38), 261
- 5) K.Sassa, G.E.Larocgue, D.E.Ccates, J.A.Darling: Department of Energy Mines and Resouces, Canada. Research Report.
 R-192, (1966)
- 6) 文献 1)
- 7) 文献 2)
- 8) 伊藤一郎, 佐々宏一:工業火薬協会誌, 29, 4, (1968), 274
- 9) 文献 4),5) および8)
- 10) J.B.Murgatroyd: J.Soc.Glass.Tech: 26(1942)156
- 11) 和田八三久編:力学物性,共立出版社(昭43)324
- 12) 文献 10)

第 4 章

空孔の存在による動的応力の じょう乱に関する数値解析

4.1 緒言

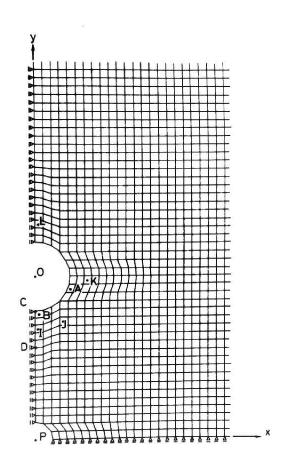
実操業の爆破作業では装薬孔が一つであるということはほとんどなく,多くの装薬孔が設けられる。そしてそれらの装薬孔内の爆薬は瞬発雷管や段発雷管を用いて起爆される。また,瞬発雷管を用いて同時に起爆しようとする場合でも、雷管の点火時間のばらつきのために,同時に起爆されないことも多く,ある装薬孔内の爆薬が爆離した時でも,降接孔内の爆薬はまだ爆暴せず,そのために,先に起爆された爆薬の爆轟にともなう現象に対しては,この隣接孔は空孔としての役割を果たすことになる。したがって,合理的な爆破設計を行なうためには、応力波の伝播にともなって生ずる動的応力が,空孔の存在によってどのように乱されるかを知る必要がある。

そこで本章では,まず第3章32節で述べた動的応力の解析方法を用いて、空孔の存在による動的応力のじょう乱について数値解析を行ない,主として伝播する応力波の波長と空孔の直径との比の値と応力状態の関係について検討した。そして,これとよく似た問題を,伝播する応力波が定常波の場合についてM.T.Jakub と C.C.Mow が理論的に解析しているので,その結果と本研究で得た結果とを比較検討した。また、別に,空孔の断面が正方形の場合についても検討した。最後に本研究の結果を,国鉄湖西線長等山トンネルの掘削の際に生ずる爆破振動がすぐ近くにある疎水トンネルによってどのように変化するかという問題に応用し,比較検討した。

4.2 円柱状空孔の存在する媒質内を応力波が伝播する場合に発生する応力 状態

4.2.1 数値解析に用いた条件

無限の拡がりをもっと考えられる媒質内に存在する円柱状空孔周辺の波動の挙動を、第3章32節で示した方法を用いて解析するためには、無限媒質をラグランジュ座標(ヒ、 ℓ)で区切られた数多くの四辺形要素に分割する必要がある。そこで、第41図に示すような要素分割を用い、問題の対称



第4.1図 動的応力解析に用いた模型

性を利用して無限媒質の $^1/4$ の部分のみについて解析を行なった。第4.1 図において、点 0 を中心とする円が、その周囲の応力状態を解析しようとする空孔 0 であり、下方の点 1 を中心とする円孔内に内圧を作用させて、媒質内に円柱面波を投射した。空孔 0 の直径を 1 の、内圧を作用させる円孔 1 のそれを 1 を 1 とし、それらの中心間距離 1 アを 1 とした。数値計算に用いた数値は 1 も 1 を 1 とした。であって、模型の大きさは、模型の端面からの反射波によって空孔周囲の応力状態が乱されないようにするため、たて×よこを 1 4 1 を 1 を 1 の 1 で 1 と 1 で 1 を 1 の 1 で 1 を 1 の 1 で 1 の 1 の 1 で 1 の $^$

円孔 P の内壁に作用する圧力波形としては, (4.1)式で示される波形を 用いた。

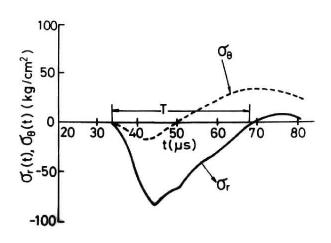
$$P(t) = P_0 N (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$$
 (4.1)

ただし、 P_0 は圧力最高値、Nは定数、 α 、 β は圧力波形を変化させるための定数、tは時間であって、 α 、 β に適当な値を代入することにより、媒質内に生ずる応力波の波長を任意の長さにすることができる。

4.2.2 波長 A と空孔の直径 d の比 A/d が 2 の場合の解析結果

まず、設定した模型内に空孔0が存在しないと仮定した場合について、応力波を投射する円孔内に(4.1)式の α を $1.0 \times 1.0 \times 8$ 。 β を $3.0 \times 1.0 \times$

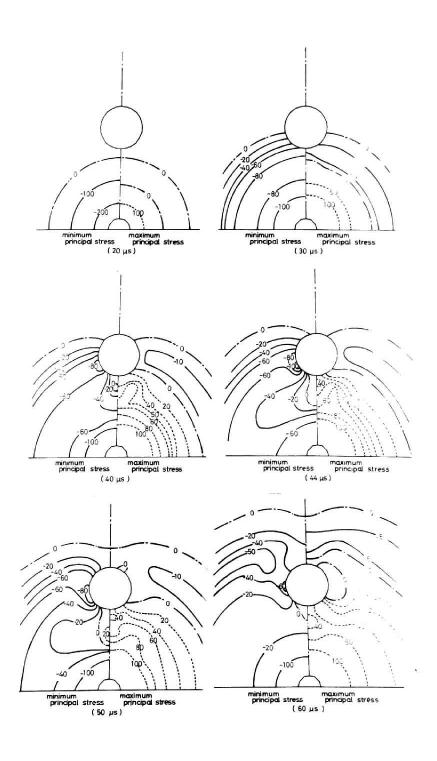
の伝播にともなって,媒質内に空孔が存在するときの空孔位置と同じ位置である点のの近傍に発生する主応力の時間変化状態を、第3章32節で示した動的応力の解析方法を用いて計算した。その結果を示したのが第4.2図である。なお、空孔が存在しない場合の主応力は、内圧の作用する円孔の軸をZ 軸とする円筒座標(γ , θ , Z) の γ , θ , Z方向と一致するから,図には



第42図 空丸がないと仮定した場合に第41図 の点 0 に生ずる応力 στ,σθ の時間的 変化状態

主応力 σ_{γ} と σ_{θ} の時間的変化状態のみを示しておいた。また,応力波の波長 λ としては、応力波がその点に到達してから,その点において半径方向に作用する主応力 σ_{γ} が最高値に達し,再び零になるまでの時間 T に縦波の伝播速度を乗じた値を用いた。

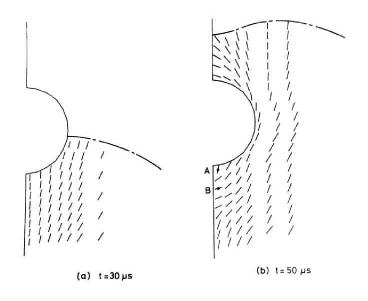
つぎに、主応力が第42図に示したような時間的な変化を示す場所に、円柱状空孔を設けた場合について解析を行なった結果を第43図に示した。第43図は、ある時間ごとの等主応力線図を示したものであって、それぞれの図の左半分が等最小主応力線図を、右半分は等最大主応力線図を表わしてお



第4.3 図 空孔周辺の動的応力の分布状態

り、実線は圧縮応力を、また点線は引張応力を示している。まず、 t=20με では、波頭はまだ空孔の位置まで到達していないが、 t=30με とな ると、波頭は空孔のほぼ中央部附近まで到達している。しかし、応力状態に はまだそれほど大きな乱れは認められない。 t=40 μs となると,空 孔近傍の応力状態はかなり乱れてきて, 空孔壁面に応力集中が発生しはじめ, 空孔壁面近傍の第4.1 図に示した点Aに最小主応力が-100 點という値の 圧縮応力の集中がみられる。しかし、もら一つの主応力である最大主応力の 応力集中は、壁面上ではまだ認められない。しかしながら、50%の等最大 主応力線から明らかなように、対称軸であるOP線上から少し離れた位置に 引張応力の集中が認められる。そしてt=44μεでは、空孔とOPとの交 点の壁面上(第4.1図に示した点B)に引張応力が4.5點という値の応力集 中が生じるようになる。 t=50μs では,波動はちょうど空孔全体を覆い かぶさるようになり、空孔の裏側にもわずかの引張応力が生ずるようにたる。 しかし、この場合も対称軸上から生ずるのではなく、少し軸から離れた位置 にまず応力集中が発生する。 t = 6 0 μs では、波動の後部の部分が空孔を 覆っているだけとなるが、空孔の裏側にはまだ明瞭な引張応力は集中してい ない。

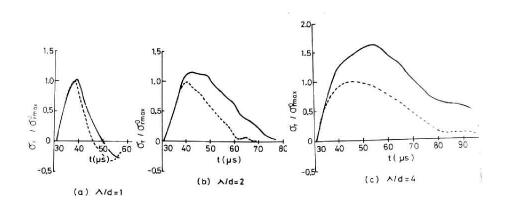
第 4.4 図は $\lambda/d=2$ の場合に空孔周辺に生ずる最大主応力が作用する面の方向を示したものであって、(a) は t=3 0 μ s , (b) は t=5 0 μ s の場合である。 t=3 0 μ s では、上に述べたように、波頭が空孔に達してからあまり間もないので、等主応力線図の場合と同様に、まだ面の方向にも大きな乱れはない。したがって、面の方向はいずれも点 P を中心とした放射状の方向を示している。 t=5 0 μ s では、面の方向は複雑な様相を示すようになり、図(b) に A で示した点では、 t=3 0 μ s のときに生じていた面の方向と大差はないが、 B で示した点では、 3 0 μ s のときに生じていた面の方向と大方のの角度で交わる方向になっている。このように、 $\lambda/d=2$ の場合には、 $\lambda/d=2$ の場合には、 $\lambda/d=2$ の場合にな、 $\lambda/d=2$ の場合にないて反射し、



第4.4図 **λ/**a=2 の場合の最大主応力が作用する 面の方向

引張応力波となって引き返えしてくる。この影響で点Bに生ずる最大主応力の作用する面は、対称軸と交わる方向に生ずる。ただし、t=50 μs のときに点Bに生ずる引張応力の大きさは、第43図からわかるように40短以下の値を示し、空孔壁面近傍の点Aに生ずる引張応力の値よりも小さい。

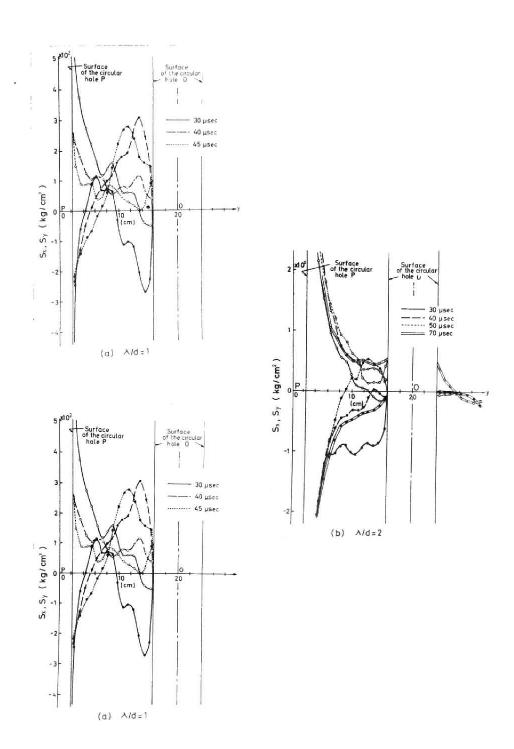
4.2.3 波長 λ と空孔の直径 α との比 λ の値が応力状態におよぼす影響 第4.5 図(α). (α), (α), (α)の実線は,それぞれ λ α = 1, 2, 4 の場合に,第4.1 図に示した点 α において空孔の接線方向に作用する主応力の時間的な変化状態を示したものである。ただし,いずれも空孔が存在しないと仮定した場合に,点 α において主として圧縮として作用する α α の絶対値の最大値を1として表わしてある。なお,比較のために,空孔が存在しないと仮定した場合に点 α において空孔の接線方向に作用する主応力の時間的変化状態を点線の曲線で示してある。図より明らかなように、 α α = 1 では,空孔が存



第45図 第41図における空孔の接線方向に作用する主応力の時間的変化 状態

在しない場合と比較して主応力の大きさはほとんどが変化しないが, λ/d = 2 では,空孔が存在する場合の主応力の値は,存在しない場合のそれの約 1.1 5倍, λ/d = 4 では約 1.6 倍となっており, λ/d の値がこれらの値の附近では,波長が長くなるにしたがって点 Δ 化圧縮応力が集中する程度は大きくなることがわかる。また,この図より、空孔が存在すると応力の大きさだけでなく応力波形にも変化が生じてくること,すなわち, λ/d = 1, 2, 4 のいずれの場合にも, t が約 3 0 \sim 3 5 μ s の約 5 μ s の間は,空孔が存在しないと仮定した場合と空孔が存在する場合とでは波形の変化がみとめられないが,それ以後の時間で, λ/d = 1 の場合は 2 \sim 3 μ s 程度, λ/d = 2 では 1 0 μ s 程度, λ/d = 4 では 1 5 \sim 2 0 μ s 程度応力が作用する時間が長くなることがわかる。

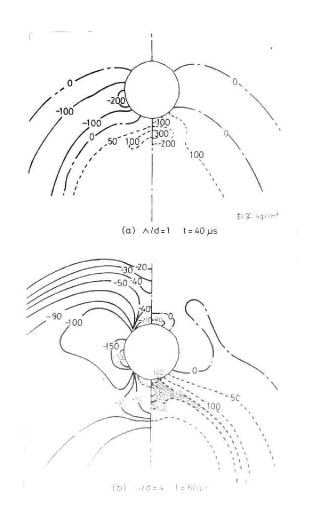
第4.6 図(a), (b), (c) は,それぞれ $\lambda/d=1$, 2, 4 の場合に,点 0 Pを結ぶ線上,すなわち,第4.1 図に示した Y 軸上の各点に生ずる主応力状態を,横軸には各点の Y 座標を,縦軸には主応力の値をとって,各時間ごとに示したものである。黒丸は Y 軸方向に作用する主応力 Sy であり,白丸は Y 軸と直交する X 軸方向に作用する主応力 Sx である。まず,第4.6 図(a),すなわ



第4.6図 OP線上に生ずる応力の分布状態

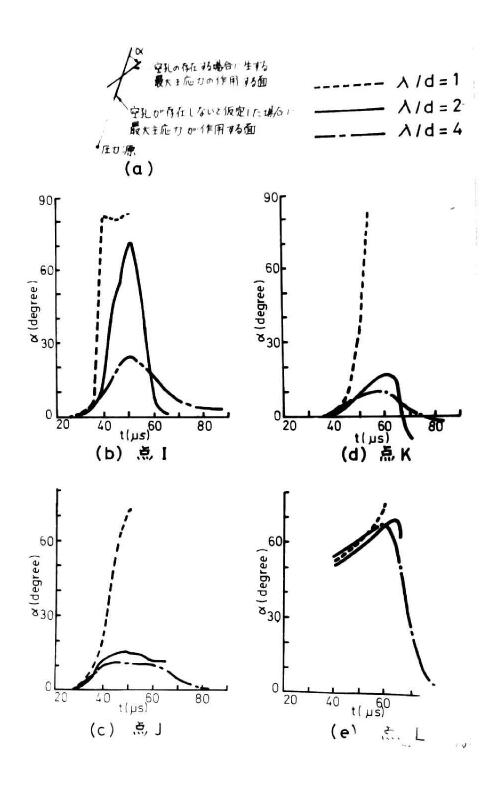
ち. λ/d =1の場合をみてみると,t=30μs では,波頭はすでに空孔 壁面に到達しているが,波動で覆われているほとんど大部分の点に生ずる主 応力 S_y は、圧縮応力を示している。ところが、 $t=40~\mu s$ では、この圧 縮応力波が空孔壁面で引張応力波として反射してくるので、波動で覆われた 部分のSァは引張応力となり.t=45με ではこの反射引張応力波による Syのピークは減衰をともないながら空孔から離れていくことが認められる。 また、 λ/d =1の場合には、空孔壁面上ではX軸方向に作用する主応力Sx による大きな応力集中は生じない。なお.との時間ではまだ空孔の裏側には 波動は到達していない。つぎに,第 4.6 図(b),すなわち, ¼/d = 2 の場合 をみてみる。上記のように, l/a =1 の場合には, Y 軸上を伝播してきた 波動の大部分が空孔壁面で反射し、空孔壁面があたかも平面の自由端である かのような応力状態を示したが、 A/d = 2 の場合には、その傾向は薄れて いる。すなわち,t=50μsでは,反射波による影響により,主応力Sァ に引張応力が生じているが、その値は小さい。また、 1/d = 2 の場合には、 第43図でも示したように,空孔壁面上でX軸方向に応力集中を生じるが, その傾向は //d = 4 の場合に比べて顕著ではない。さらに,第 4.6 図(c), すなわち, 1/d = 4 の場合をみてみる。との場合の特徴は, 主応力Sx に 現 われており、Sy はいずれの時間においても空孔壁面に向って大きた圧縮 の値から零へと滑らかに分布する様相を示しているが、Sxは壁面上で大き な引張応力の集中を示しており、壁面から少し離れた位置で引張応力の極小 値を持つようになる。このように、 $\lambda/d=2\sim3$ 前後で、 $S_{\mathbf{X}}$ および $S_{\mathbf{y}}$ の分布に大きな変化がみとめられる。

つぎに、第47図(a)、(b)はそれぞれ $\lambda/d=1$ 、 $\lambda/d=4$ の場合について、波動がちょうど空孔を覆った頃の応力状態の例を、等主応力線を用いて示したものである。第47図(a)、(b) および第43図の t=44 μ s の図の等最小主応力線図より明らかなように、 λ/d の値が大きくなるにしたがって、空孔壁面から離れた部分にまで圧縮応力が集中する範囲が広がる傾向がみら



第4.7図 空孔周辺の等主応力線図の一例

れる。また、等主応力線図より明らかなように、 A/d の値が大きくなるにしたがって、空孔の裏側にも引張応力が集中し、その範囲も広くなり、静的な応力状態の様相に近くなるものと思われる。さらに、最大主応力が120 %と140%の間の値となる部分は、第47図(b)に斜線で示すような範囲となり、対称軸上では120%より小さな値をとる部分が生ずる。このような傾向は、第3章の一自由面爆破の際の応力状態にもみられた。



第4.8図 主応力方向の時間的変化状態

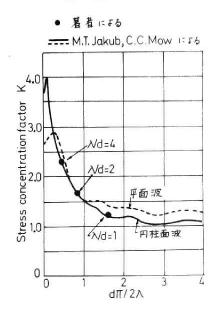
第48図は,第41図に I, J, K, Lで示した点に生ずる最大主応力が作用する面が, $\lambda/d=1$, 2, 4のそれぞれの場合に,時間 t とともにどのように変化するかを示したものである。第48図(0),(c),(d),(e)の縦軸に示した α の値としては,第48図(a)に示したように,空孔が存在しないと仮定した場合に生ずる最大主応力の作用する面から変化した角度の大きさを示す値をとった。

第48図(ロ)より明らかなように,対称軸に近い点Ⅰでは,t<35μsで, $\lambda/d=1$, 2, 4のいずれの値をとる場合であっても, α の値に大差はな く,最大主応力が作用する面はほぼ対称軸に平行な方向を示している。とこ ろが,t>35μεでは,αの値はそれぞれ大きな変化を示すよらになり, $\lambda/d = 1$ の場合は $\alpha = 80$ 度、 $\lambda/d = 2$ の場合は $\alpha = 70$ 度にまで変化 するようになる。したがって、 $\lambda/d=1,2$ の場合、最大主応力が作用する 面は、対称軸と直角に近い角度で交わる方向になることになる。ところが、 第48図(c)より明らかなように、対称軸から少し離れた点」では、αの値が 時間とともに大きく変化するのは, A/d =1 の場合だけであって, A/d = 2,4の場合はあまり変化しない。また, l/d = 2 の場合でも,波長が長 い $\lambda/c=4$ の場合に比べて α の値は大差はない。第4.8 図(b), (c)に示した 結果において, 時間とともにαの値が大きく変化するのは, 第4.6 図からわ かるように、いわゆるホプキンソン効果に基づくものと考えられる。したが って,第48図(b)と(c)との差違は,波長が少し長くなると,対称軸から離れ た点にはホプキンソン効果の影響が急激に減少することを示していることに あると思われる。つぎに,点Κにおけるαの値の時間的変化状態を示した第 4.8 図(d)をみてみると,この場合も, $\lambda/d=1$ の場合は時間とともに α が 急に大きな値を示すようになり、また、 $\lambda/d=2$ の場合はlphaの値が負にな るという(b), (c)では認められなかった現象が認められる。空孔壁面で反射し て生じた反射縦波が点 K に伝播してきたとしても, その縦波の点 K に入射し てくる径路は、線分PKとそれほど大きな角度では交わらないものと思われ

る。したがって、 $\lambda/d=1$ の場合に点 Kにないて $\alpha = 8$ 0度という大きな値をとるのは、圧力源からの応力波が空孔壁面で反射することにより生じた横波の影響によるものと思われる。また、空孔の裏側の点 Lにおける α 0時間的変化を示した第48図(e)をみてみると、 $\lambda/d=1$ 、2、4のいずれの場合も、 α 0変化のしかたには大差はないが、波長が長い場合は、遅い時間で α 0値は零に近くなり、最大主応力が作用する面が、対象軸と交わる方向から次第に軸と平行になるようになる。

4.2.4 理論解との対比

つぎに、第3章32節で述べた近似解法による今回の計算結果と理論解 とを対比して検討したいが、空孔の存在によるバルス状の波動のじょう乱に ついての理論解はみあたらないようである。そこで、今回はとりあえず上記 の解析条件に比較的近い条件の場合について求められているM・T.Jakub と C . C . Mow による理論解と対比することとした。 M . T . Jakubと, C.C.Mow は、線状の応力波源および平面状の応力波源を考え、それらか ら正弦波的に変化する円柱面波および平面波が材料内へ連続的に投射されて いる場合について、その材料内に存在する円孔周辺の応力状態を理論的に解 析している。今回はとりあえず, 円孔の中心軸を通り Y 軸と直交する面と円 孔壁面との交点に発生する接線方向(Y 方向) の応力の大きさ Sh と, 円孔 が存在しないと仮定した場合にその位置に発生するγ方向の応力の大きさ So との比K=Sh/S。の値について比較してみることにした。なお、係数Kを 応力集中係数とよぶことにする。第49図は、円孔の直径4と波長との比に 対応する $d\pi/2$ λ の値を横軸にとり、縦軸に応力集中係数K の値をとって、 今回用いた近似解法による解析結果とM.T.Jakub らが上記の解析条件と 低度同一で定常波の場合について求めた理論解とを対比して示したものであ る。第4.9図より、今回実施した近似解法による計算結果と理論解とはかた りよく一致していることがわかる。

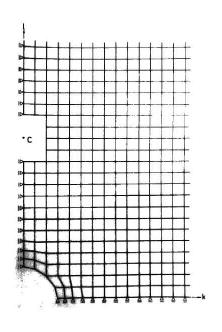


第4.9図 応力集中係数 K と dπ/2 l との関係

- 4.3 断面が正方形の角柱状空孔が存在する媒質を応力波が伝播する場合に 発生する応力状態
 - 4.3.1 数値解析に用いた条件

今回用いた動的応力の解析方法によれば、任意の断面を有する空孔の周囲の動的応力状態が解析できるが、ここでは第4.10図に示すように、断面が正方形の角柱状の空孔が存在する場合の解析について簡単に述べる。空孔の断面が正方形の場合には、定常解さえもみあたらないようである。したがって、断面が正方形の場合には、応力波のじょう乱の傾向を調べ、静的な場合の応力状態と比較できるように波長は長くした。波長が長い場合の応力状態を解析するにはそれだけ長い時間と、大きな模型が必要となる。そこで、円孔の場合に比較して精度は悪くなるが、粗い四角形要素で解析を行なった。空孔の断面の一辺の長さを1.2 cm、媒質内に円柱面波を投射するための円孔

の直径を1.7 cmとした。正方形 の部分の四辺形要素の一辺の長 さは0.3 cmで,要素数は約1500である。 \triangle t は 0.5μ s であっ て,120回繰り返してt=60 μ s まで計算するのに必要な計 算時間は約280秒である。な お,模型の弾性定数は,ポアツ を 3.0×10^4 髪,ポアツ 比た。この場合の縦波の伝播速の 伝播速度は 1.2×10^3 m/s である。円孔内に加えた圧力最高値が 1×10^3

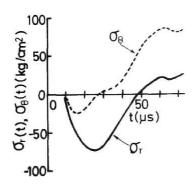


第4.10図 角柱状空孔が存在する 場合の模型

魁、1周期が $2\times10^2~\mu$ s の正弦波の半周期だけを取り出したパルス状の波形である。

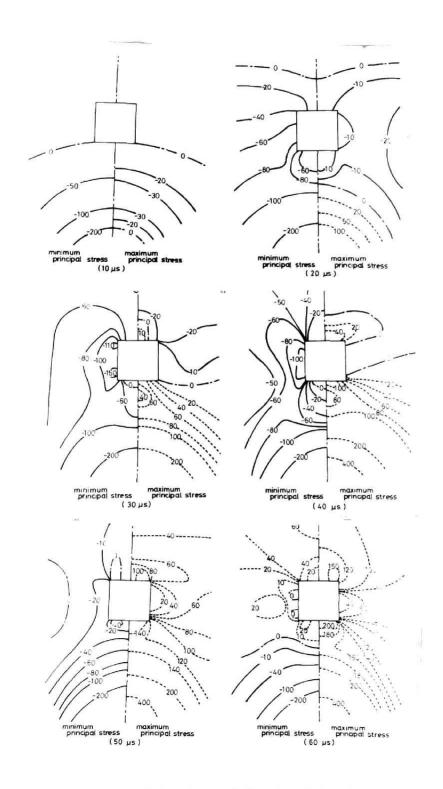
4.3.2 解析結果

まず、設定した模型内に正方形の角柱状空孔が存在しないと仮定した場合について、円柱面波の伝播にともなって媒質内の空孔となるべき点近傍に生ずる主応力の時間的変化状態を計算し、それを示したのが第4.11図である。第4.11図に示すように、この点に生ずる応力波の波長は11cmとなるので、空孔断面の一辺の長さのほぼ10倍の長さをもつ波長の応力波と考えることができる。このような応力波が生ずる点に、断面が正方形の角柱状空孔を設けた場合の解析結果を、第4.3図と同じあらわし方で等主応力線として示したのが第4.12図である。



第4.11図 空孔が存在しないと仮定した場合に第4.10図の点0に生ずる応力 $\sigma \tau$, $\sigma \theta$ の時間的変化状態

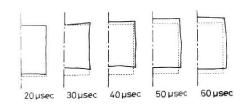
この場合には、 $t=10~\mu s$ で波頭が空孔に到達する。 $t=20~\mu s$ では、応力のじょう乱が現われはじめ、-80~Mの値の等最小主応力線をみてみると、正方形の隅の部分に圧縮応力が集中しはじめるのがわかる。さらに、 $t=30~\mu s$ における等最小主応力線図をみてみると、圧縮応力が大きく集中しているのが認められ、その点は正方形の四つの隅の近傍に分れている。また、等最大主応力線図より、 $t=30~\mu s$ 程度の時間が経つと、正方形の裏側に引張主応力が生じはじめているのがわかる。 $t=40~\mu s$ では、正方形の裏側に引張主応力の最大値は40~M以上の値を示すようになり、引張の生じている範囲も $t=30~\mu s$ のときに比べて大きくなっている。この時刻での主応力線図は、 $G\cdot N\cdot Savin$ が静的な応力場の問題として求めた主応力線図と比較的よく近似している。



第4.12図 角柱状空孔周辺の動的応力の分布状態

さて,等主応力線図にみられるように,圧縮応力は4個所に集中するが,こ のことは円柱空孔の場合にはみられなかった現象である。

第4.13図は、点線で正方形 断面をもつ空孔の最初の位置 および形を示し、実線で応力 波が投射されたのちの各時間 に対応する空孔各点の変位を 100倍に拡大して変位の状 況をわかりやすく図示したも のであるが、正方形断面の空



第4.13図 角柱状空孔壁面の変位

孔周辺の応力状態にみられる上記の特徴は、 t = 3 0 μs 以後の変位の状態 にもよく現われてきている。すなわち、圧縮応力が集中する4点は空孔の内 側に向って変位し、断面の形状は凹凸の多い形となっている。

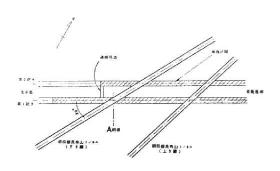
3 4.4 疎水トンネルの周囲における爆破振動

4.4.1 爆破振動の測定方法

本節では、以上に述べてきた解析結果を、地下にある大規模な構造物の近くで実施された爆破による振動測定の解析に応用した例について説明する。なお、本節での説明に用いた爆破振動の測定データは、1968年11月頃から1969年初めにかけて京都大学工学部資源工学教室開発工学研究室と京都市水道局とが行なった測定によって得られたデータの一部であることを記しておく。

国鉄 湖西線長等山トンネル下り客車線の導坑掘さく爆破に起因する爆破振動によって、長等山トンネルと立体交差する疎水トンネルにどのような影響が発生するかを検討するために、第1 疎水トンネルと長等山トンネル(下り客車線)との交差点近傍の岩盤内および第1 疎水トンネルのコンクリートライニングに接している岩盤面において、爆破振動の測定が実施された。第4.

14図は、疎水トンネルと長等山トンネルとの交差部近傍の概念図を示した ものであって、長等山トンネルは疎水トンネルと30度の角度をもって立体 交差し、第1疎水トンネルの頂部と長等山トンネル(下り線)の床面との間 の距離は6.43mである。



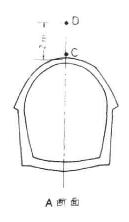
第4.14図 疎水トンネルと長等山トンネル との立体交差部概念図

測定に使用された振動計は、日本測器株式会社製 5 4 1 A 型および 5 4 3 A 型圧電型加速度計である。5 4 1 A 型は 1 成分加速度計あり、5 4 3 A 型は 5 4 1 A 型加速度計を 3 個組み合せ 3 成分型としたものである。

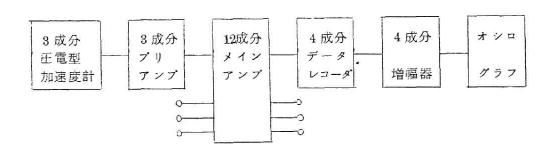
今回使用したデータは、長等山トンネル(下り線)と第1疎水トンネルとの交差部であるA断面内に設置された振動計によって得られたものであって、断面Aにおける振動計取り付け位置は、第415図に示すとおりである。疎水トンネル頂部より上方に向って穿孔されたボーリング孔内で、ライニング頂部より2m上方の位置が第415図に示した点Dであって、ここには541A型加速度計3個をその受感方向が互いに直交するように取りつけられている。また、ライニングの頂部にあたる第415図に示した点Cには、543

A型3成分加速度計が取り付けられている。 いる。なお,疎水トンネルの断面を円 とみなしたときの直径の大きさは約4 mである。

また、点で、Dなどで受信された爆 破振動は、第416図に示すような信 号系統でデータレコーダに記録された。 すなわち、圧電型加速度計はそのイン ピーダンスが高いためにその出力使号 を長い電線で送ることができない。



第4.1 5図 第4.1 4図のA 断面の振動測定 点の位置



第416図 測定方法概念図

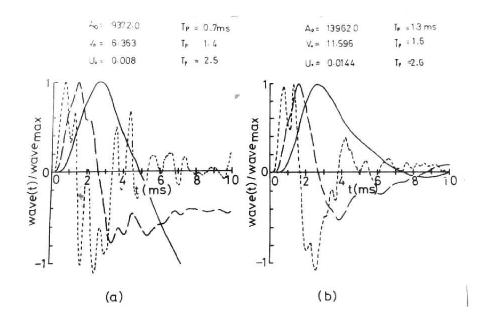
そのため、測定点のすぐ近くに3成分のブリアンブ(インピーダンスコンバータ)を置き、これでインピーダンスを下げたのち、同軸ケーブル(3°2°V)を用いて測定室内に設置された12成分のメインアンブまで信号を伝送し、メインアンブで信号電圧を増幅(100°0倍)したのち、3台の4成分データレコーダを用いて記録された。したがって、データレコーダの磁気テ

-ブに記録された信号は振動測定点の変位加速度に対応する信号が記録されている。

4.4.2 振動測定結果と数値解析結果との対比

この測定で、点で、Dで得られた爆破振動の測定結果と4.2節で示した数値解析結果とを対比して検討するためには、まず、数値解析の模型と幾何学的にもっとも近いと考えられる位置関係となる、長等山トンネル導坑掘削工事の切羽がちょうどA断面内に存在する場合に行なわれた爆破による振動を受信した結果を検討する必要がある。

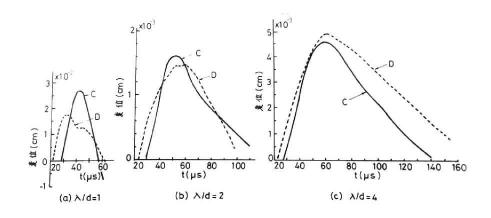
この場合の測定結果の一例を示したのが第417図(a), (b)で, (a)は点Cで 測定された結果であり, (b)は点Dで測定された結果であって、いずれも振動 の鉛直方向の成分を示したものである。また,点線で示した曲線は,測定され た信号である変位拠速度の,破線は変位加速度を数値積分して得られた変位



第4.17図 実験で得られた結果の一例

速度の、実線は変位速度をさらに積分して得られた変位の時間的な変化状態を示したものである。ただし、これらの曲線はいずれも、それぞれの時間的変化状態を示す曲線において最初に現われるピークの値を1として、他の時間における振幅をこの値との比をとって表わされている。第417図に示した記録が得られた場合の実際のピークの大きさとしては、点じに生じた変位加速度のピーク値は9372 cm/S^2 、変位速度のピーク値は6.36cm/S、変位のピーク値は0.00804cmであって、また、点Dに生じた変位加速度のピーク値は13960 cm/S^2 、変位速度のピーク値は1.6cm/S、変位のピーク値は0.0145cm/S0。変位のピーク値は0.0145cm/S0。変位のピーク値は0.0145cm/S0。変位のピーク値は0.0145cm/S0。

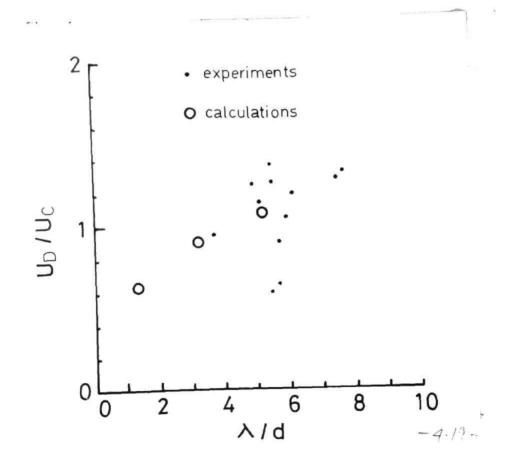
さて、数値解析結果と測定結果とを対比するまえに、陳水トンネルの大き さと測定点 C, Dとの間の幾何学的な位置関係が同一とみなされる、第41 図に示した点 C, Dに生ずる変位の時間的変化状態を第4.18図に示す。



第418図 第41図の点C, Dの変位の時間的変化状態

第418図より明らかなように、波長が短いと、空孔壁面上にある点 C の変位が点 D の変位よりも大きいが、波長が長くなると、点 C の変位の方が点 D の変位よりも小さくなるのがわかる。これは42節でも述べたように、波長が短いと空孔壁面があたかも平面であるかのように作用するからである。

つぎに、空孔または瘀水トンネルの頂部にある点 Cの変位の最大値を U_C とし、空孔から離れた点 D あるいは疎水トンネルから離れた位置にある測点 D の変位の最大値 を U_D として、縦軸に U_D U_D の値をとり、横軸に波長 λ の値を空孔または疎水トンネルの直径 d の値で徐した値をとり、数値解析結果と測定結果とを対比して図示したのが第419図ある。ただし、第417 図に示した変位の時間的変化状態からわかるように、測点 C , D における変



第4.19図 空孔またはトンネルの付近に生ずる変位の最高値の比 U_b / U_c と変位波動の波長との関係

位波動の波長は異なり、データのばらつきにより定まった傾向はみあたらない。したがって、変位波動の波長としては、測定この変位が零から最高値に達して再び零になるまでの時間と、測点Dの変位が零から最高値に達して再び零になるまでの時間との平均値に、疎水トンネル周辺の岩盤を伝わる縦波の伝播速度(約4×10³m/S)を乗じたものを採用した。数値解析結果の場合も同様にして変位波動の波長を決定した。また、数値解析では完全弾性体として解析を行なったために、伝播距離による変位波動の最高値の減衰指数はほぼ2.0程度と思われる。したがって、図には実測の場合のUD/UCの値を補正した値を黒丸でプロットし、数値解析結果は白丸でプロットした。ただし実測結果を補正する際、減衰指数が変化しても、応力集中係数や空孔の存在による変位の増加の割合などは変化しないものと仮定した。

ブロットした実測値は、1968年12月24、25日に行なわれた爆破の際に記録されたものであるから、波動の伝播径路はほぼ等しいと考えられるにもかかわらず、実験結果にはかなりのばらつきがみられる。とくに同じ爆薬を使用しているにもかかわらず、横軸に示した 1/d の値でも大きくばらついていることが注目される。これは、装薬孔近傍の岩盤の状態により、装薬孔周辺の破壊圏の大きさなどが異なり、そのため、波長に大きな変化が生じたものと思われる。このように測定結果にはばらつきがみられるが、測定結果に示された UD/UCと 1/d の関係を示す傾向は、数値解析結果に示されているそれと比較的よく一致しているものということができる。

したがって、疎水トンネルのA断面附近では、第43図や第47図に示したような応力状態が生じていると考えてもよいと思われる。

4.5 結言

本章では、円柱状または断面が正方形の角柱状の空孔が存在している無限 媒質中をバルス状の応力波が伝播する場合に、空孔の周囲に生ずる応力状態 を第3章32節で述べた動的応力の解析方法を用いて検討した。その結果,応力波の波長 ~ と円柱状の空孔の直径 d との比 ~ / d の値が 2~3 の近傍では,応力波の考動に大きな差違が認められ,この値 * b ~ / d の値が小さいときは,波動が円柱状空孔の壁面に達したとき,壁面があたかも平面であるかの * 5 に反射し,空孔周辺はそれに応じた応力状態を示すが,この値 * b ~ / d の値が大きいときは,波動による動的な応力状態が静的な応力状態に近い状態を示すようになることを示した。したがって,一般的に ~ / d の値が 2~3 * b 小さければ,波長は直径に比べて短いと伝え,2~3 * b 大きければ,波長は直径に比べて長いと言えるであろう。

また、M.T. Jakub と C.C. Mow によって理論的に求められた定常解と、著者の行なった数値解析結果とを**対**比して、両者が比較的よく一致する ことを示した。

さらに、国鉄湖西線長等山トンネルの導坑掘進爆破が、疎水トンネルにおよぼす影響を調べた振動測定のデータを利用し、大規模な振動の実測結果からの推論と数値解析結果からの推論とが比較的よく一致することを示し、その結果、爆破振動によって疎水トンネルの周辺に生じている応力状態が第43図および第47図に示した応力状態に近似したものであろうと推定した。

参 考 文 献

- 1) M.T.Jakub, C.C.Mow: J. Apllied Mehanics 1967, 6,359~364
- G.N.Savin: Stress Concentration Around Holes, VED,
 Verlag Berlin ,1956,58
- 3) 伊藤一郎,寺田孚,佐々宏一:国鉄湖西線長等山下り線トンネル掘進 爆破が疎水トンネルにおよぼす影響調査総括報告書

第5章 スムース・ブラステイングの場合の破壊機構 と最適爆破条件の検討

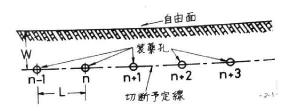
5.1 緒言

第2,3,4章では,合理的な爆破設計を行なりために必要と考えられる二, 三の問題についての基礎的な研究結果について述べてきたが,本章では,さ らにすすんで実際に工事現場で施工されつつある一種の制御爆破工法につい て考察を行なりことにする。

近年,火薬類を用いて岩石などを破壊する場合に,破壊しないで残しておきたい部分をできるだけ損傷せずに,希望する部分のみを破壊したいという要望が高まっており,そのためにスムース・プラスティングと呼ばれる特殊な制御爆破工法が開発されてきている。この工法は,愛何学的には単純な設計によって施工されるが,実際には使用する雷管のばらつきのために岩盤内に生ずる動的な応力状態は複雑となる。したがって,スムース・プラスティングによる破壊の機構も各装薬孔に装てんされた装薬の爆発の状況に応じて少しずつ異なってくるものと考えられる。そこでこの研究では,第3章32節で述べた電子計算機を用いる動的応力の解析方法を用いて,スムース・プラスティングによるき裂の生成状況をシミュレートすることにより,一,二の条件の場合の破壊機構について検討し,さらに,より有効なスムース・プラスティングを実施するための適当な装薬孔間隔について検討した。

5.2 数値解析に用いた条件

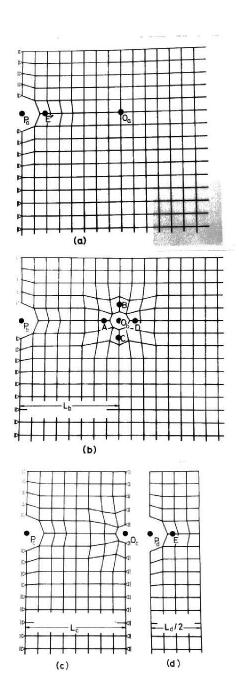
スムース・プラスティングは,第 $5 \cdot 1$ 図に示すように,自由面から \mathbb{W} だけ離れた切断予定線上に等間隔 \mathbb{L} で設けた装薬孔内に爆薬を軽装填し,それらを同時に起爆するのが一般的な方法である。しかしながら,瞬発雷管を使用して起爆したとしても,雷管の点爆時間のばらつきのために,媒体内には



第5.1図 スムース・プラスティングの概略図

種々の応力状態が生ずるものと考えられる。たとえば,第5・1図に示した n番目の装薬が起爆され,応力波が媒体内に投射された時に,わずかな点爆 遅れのために他の装薬孔内の爆薬はまだ起爆されていなければ,最初はn番 目の装薬の爆発により投射された応力波のみによる応力状態が支配的となる。 また,n,n+2,n+4,・・・・などの装薬はまだ起爆していない場合や、 n-1,n,n+1,n+2,・・・などの装薬がすべてまったく同時に 起爆される場合や,その他にも互いに少しの時間だけ,ずれて起爆される場合などが種々考えられる。したがって,スムース・プラスティングを行なった際に媒体内に生ずる動的応力状態を解析するためには,種々の模型を考え る必要がある。

そとで今回は,第 $5 \cdot 2$ 図,(b),(c),(d)に示すようなラグランジュ座標で分割した 3 種類の模型を考えて,動的な応力解析を行なった。なお,第 $5 \cdot 2$ 図、(a)は,比較のために行なった一自由面爆破の際の模型である。第 $5 \cdot 2$ 図(b)は,第 $5 \cdot 1$ 図に示したn番目の装薬だけが爆難し,他の装薬はまだ爆 越していない場合,第 $5 \cdot 2$ 図(c)は, n , n+2 , n+4 ,などの 1 孔 かき の装薬が同時に爆難し,他の装薬はまだ爆離していない場合、第 $5 \cdot 2$ 図(d)は すべての装薬がまったく同時に爆離した場合のそれぞれについて,動的な応力状態を解析するために用いた模型である。想定した模型は,メタアクリル酸樹脂板を 1 号電気雷管を用いて衝撃した場合に生成するき裂の様相と計算結果とを対比して検討するために,W=2 cm,点 P_a , P_b , P_c , P_d を中心



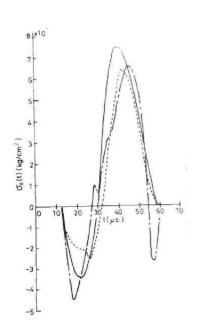
とする内圧が作用する円柱孔の半径 を 0. 6 cm ,点 O _b , O _cを中心とする円 柱孔の半径を 0.35㎝,正方形の部 分の四辺形要素の一辺の長さを, 0.4 2 cmとした。模型の大きさは,(a),(b)の 場合はたて×よこが約40cm×25cmであっ て、四辺形要素数は約6000,応力計算を 行なった時間間隔△tは1μ8であって, 80回繰り返してt=80 usまで計 算するのに必要な計算時間は約770 秒であった。また,いずれの場合も 平面ひずみの問題として解析を行な った。また、き袈の成長過程をシミ ュレートするために,模型の弾性定 数はメタアクリル酸樹脂のそれらの 値を用いた。 すなわち, 縦波の伝播 速度は3.0×10⁸m/s, 横波の伝 播速度は1.2×10 3m/s, 密度は 1.2 8/cm である。また, 引張強度 は約7.5×10²~1.0×10³×Kg /ch であるため,今回は $9.0 imes 10^{2}$ Kg/cm という値を採用して計算を行 なった。

第5・2図 動的応力解析の模型

装 薬 孔 P_a , P_b , P_c , P_d の内壁には、つぎの(5・1)式で示されるパルス状に変化する圧力を作用させた。

$$P(t)=P_0N \cdot (e^{-\alpha t}-e^{-\beta t}) \qquad \qquad \dots \qquad (5 \cdot 1)$$

ただし、 P_0 は圧力最高値、N は定数、 α 、 β は圧力波形を定める定数、 t は時間である。これらの P_0 N 、 α および β の値としては、自由面が存在しないと仮定した場合に、厚さ、1.8 cm のメタアクリル酸樹脂板に設けられた直径 0.7 cm の装薬孔内で 1 号電気雷管 E 爆M させた場合に、爆源から 4 cm 離れたメタアクリル酸樹脂板内の点に生ずる接線方向の主応力 σ θ (t)の値を、材料粒子の変位や変位速度などの実測結果を(2 · 1) 式に適用するととによって算出した結果と、今回の数値計算により求めた結果とがほぼ一致するような値となるように選定した。第5・3 図は、上に述べたそれぞれの



第5・3図 爆源から4cmの点 に生ずる主応力のもの時間 的変化状態

方法で計算した結果を示したものであっ て,点線で示した曲線が,変位速度など の実測結果に弾性理論を適用して得られ たのの時間的変化を示す曲線で,実測 値に対応すると考えられるものである。 また,実線および一点鎖線で示した曲線 が,今回の解析方法を用いた数値計算に より得た結果であって,実線で示した曲 線は破壊を考慮しない場合,一点鎖線で 示した曲線は破壊を考慮した場合に得ら れた結果である。ただし,破壊をともな いながら応力波が伝播する場合には、応 力波はその波形を変化させながら伝播す るので,第5・3図に示したように,爆 源から4cm離れた点,すなわち,今回の 応力解析の対象とした範囲のほぼ中央に 位置する点に生ずる応力の時間的変化状 態を,材料の破壊を考慮した場合およ

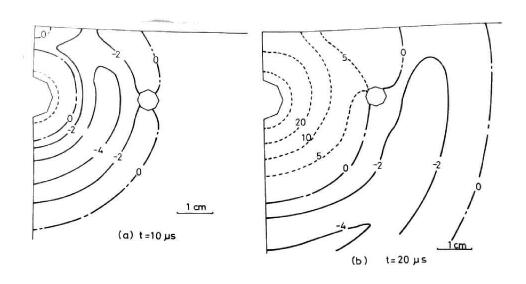
び考慮しない場合のいずれの場合についても,実測値から求めた応力の時間的変化状態と一致するようにするためには,それぞれの場合に作用させる圧力の時間的変化状態を変化させて作用させなければならない。そのために,($5\cdot1$)式に示した α , β ,P。の値は ,破壊を考慮した場合と考慮しなかった場合とではそれぞれ異なった値が採用されている。なお,異なった方法で求めたこれらの応力状態がほぼ一致しているということは,実際に爆破を行なった場合に材料内に発生している応力状態が今回実施した応力解析によって的確に解析されているということを示しており,以後に説明する破壊のシミュレーションの結果の妥当性を裏づけているものと考えられる。

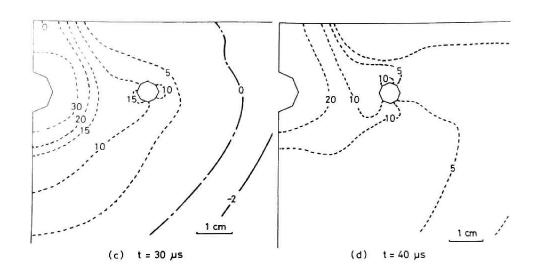
5.3 1孔のみが爆轟した場合の応力状態とき裂のシミュレーション

5.3.1 破壊を考慮しない場合

瞬発雷管の点爆時間のばらつきにより、一つの装薬孔内の爆薬が、他の装薬孔内のものより早く爆酶した場合には、まだ爆薬が起爆されていない装薬孔は空孔とみなされる。そこで、まず、空孔とみなされる装薬孔周辺の応力状態を、破壊を考慮しないで解析してみる。ここで応力解析に用いた模型は、第 $5 \cdot 2$ 図(b)に示した模型であって、とりあえず、装薬孔間隔 L_b が1.6 W の場合について解析を行なった。得られた結果は、第 $5 \cdot 4$ 図に示すとおりであって、実線は圧縮の値をとる等最大主応力線であり、点線は引張の値をとる等最大主応力線である。 $t=10\,\mu s$ で波頭は隣接孔 0_b に達しているが、空孔 0_b の存在による応力状態の乱れはまだ大きくは現われていない。 $t=20\,\mu s$ では、空孔 0_b の周辺の等最大主応力線は複雑な様相を示すようになるが、それでも第 $3 \cdot 6$ 図(d)に示した空孔が存在しない場合の一自由面爆破の際に生ずる応力状態を比較してき裂の生成状況に影響をおよぼすほどの大きな差違は認められない。ところが、

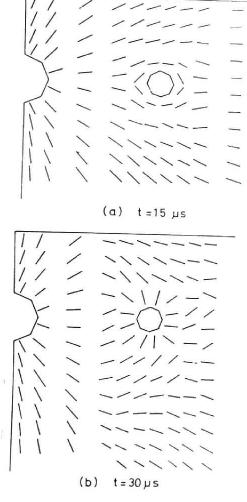
t = 30 μs では,第3・5図に示した応力状態とは大きく異なる。 すなわ





第5.4図 一孔のみが爆轟した場合の等最大主応力線図

ち,第5・2図(D)に示した点 A ,点 D に大きな引張応力が生ずるようになり,これらの点で引張破壊が生じやすいことを示している。なお,これらの点に引張応力が集中することは,第4章で示した空孔の直径に比べて波長が長い場合の応力解析結果からも明らかなことである。 $t=40\,\mu\rm B$ では点 A ,点 D における引張応力の集中はなくなっているが,第5・2図(D)に示した点 B ,点 C で大きな引張応力が生じていて,この時間では,点 B ,点 C にも引張破壊が生ずる可能性があることを示している。第5・5図は

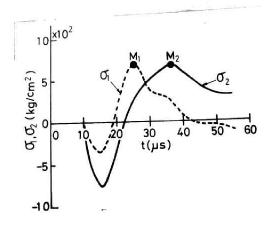


第5.5図 最大主応力が作用する面の方向

最大主応力が作用する方向を示した図であって、引張破壊により材料内にき裂が生ずるとすれば、この方向に生ずるという方向を示している。空孔 $_0$ の周辺に注目してみると、 $_0$ もこれが作用する方向は、空孔周辺のすべての点で、空孔 $_0$ の壁面に沿った方向を示している。ところが、空孔周辺で引張破壊が生ずるであろりという応力の大きさになるころの $_0$ を孔周辺で引張破壊が生ずるであろりという応力の大きさになるころの $_0$ ものなる。したがって、第5・4図および第5・5図から明らかなように、空孔 $_0$ の存在によって生ずる応力集中のために、疾寒孔 $_0$ の壁面から放射状に生ずるき裂とは別個に空孔壁面から新しいき裂が生ずる可能性がある。そして、この新しいき裂が生ずるとすれば切断予定線 $_0$ の上にある点 $_0$ 点 $_0$ では、切断予定線に沿って生成し、 $_0$ と直交する線上にある点 $_0$ にでは、切断予定線と直交する方向に生成することになる。

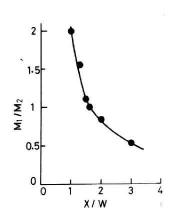
つぎに、空孔として作用していた装薬孔 O_b 内の装薬が爆轟すると、切断予定線方向に生じていたき裂が助長されると同時に、切断予定線と直交する方向に生じていたき裂も助長され、損傷させたくない部分にまでき裂は生成することになる。効果的なスムース・プラスティングを実施するためには、空孔壁面から別個に生ずるき裂のうち、点B, C を結ぶ方向に生ずるであろうき裂をなくし、点A, D において切断予定線上に生ずるであろうき裂を長くすることが好ましい。そのためには、 P_b と O_b との間隔 L_b をどの程度にしなければならないかについて検討しなければならない。

さて、第5・6図は、第5・2図(a)に示した隣接孔がない場合の模型に おいて、装薬孔 P_a に作用する内圧により、切断予定線上で爆源からX=1.6Wの距離にある点 O_a に生ずる主応力の時間的変化状態を示したもので あって、主として接線方向に作用する主応力を σ_1 、半径方向に作用する主 応力を σ_2 とし、それぞれの引張応力の最大値を M_1 、 M_2 として表わして



第5.6図 切断予定線上でx=1.6 wの点 に生ずるσ₁,σ₂ の時間的変化状態

ある。図より明らかなように,との点においては, $M_1 = M_2$ であるが, 爆源からの距離xを横軸にとり,直線 P_a O_a 上の任意の点に生ずる主応 力の M_1/M_2 の比の値を縦軸にとって示した第 $5\cdot7$ 図より明らかなよう に, M_1/M_2 の比の値は爆源からの距離によって変化し,爆源から離れる にしたがって, M_2 の値の割合が大きくなることがわかる。すなわち,x>

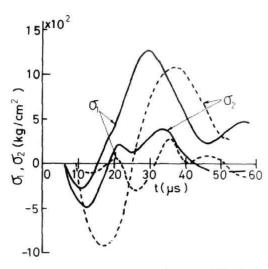


第5.7図 σ_1 の最大値と σ_2 の最大値との比 M_1 / M_2 との爆源からの距離x と の関係

1.6 Wでは M_2 > M_1 となってしまい, σ_1 で 引張破壊をしなくても, σ_2 で引張破壊をしてしまり場合が生じてくる。 切断予定線 P_a O_a 近傍において, σ_1 により引張破壊が生ずる場合はほぼ切断予定線に沿ってき裂が生成するが, σ_2 により引張破壊が生ずる場合は切断予定線と交わる方向にき裂が生成するととになる。したがって,L D > 1.6

wの範囲に装薬孔 ○ _b を設けておくと,スムース・ブラスティングにとっては好ましくないことになる。この観点から装薬孔間隔がこれ以上大き**く**

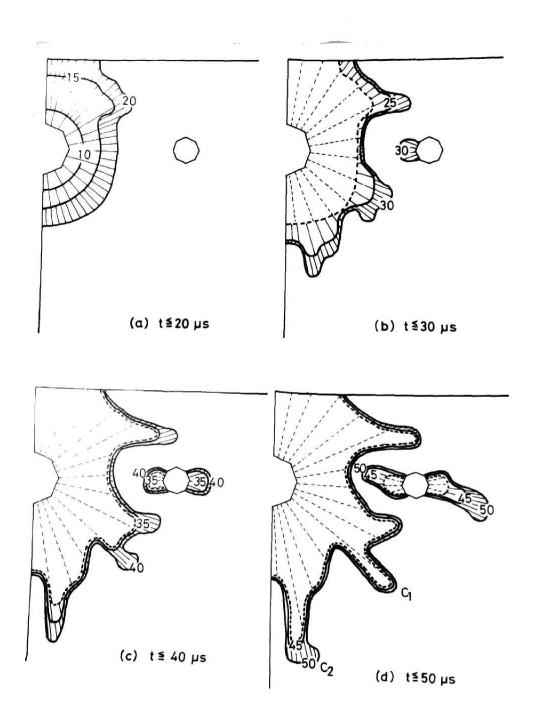
ては好ましくないと思われる。 $\rm L_b=1.6~wo$ 場合の等最大主応力線図を第 $\rm 5.4~W$ に示しておいた。つぎに,第 $\rm 5.8~W$ は,空孔 $\rm O_b$ が存在する場合に,



第5・8図 空孔 ○_b が存在する場合に 空孔近傍の点に生ずる主応力 ^σ₁ σ₀の時間的変化状態

第5.2 図(b)に示した点 A ,点 B に生ずる主応力の時間的変化状態を示したものであって、実線で示した曲線は点 A に生ずる主応力であり、点線で示した曲線は点 B に生ずる主応力である。

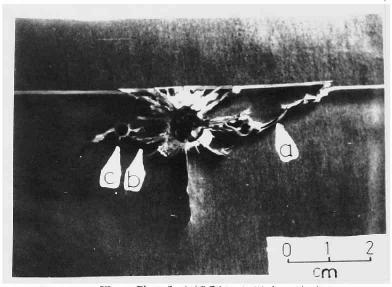
5.3.2 破壊を考慮した場合



第5・9図 き裂の成長過程のシミュレーション

つぎに、破壊を考慮した場合の応力解析結果を第5・9図に示す。第5・9図は装薬孔壁面から成長するき裂の先端かよび空孔のの壁面から別個に成長するき裂の先端が、爆轟後、ある時間経てばどこまで進展しているかを示した図であって、たとえば、第5・9図(D)には t = 25 μs, t = 30μs の場合のき裂の先端の位置が実線で示してある。なか、破線は第5・9図(a)に示した t = 20 μs のときの状態を表わす曲線と同じものである。 t = 25 μs 以下では、燥源から放射状に生成するき裂のみしかみられないが、t = 26 μs ではじめて空孔のの壁面から切断予定線に沿い爆源に向う新しい別個のき裂が生成しはじめる。 t = 35 μs では、爆源とは反対側の空孔壁面からもき裂が生成する。そして空孔壁面から生成した上記の2本のき裂はほぼ切断予定線に沿って時間とともに放長していくが、その途中で、あるいはその生長後においてでも、空孔として作用していた装薬孔の。内の爆薬が爆離すれば、それまでにすでにの。の壁面から生成している2本のき裂はさらに助長されて破断面を形成するので、良好なスムース・プラスティングが実施されることになるであろう。

第5・10図は、上記の応力解析を行なった場合とほぼ同じと考えられ

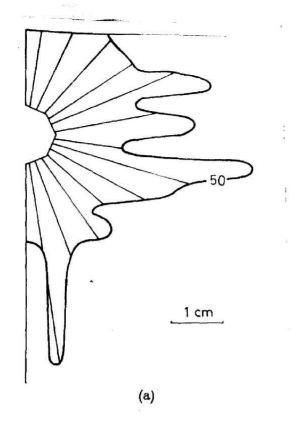


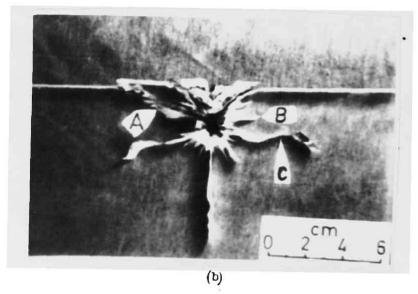
第5・10図 一孔のみが爆轟した場合に生成したき裂の様相

る条件で、メタアクリル酸樹脂板を用いて実験を行なった結果生成したき 翌の様相を示したものである。第5・9図,第5・10図を比較すれば明 らかなように、計算によるシミュレーションの結果と実験によって得られ たき裂の様相とはよく一致していることがわかる。第5・10図の右半分 の部分に生じたき裂のうち、aで示したき裂は空孔を通り自由面にまで到 達していて,シミュレーションの結果とは一致していない。これは,第3 章の一自由面爆破の場合にも述べたように、ガス圧の作用に基づくものと 思われる。すなわち,空孔を通り,自由面にまで到達しているき裂aの面 は、装薬孔壁面から2.5㎝のところまでガスにより黒く着色されているが Dで示したき裂の面は,装薬孔壁面から1.2 cmまでしか黒く着色されてい ない。このように,き裂aにはガスがより先端の方まで進入しており,逆 にこの影響を受けて,左半分の部分にはガス圧の影響が少なくなったもの と思われる。したがって、左半分に対しては動的な要素が強く現われるよ うになり、シミュレーションの結果とよく一致しているものと思われる。 また,第5·10図にCで示したように,空孔壁面から切断予定線と交わ る方向に小さなき裂が生成しているが,これはシミュレーションの結果で は現われていない。その理由は,今回実施した応力解析では,空孔の直径 に比べて四辺形要素が大きいために,応力集中の程度が小さく計算されて いるためと、計算では直接空孔壁面上の応力が算出されていないためによ るものと思われる。

第 $5 \cdot 10$ 図からも, \mathbb{L}_{b} =1.6wでは,空孔壁面から第 $5 \cdot 2$ 図(b)に示した点 \mathbb{B}_{b} , \mathbb{C}_{b} 方向にき裂が生成する危険性があることがわかる。

第5・11図は,比較のために,空孔 0_b がない場合について,すなわち,第3章で述べた一自由面爆破の場合についてのシミュレーションの結果と実験結果とを示したものであって,第5・11図(a)は $t=50~\mu s$ におけるき裂先端の位置を示し,(b)は実験によって得られたき裂の様相を示したものである。第5・9図,第5・10図および第5・11図をそれぞ





第 $5 \cdot 11$ 図 一自由面爆破の際のシミュレーションとき裂の様相

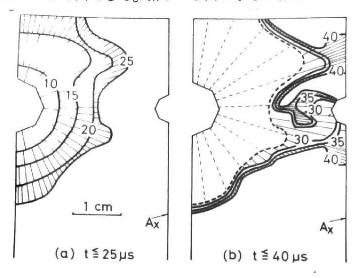
れ対比すると,第5 · 9図(d)に C₁で示したき裂が長く生長するのがスムース・プラスティングを行なった場合の特徴の一つであることが,シミュレーションの結果からも実験結果からも明らかである。

以上に述べたように、き裂の成長過程のシミュレーションの結果と、実験によって得られたき裂の様相とは、スムース・プラスティングの場合も一自由面爆破の場合もよく一致していることがわかる。そこでつぎに、雷管の点爆時間のばらつきのために、雷管を用いて実施することは困難と考えられる完全斉発という現象を、数値解析によってシミュレートし、その結果から、そのような条件で起爆した場合のスムース・プラスティングによる破壊状況について検討してみる。

5.4 n , n+2 1 · · · · の装薬が完全に斉発した場合のシミュレーション 瞬発雷管を用いてすべての装薬を完全に斉発させることはむずかしいことは上にも述べたが、いま、点爆時間のばらつきの最大値をTとし、斉発しようとする装薬孔の数を n_o とすると、隣接孔相互の、点爆時間のばらつきの平均値は T/n_o とみなすことができる。したがって、 n_o が大きくなれば、それだけ隣り合った装薬の点爆時間のばらつきの差は小さくなり完全に斉発する場合に近くなると考えられるので、実操業のように、数多くの装薬孔を設けてスムース・プラスティングを実施する場合には、いくつかの装薬孔から投射される応力波の干渉によって、き裂がどのように生成するかを検討しておかなければならない。

ことでは,n ,n+2 ,n+4 , \cdot ・ の を 薬が まった く 同時 に 爆 轟 し 他 の n-1 ,n+1 , \cdot ・ ・ の 装 薬 は ま だ 爆 轟 し な い 場 合 に , 媒 体 内 に 生 ず る 動 的 を 応 力 状 態 は ど の よ う に な る か を 考 え て み る 。 と の よ う な 場 合 に つ い て の 解 析 は , 第 5 ・ 2 図 (C) に 示 し た 装 薬 孔 P_c の 内壁 に の み 圧 力 を 作 用 さ せ , 装 薬 孔 O_c は 空 孔 と す る と と に よ り 解 析 で き る 。 と の 場 合 も , P_c O_c 間 の 距 離 L_c は L.6 w で あ る と 考 え 破 壊 を 考慮 し て 応 力 解 析 を 行 な っ

た。との解析で得られた、き裂の進展状況のシミュレーションの結果を示したのが第5、12図である。第5・9図に示した結果と比較して、第5



第5・12図 一孔おきに繰越した場合に生成するき 裂の成長過程のシミュレーション

・12図に示されている結果には三つの大きな特徴が認められる。その一つは,切断予定線に沿って,空孔壁面から別個に生ずるき裂が生成する時間は $t=26\,\mu s$ と同じであるが,それらが,さらに成長していく時間は,第5・9図では $t=45\,\mu s$ であったが,第5・12図では $t=35\,\mu s$ と短かくなってかり,この条件の場合の方が切断予定線に沿って空孔壁面から生ずるき裂先端の進行速度が速くなっているということである。第二の特徴は,第5・9図(d)に C_1 , C_2 で示したき裂が第5・12図では生成していないことである。これは,いま装薬孔 P_c を第5・1図にかける n番目の装薬孔とすると,第5・9図に示した C_1 , C_2 のき裂は, n番目の装薬孔を中心として接線方向に生ずる引張応力によって生成したものであるが C_1 , C_2 のき裂を生じさせる原因となった n番目の装薬孔の接線方向とは,n+2番目の装薬孔を中心として考えれば,その半径方向とほぼ一致する

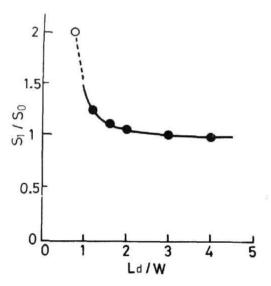
方向である。したがって,第5・12図に解析結果を示した条件の場合には,n+2番目の装薬孔から投射され,しかも主としてその半径方向に圧縮として作用する応力波が干渉することにより,第5・9図に解析結果を示した条件の場合よりもC₁,C₂のき裂を発達させるべき引張応力の値を減少させるためと考えられる。他の一つの特徴は,第5・9図,第5・12図のそれぞれについて,t=40με におけるき裂先端の位置をみれば明らかなように,第5・12図の場合には,空孔として作用する装薬孔O_cの存在する側の対称軸Ax 近傍でかつ切断予定線近くでき裂が多く生成していることである。以上に述べた特徴は,いずれも,2孔以上の装薬孔から投射された応力波の干渉により,生成するき裂が切断予定線附近に集中するような特徴を示していて,スムース・プラスティングにとって好ましいき裂の発生状況を示しているものといえる。

以上に示したき裂のシミュレーションの結果から、空孔として作用していた装薬孔 0。内の爆薬が爆凝しないときでも、一応切断予定線に沿って媒体は切断される可能性があることがわかる。しかし、対称軸 A× 近傍に生じているき裂は非常に細いと考えられるから、実際には装薬孔から成長してきたき裂が互いにつながり合うかどうかは疑問であり、結局は装薬孔 0° 中の爆薬が爆轟することにより切断予定線に沿って媒質が切断されることになるものと思われる。

5.5 すべての装薬が完全に斉発した場合のシミュレーション

すべての装薬孔内の爆薬が同時に爆轟すると、5.4 節に述べたことからもわかるように、応力波の干渉により切断予定線に沿って大きなき裂が生成するものと思われる。しかし、装薬孔間隔が大きければ、別々に爆轟した場合と変らないであろうし、そのような場合には、スムス・プラスティングの良さは現われない。

スムース・プラスティングにおいて良好な結果をうるためには,装薬孔か



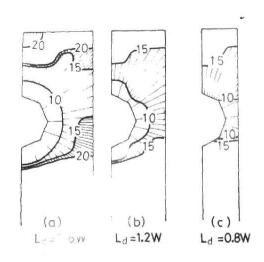
第5・13図 全装薬孔が斉発した場合 に点Dに生ずる応力の集 中の程度と装薬孔間隔 Ld との関係

おいて接線方向に作用する引張応力の最大値 S_1 を第 $5 \cdot 2$ 図(a)に示した点 Eにおいて接線方向に作用する引張応力の最大値 S_0 で除した値 S_1/S_0 を とってある。

第 $5 \cdot 1$ 3 図より明らかなように,全装薬孔が斉発した場合は,装薬孔間隔が大きくなれば点 \mathbb{E} に生ずる引張応力の値は小さくなっていき, \mathbb{E} Ld ≥ 1.6 W では $\mathbb{E}_1/\mathbb{E}_0 \leq 1.1$ となって,斉発の影響は無視されるようになる。したがって, $\mathbb{E}_1/\mathbb{E}_0 \leq 1.1$ となって,斉発の影響は無視されるようになる。したがって, $\mathbb{E}_1/\mathbb{E}_0 \leq 1.6$ W では,装薬孔壁面から生ずるき裂に方向性を持たせることはできないとみなしてもよいであろう。以上は,破壊を考慮に入れない場合の解析結果からの推論であって,破壊をともなう現実の場合には直接適用で

きないが、一応の目安とはなるであろう。

つぎに、引張破壊を考慮に入れた場合の解析結果を示したのが第5.14図であって、、この図の(a)、(b)、(c)はそれぞれ Ld=1.6 W 、1.2 W 、0.8 W の



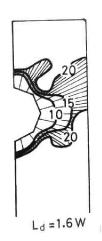
第5・14図 完全に斉発した場合のき裂の成 長過程のシミュレーション

場合に得られたき裂の成長過程のシミュレーション結果を示したものである。図より明らかなように、t=10μsにおいてLd=1.6Wの場合には、まだ装薬孔を中心として放射状に多くのき裂が生成しているが、Ld=1.2W、0.8Wとなるにしたがって、装薬孔周辺に生成するき裂は少なくなっていき、とくにLd=0.8Wの場合は、t=10μsでは切断予定線方向のみしか、き裂は生成していないことがわかる。また、Ld=1.6Wの場合にはt=20μsで破壊が終了しているが、Ld=1.2Wおよび0.8Wの場合には、t=15μsと早い時間で破壊が終了しており、さらにLdの値が小さい方が、損傷を与えたくない部分を破壊する割合は少ないことがわかる。5.4節、5.5節で述べたことは、いずれも理想的に斉発が行なわれた場合であって、爆轟に時間差があって、1孔の周囲に放射状のき裂が生成してから

隣接孔の爆薬が爆轟すると、先に生成していた放射状のき裂はさらに助長され、破壊させたくない部分にもこのき裂は長く進展していき、スムース・プラスティングとしては好ましくないであろう。したがって、より精度のよい電管が望まれる。

5.6 軽装薬の効果について

スムース・ブラスティングの場合は、一般に軽装薬をして実施することはすでに述べたが、軽装薬をする方法としては、第2章でも述べたように、装薬孔の直径よりも小さい直径の爆薬を装塡する、いわゆる、デカップリング装薬をする方法が用いられている。この方法を用いて爆破を行なうと、媒体内に生ずる応力波形が変化するとともに、生ずる応力の大きさも密装塡の場合のそれに比べて小さくなる。ここでは、デカップリング装薬をすることによって生ずる効果のうち、装薬孔内壁に作用する爆轟圧の大きさが減少することによって生ずる効果について検討した。すなわち、第5・15図は、第5・14図(a)に示したシミュレーションを行なった場合の解析条件のうち、装薬孔内壁に作用する爆離圧の大きさのみを1/2



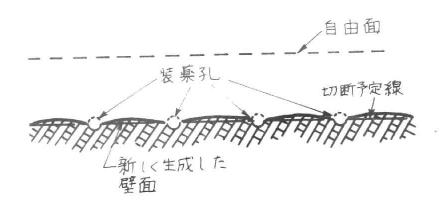
第5・15図 軽装薬を した場合のき裂の成 長過程のシミュレーションの一例

として、応力解析を行なって得られたき裂の成 長過程のシミュレーションの結果を示したもの である。

第5・14図(a)および第5・15図を比較すれば明らかなように、爆轟圧の値を1/2にした場合に生ずるき裂は爆轟圧がその倍の値をとる場合に比べて切断予定線近傍に集中して生成し、より有効なスムース・プラスティングを実施で

きることがわかる。ただし、図より明らかなように、自由面近傍におけるき裂は生成しにくくなり、したがって自由面附近に生ずる破砕片の大きさは大きなものとなる可能性がある。また、破砕片の大きさが大きくなる傾向は、1孔の装薬のみ爆造した場合、すなわち、段発に近い場合よりも、斉発した場合の方が強いことは、第5・9図および第5・14図、第5・15図を比較すれば明らかであり、これらのシミュレーションの結果は、現実に生ずる現象と一致している。

スムース・プラスティングは岩盤を対象にして実施され、しかも、スムース・プラスティングを行なったことにより、新しく生成した壁面より内部の岩盤に生成しているであろうき裂の様相を肉眼で観察することは不可能である。したがってなんらかの方法を用いることによる以外、スムース・プラスティングの効果を知る手段はないが、本章で示したき裂のシミュレーションの結果から、スムース・プラスティングを実施することにより新しく生成した壁面が、第5・16図に示したように、装薬孔と装薬孔との間で少しふくらんだ形状をしていれば、岩盤の内部深くにまで損傷を与えず良好な結果が得られたと考えてよいものと思われる。



第5·16 図 良好なスムース・プラスティングにより新しく生成した壁 面の形状

5.7 結 言

スムース・プラスティングは,切断予定線に沿って数多くの装薬孔を設け,斉発をするのが一般的な方法であるが,電気雷管の点爆時間のばらつきのために,それぞれの装薬孔周辺には種々の異なった応力状態が生ずる,したがって,スムース・プラスティングによる岩盤の破壊の機構も,各爆破孔に装填されている装薬の爆離の仕方によって異なってくる。今回はとりあえず,装薬が3種類の異なった爆離の仕方をした場合について検討を行ない,それぞれの場合に生ずるであろうき裂の成長過程のシミュレーションを行なって,破壊の機構について考察をし,さらにより滑らかな壁面を得るための一,二の条件を提示した。

点爆時間のばらつきの大きい装薬孔間では,まず最初に爆趣した装薬周辺にき裂が生ずるとともに,空孔としての役割りを果す隣接孔壁面から別個に切断予定線に沿ってき裂が生じ,ついで空孔として作用していた装薬孔内の爆薬が爆震することにより,別個に生成していたき裂がさらに助長されて,スムース・ブラスティングとしての良好な結果が得られることになる。また,点爆時間のばらつきが小さい装薬孔間では,応力波が干渉するために,装薬孔壁面から生ずるき裂は,切断予定線に沿って生成し,隣接孔からのき裂とつながり合って破断面を形成し,損傷させたくない部分にはき裂は生成しにくくなる。

良好なスムース・プラスティングを実施するためには,装薬孔間隔が小さい方が望ましく,装薬孔間隔が最小抵抗線の長さの1.6 倍より大きくなれば良い結果は得られない。また,点火方法としては斉発が望ましく,そのためにも,実用上は点爆時間のばらつきの少ない精度のよい電気雷管の使用が望まれる。

さらに,装薬方法について述べ,軽装塡をすれば,より良い結果が得られるが,生ずる破砕片が大きくなる可能性があることを示した。

最後に,シミュレーションの結果から,良好なスムース・ブラスティング

により、新しく生成するであろう壁面の一般的な形状を推論し、装薬 孔間にある岩盤が少しふくれていれば、岩盤の奥には大きなき裂が生 成はしておらず、良好なスムース・プラスティングが行なわれたとい いうることを述べた。

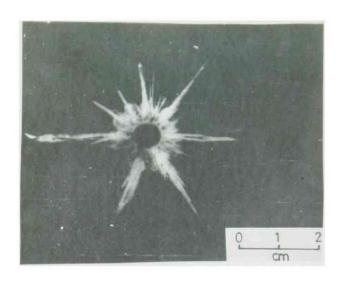
第 6 章

スムース・ブラスティングにおけるガイドホールの効果

6.1 緒 言

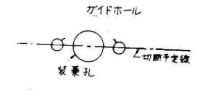
第 5章においては、一般的に施工されているスムース・プラスティングに かける被接機構について考察し、さらに隣接する装築孔が空孔として作用 する場合の効果や、応力波の干渉がき製の生成におよぼす影響について検討 した結果、スムース・プラスティングにおいては切断予定線に沿ってのみ大 きなき器が生成することを明らかにした。

無限媒質内に存在する装薬孔内で爆業を爆舞させた場合には,第6·1図 の写真に示すように,装薬孔瑩面から放射状に生ずる数多くのき裂には方向



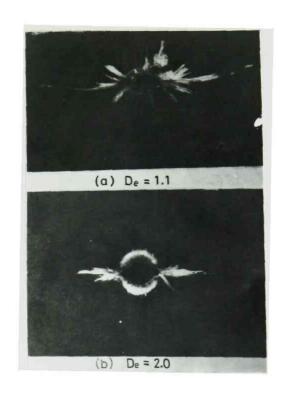
第6・1図 ガイドホールの無い場合に,爆設 によって放射状に生ずるき裂の様 相

性は見当らないことは第2章において、すでに述べたとおりである。ところが、第6・2図に示すように、装薬孔に隣接して空孔(これをガイドホール



という)を穿孔しておくと、第6・3図 の写真のように装薬孔壁面から生ずるき 裂に方向性を持たせることができる。た だし、第6・3図(a)は装薬孔の直径を爆 薬の直径で除した値、すなわち、デカッ

第6・2図 ガイドホールの 説明図



第6・3図 ガイドホールを有する場合に生 じたき裂の様相

プリンク係数が1.1の場合に,(b)は2.0の場合に生じたき裂である。また,

ガイドホールの方向に発生したき裂によってガイドホールの方向以外の方向のき裂の生成が抑制されるように思われる。そとで、本章においては、主としてガイドホールが存在することによりガイドホールの方向以外に発達しようとするき裂を抑制する効果について、生成したき裂の状態が容易に観察できる、メタアクリル酸樹脂板を用いて、検討した結果と、操業現場においてガイドホールを有するスムースプラスティングを実施し、その効果について検討した結果を述べる。

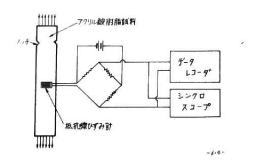
6.2 き裂からの応力解放波

6.2.1 一軸引張試験で材料が破断した際に発生する応力解放波

第6・2図に示すように装薬孔の近傍にガイトホーレが存在すると装薬孔内の爆 薬が爆症すればガイドホールの方向へ向うき裂がまず最初に生成し、このき 裂の生成によってガイドホールの方向以外の方向へのき裂の生成が抑制さ れるという現象に対しては、ガイドホールの方向に生成したき裂から材料 内に投射される応力解放波が大きく寄与しているものと推定することがで きる。すなわち,装薬の爆離により装薬孔壁面の円周方向に生ずる引張応 力によってガイドホールの方向に向らき裂がまず最初に生成すると,き裂 の面においては円周方向の引張応力が零となるから、そのき裂面から円周 方向の引張応力を解放する応力解放波が材料内へ投射され、その近傍の点 に生ずる円周方向の引張応力, すなわち, hoop stress は, き裂の位置 から順次解放されて消失するものと考えられる。したがって、ガイドホー ル近傍の点における引張応力の大きさは,ガイドホールの方向に発生した 引張応力の最高値よりも大きくなり得ないので,装薬孔とガイドホールと を結ぶ線の近傍には別の長いき裂は生成しないものと考えられる。そこで このような推定を確かめるために、応力解放波の性質について検討するこ とにした。

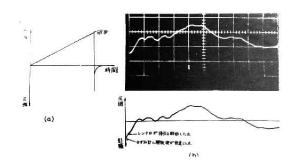
まず、理論的検討が比較的容易な一次元の問題について検討することに

する。第6・4図は実験方法について説明した図であって,メタアクリル酸樹脂棒に抵抗線ひずみ計を接着しておき,これを材料試験機を用いて引



第6・4図 一軸引張試験による応 力解放波に関する実験 の説明図

張り、ノッチの部分で破断させた。との場合には、破断と同時に破断面から応力解放波が試料内へ投射されるので、その波形と伝播速度とを抵抗線ひずみ計を用いて測定した。なお、ひずみ計の出力信号の記録にはデータレコーダとシンクロスコープとを併用した。得られた記録の代表的な一例を示したのが第6・5図である。第6・5図(a)はデータレコーダによる記録でありこれは

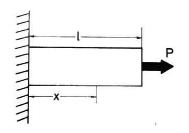


第6 5図 一軸引張りによる応力解放波の 時間的変化状態

荷重を加え始めた時から破断した時までのひずみと時間との関係を示した

ものである。また、(D)はシンクロスコーブによる記録であって、破断した 時以後のひずみと時間との関係、すなわち、応力解放波の波形を掃引を速 くして求めたものである。この実験結果より、メタアクリル酸樹脂棒が破断 した場合に発生する応力解放波によって、材料内に存在する引張応力が解 放されるのに要する時間は、応力解放波の波頭がひずみゲージ接着点に到 達してからほぼ20μB程度であり、その間、引張応力はほぼ直線的に減少 している。そして、その後は圧縮応力、引張応力と振動的に変化しながら 棒内の応力は解放されていく。応力解放波の伝播速度は、当然のことをが ら縦波の伝播速度と一致するということがわかった。

なお,以上に述べた実測の結果は,以下に示す理論的検討の結果から考 えても妥当である。すなわち,いま第6・6図に示すように,一端固定の



弾性棒の他の自由端に作用していた P なる引張力が、 t = 0 の瞬間に急 に解放されたとするど、棒内の任意 の点のひずみは弾性理論によりつぎ のようにして得られる。

第6-6図 応力解放波に関する 理論計算の説明図

すなわち、振動している棒の固定端から×の距離にある点の変位をuとすると

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_L^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

が成立する。ただし、t は時間、CL は棒内での縦波の伝播速度である。 初期条件を

$$t = 0 \oslash B$$
, $u = x \cdot \frac{P}{AE}$

として,(6.1) 式を三角級数を用いて解くと,u は(6.2) 式で与えられる。ただし, Δ は棒の断面積,B はヤンク率である。

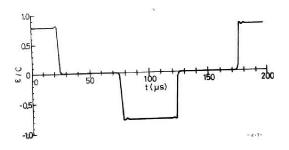
$$u = \frac{8P\ell}{\pi^2 AE} \cdot \sum_{i=1,35,\dots,i^2} \frac{\frac{1-1}{2}}{\sin^2 \frac{1}{2\ell}} \sin \frac{i\pi x}{2\ell} \cdot \cos \frac{i\pi C_L t}{2\ell} \qquad (6.2)$$

したがって、固定端からxの距離にある点に生ずるx方向のひずみ ϵ の時間的変化状態は

$$\varepsilon = \frac{4P}{\pi AE} \cdot \sum_{i=1,2,5,\dots} \frac{(-1)^{\frac{i-1}{2}}}{i} \cos \frac{i\pi x}{2\ell} \cdot \cos \frac{i\pi C_L t}{2\ell} \qquad (6.3)$$

で表わされる。

いま, $\ell=15cm$, X=8cm, $C_L=3000m/s$ という値を用いて,固定端より8cmの位置におけるひずみの時間的変化状態を $(6\cdot 3)$ 式を用いて計算し,その結果を示すと,第 $6\cdot 7$ 図のようになる。第 $6\cdot 7$ 図より,棒状試料内に存在している引張応力は,応力解放波の波頭の到達とともに急



第6・7図 固定端より8cmの点に生ずるひずみの時間的変化状態の理論解

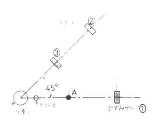
激に減少し、一たん無応力状態となり、その後引張応力と同じ大きさの圧縮応力の状態を経て再び応力が零となるように、棒状試料内では振動的に応力が解放されることがわかる。なお、第6 ° 5 図(b)に示した実測結果で

は、応力解放波が到達してから引張応力が解放されるまでに要する時間が ほぼ20µsとなっており、計算結果とやや異なっているが、この差違には 実際に材料が破断する場合には、き裂が発生してから材料が完全に破断す るまでにある程度の時間を必要とすること、および、材料の粘性などの影響が含まれているものと考えられる。そして計算結果にみられるこのよう な応力解放の様相は、第6・5図に示したメタアクリル酸樹脂棒の破断時 のひずみ測定結果にみられる応力解放の様相とよく一致している。

6.2.2 hoop stress の解放波について

以上に、引張応力状態にある棒状試料が破断した場合に生成する応力解放波の様相について検討した結果を示したが、ガイドホールを有する爆破の場合には、装薬孔とガイドホールを結ぶ方向に生成したき裂からの応力解放波によってガイドホール周辺の点に生成しているhoop stressが解放されるものと考えられるので、この場合に発生する応力解放波によってhoop stressが解放される様相についても検討しておく必要がある。

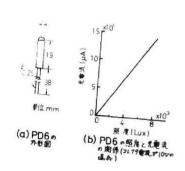
そこで,第6・8図に示すように,厚さ,1.8cmのメタアクリル酸樹脂板に直径0.72cmの装薬孔とそれに接して直径0.27cmのガイドホールを



設け、装薬孔内で1号電気雷管を起爆してガイドホールの方向に長い き裂を生成させた。この際、第6・8図に示す三つの点にあらかじめ接着しておいた抵抗線ひずみゲージにより、ガ

第6・8図 応力解放 波に関する実験方 法の説明図

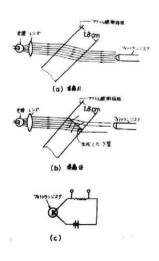
イドホールの方向に生成した,き裂からの応力解放波によってとれらの三 つの点のひずみがどのように変化するかを測定した。なおこの場合には, 雷管の爆轟によってガイドホールの方向にき裂が生成した瞬間,すなわち,き裂から応力解放波が材料内へ投射された瞬間を検出する必要がある。そこで今回は,フォトトランジスタを用いてき 裂が 生成 した瞬間を検出した。用いたフォトトランジスタはNEC製のPD6であって,その外形および照度と光電流に関する特性は .第6 ・9 図に示すとおりである。



第6・9図 フォトトランジスタ PD6の説明図

第6。9図(b)より明らかなように、照度と光電流との関係は直線的であるため、き裂が生成することによる影響も容易に知ることができる。

第6 · 8図に示した点Aに,き裂が生成した瞬間を知りたい場合には,

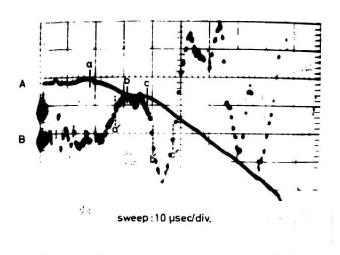


第6°10図 フォトトラン ジスタを用いた実験 装置の概念図

まず第6・10図(a)に示すように、爆融前には、光源からの光をレンズを用いて、平行光線として点Aに投射し、メタアクリル酸樹脂板を通過してきた平行光線をフォトトランジスタで受けると、第6・10図(c)に示した検出回路の出力端子には、き裂が生成していない試料を通過してきた光の強さに対応する電圧が発生する。つぎに雷管が起爆して第6・10図(b)に示すように、点Aにき裂が生成すると、光線の一部は

当然,き裂面で反射し,他の一部は屈折してフォトトランジスタに到達する。したがって,き裂が生成した場合には,フォトトランジスタへ入射する光の強さは,き裂が生成していない場合に比して弱くなり,それに対応して,フォトトランジスタを用いた検出回路の出力電圧が変化する。したがって,この検出回路の出力電圧の変化を記録すれば,き裂が生成した瞬間を検出することができる。

第6。11図は,第6。8図に示したひずみゲージ①による,ひずみ記録とフォトトランジスタによる記録の一例であって,掃引Aはフォトトランジスタの,Bはひずみゲージ①の記録である。フォトトランジスタによる記録においては,入射する光の強さが弱くなるにつれてマイナス側,すなわち,下方に光点が移動し,ひずみゲージにおいては,プラス側,すなわち,上方が引張ひずみを示している。なお,これらの掃引の起動は雷管が起爆した瞬間と一致しており,掃引A上に示された点a,b,cは,掃引B上に示したa、b、cと時間的に対応している。



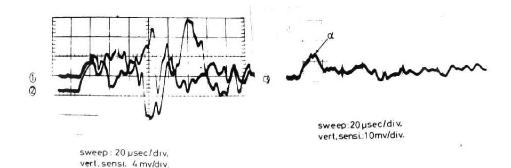
第 6 •11 図 フォトトランジスタ とその方向のひずみの記録

まず、掃引Aをみてみると、点aで示されている時間で初めて曲線は下降

し始めている。

これは、光源からの平行光線が遮断され始めたことを示しているのであるから、き裂が生成し始めたことを意味しているものと考えられる。また、点り、cの間では掃引Aは横軸にほぼ平行である。このことは光の強さが変化していないことを示しており、点り、cの間に対応する時間では、き裂は発達していないものと考えられる。なお、この時間に対応するひずみ記録をみると、点り、cの間では、ひずみも主として圧縮ひずみであってこのことを裏付けている。また、点cに対する時間で再び掃引Aが下降し始めていることは、点cの時間に生じている引張ひずみの大きさが、き裂を再び発達し始めるのに十分な大きさになったことを示しているのではないかと考えられる。また点aとっとの時間におけるひずみの大きさを比べると、点cの時間におけるひずみの値の方が小さい。このことは、一度き裂が生成すると、そのき裂を伸ばすためには、より小さなひずみを与えるだけでよいことを示している。

第6・8図に示した、ひずみゲージ②の爆源からの距離は、ひずみゲージ①のそれと同じ距離であって、ひずみゲージ③はガイドホールの方向に生成するき裂からの応力解放皮によってhoop stress が解放される可能性のある点に接着してある。これらのひずみゲージによるひずみ測定結果の一例を示したのが、第6・12図であって、掃引①、②、③はそれぞれひずみゲージ①、②、③が接着されている点のひずみの時間的変化状態を示すものである。ひずみゲージ②の記録では、ひずみが最後まで振動しながら大きな値を示しているにもかかわらず、これよりも爆源に近い点に接着してあるひずみゲージ③の記録では、ガイドホールの方向に生成したき裂からの応力解放波が到達(ひずみ 記録上で点αで示した時間)することによって、この点のひずみが急激に消失する様子を明瞭に認めることができる。この場合には、応力解放波が到達してから、ひずみが零になるまでの時間は、ほぼ10μ8という値であった。なお、第6・12図に示し



第6・12図 hoop stress の解放波に関するひずみの時間的変化状態

たひずみゲージ③の記録において、点 α が現われるまでの掃引開始からの時間 t_3 は、第 $6 \cdot 1$ 1 図の掃引 Aに示した点 α が現われるまでの掃引開始からの時間、いいかえれば、雷管が爆轟 してから き裂が生成するまでの時間 t_1 と、き裂からの応力解放波がひずみゲージ③の位置に達するまでの伝播時間 t_2 との和にほぼ一致しており $(t_3 \cong t_1 + t_2)$ 、このことからも、ひずみゲージ③の記録に示した点 α がガイドホールの方向に生成したき裂からの応力解放波がひずみゲージ③の位置に到達した瞬間であると理解することができる。

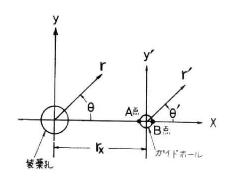
6.3 ガイドホールによるき裂の抑制効果

6.3.1 ガイドホール近傍の応力計算の一方法 2)

空孔またはガイドホールの周辺に生ずる動的な応力状態については,すでに第4章において詳細に述べた。しかし,第4章などで用いた方法で応力計算を行なうと,すべての点に生ずる応力状態が求められると同時に,また,不必要な点の応力状態も計算しなくてはならず,計算時間が莫大な

ものとなるが、伊藤 ,佐々らの方法を用いると短い計算時間で ,動的な応力状態を求めることができる。ただし , この計算方法が適用できるのは , 応力波の 波長がガイドホールの直径に比べて長い場合で , しかも応力を求める点が装薬孔の中心とガイドホールの中心とを結ぶ線上にある場合に限られる。さて第4章で述べたように , 応力波の波長がガイドホールの直径の数倍以上であれば , 一般にその応力波の波長はガイドホールの直径に比べて長いということができる。したがって , 第6・3 図で示したような小規模な実験の場合には , 測定されたひずみ波の波長が 15 cm程度で , この値は , ガイドホールの直径の50倍程度の長さであり , ガイドホールの直径に比べて十分長いと考えられるので , 伊藤 , 佐々らによって示されている方法で , 応力計算ができるものと思われる。

以下に,この方法による応力計算法を簡単に示す。第 $6\cdot 13$ 図に示すように,装薬孔の中心を原点とした座標 (r,θ,Z) と,ガイドホールの中心を原点とした座標 (r',θ',Z') を考える。



第6・13図 ガイドホールに関する説 明図

ガイドホールの存在しない場合,装薬孔から投射される応力波によって $\gamma=\gamma_x$ の点に生ずる応力 $\sigma_{\gamma_x}(\tau_x)$, $\sigma_{\theta_x}(\tau_x)$, $\sigma_{z_x}(\tau_x)$, (ただし $\tau_x=t-\gamma_x/c_{L}$) は(2・1)式により求められる。との場合,応力波の波長

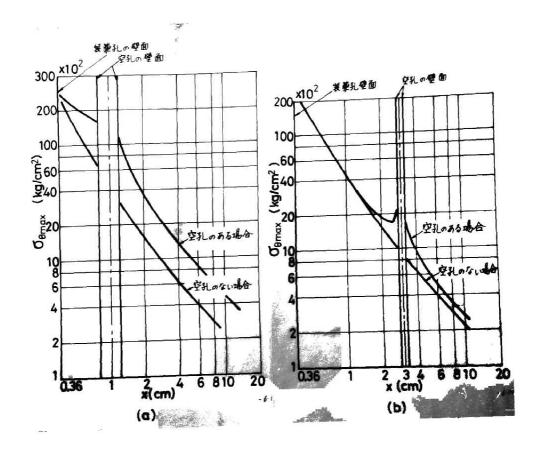
が長い場合は,第6-13図に示した点A,Bに発生する接線方向の応力 $\sigma_{ heta^{-1}A\cdot B}(au_{f x})$ は

 $\sigma_{\theta^{'}A,B}(\tau_{x})=-\sigma_{\gamma x}(\tau_{x})+3\sigma_{\theta x}(\tau_{x})$ ・・・・ (6・1) で求めることができ,その作用方向は $\sigma_{\theta x}(\tau_{x})$ の作用方向と一致する。 (6・1) 式を

$$\sigma_{\theta_{A},B}^{\prime} = \sigma_{\theta_{X}}(\tau_{X}) + \{ 2 \sigma_{\theta_{X}}(\tau_{X}) - \sigma_{\gamma_{X}}(\tau_{X}) \}$$
 · · · (6 · 2)

のように変形すると、(6・2)式の第2項は、ガイドホールが存在する ことにより、点A、Bに新たに発生した応力とみなされる。したがって、 この第2項に示される応力が、時間とともにその最高値を減衰させながら 伝播していき、X軸上の任意の点の応力状態は、爆源から直接その点に入 射する応力波によって生ずる応力と、点A、Bを応力源とする上記の応力 波による応力とが 重畳して決定されるととになる。

6.3.2 応力解析結果



第6・14図 X 軸上に生ずる σ_{θ} の最大値がガイドホールの存在によってどのように増加するかを示した図

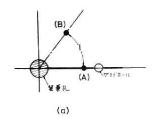
ガイドホールの壁面から新しくき裂が生成する可能性があることを示している。さらに、以上に述べたような伊藤、佐々らの提示した方法を用いて解析して得られたガイドホールの存在による応力値の増加の傾向は、すでに第4章および第5章において説明した、第3章3.2節に述べた動的応力の解析法により求めたそれらの傾向とよく一致している。

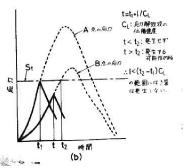
6.3.3 ガイドホールによるき裂の抑制効果

以上に示した応力解放波に関する実験結果および応力解析結果を総合す

ると,ガイドホールによるき裂の抑制効果はつぎのように説明することが できる。

いま,材料が破壊しないと考えた場合に,装薬の爆轟によって第6・15 図^(a)に示す点Bに発生する円周方向の応力が,第6・15図(b)に点線で示したような状態であるとすると,ガイドホールの方向でしかも爆源からの距離が点Bと同じ位置にある点Aの応力は;ガイドホールの存在によって点Bの応力よりもその応力最大値が大きくなる。そとで,材料の動的引張強さをSt とし,材料内の引張応力がSt に達した時にその材料は破断す



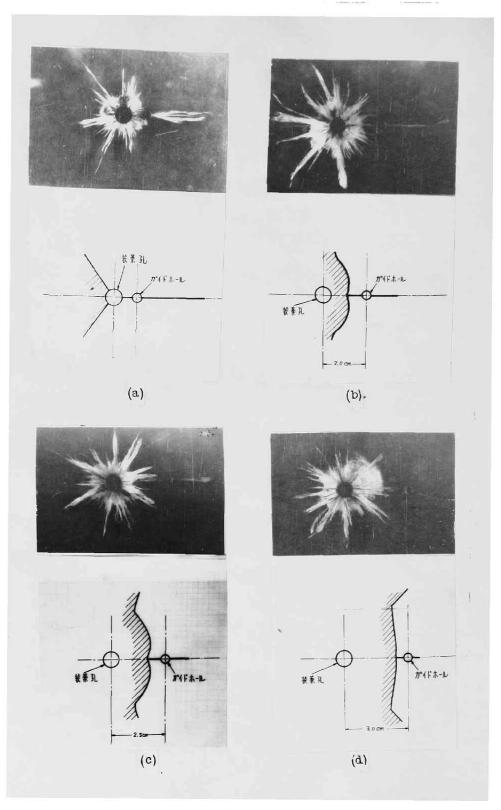


第6・15図 ガイドホールによる さ裂の抑制効果に関する 説明図

ると考えると、点Aには、点Aに応力 波が到達してからす、時間後にき裂が 生成することになる。しかし、その瞬 間には点Bの応力はまだStに達して いないので、点Bには、き裂は生成し ない。さて、点Aにき裂が発生すると 点Aの応力は実線で示したように急激 に減少し、応力解放波が材料内へ投射 される。

点 A と点 B との間の距離を $^{\ell}$ とすると,点 A に発生したき裂からの応力解放波が点 B に達するのは,点 B に応力波の波頭が到達してから t 1+ $^{\ell}$ 1、時間後である。したがって,点 B の応力が S 1 に達する t 2 時間後までに応力解放波が点 B に達すれば,応力解放波によって,点 B の応力は図に実線で示したように減少し, S 1 に達しないからき裂は生成しないものと考

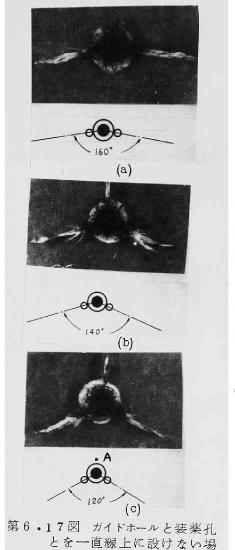
えられる。しかし、 ℓ がある程度長くなり、 $t_1+\ell$ /CL が t_2 より長くな ると、応力解放波が点Bに達するまでに点Bの応力がSt に選するから 点Bにはき裂が発生する可能性が生ずる。したがって、点Aからの距離が ℓ < (t_2-t_1) CLを満足する範囲内にはき製が生成する可能性はなく, ℓ≧(t₂-t₁)Сьの範囲にはき裂が発生する可能性があることになる。 とのような考えのもとに、メタアクリル酸樹脂板に設けた直径 0.72 cm の孔内で1号電気雷管を起爆した場合について,装薬孔とガイドホールと の間隔を変化させた種々の場合について,き裂の発生が可能な範囲を計算 により求めるとともに、他方、これらの計算を行なった条件とまったく同 一の爆破条件で1号電気雷管を用いてメタアクリル酸樹脂板を衝撃し,発 生したき裂の様相と計算結果とを対比した。その結果の数例を示したのが 第6.16図(a),(b),(c),(d), である。なお,これらの図においては,ガ イドホールの方向に示した太い実線の位置なよび斜線をほどとした部分が 計算により求めたき裂が生成する可能性のある範囲を示すものである。 まず ,第6 ・16図(a)は, 第6・14図(a)に応力解析結果を示した場合と 同じように、装薬孔とガイドホールとの間隔が1.0㎝の場合に得られた結 果を示したものであるが この図より解析結果から推定したき裂の生成す る範囲と実際の爆破試験によって生成したき裂の範囲とはかなりよく一致 していることがわかる。(D)は孔間隔が2.0 cmの場合,(c)はそれが2.5 cmの 場合 ,(d)はそれが30㎝の場合であって,いずれも計算結果とき袈の様相 とはかなりよく一致しており、さらにこれらの図より孔間隔が長くなるに したがって ,き裂の**抑**制効果は順次減少していくことがわかる。(a)の条件 の場合にはガイドホールの影響が現われるのはガイドホールの近傍に限ら れており、第6.14図の応力解析結果からも、このことは推定される。 以上に示したように、応力解析結果から推定した、き裂の生成範囲と、爆 破実験において実際に生成したそれらとはかなりよく一致した。とのこと は、ガイドホールによるき裂の抑制効果の機構に関して著者が行なった上



第6・16図 ガイドホールが存在する場合に生ずるき裂の様相

記の推定が、ほぼ妥当であることを意味しているものと考えられる。

第6・17図(a),(b),(c)は、ガイドホールと装薬孔とを一直線上に設け



ずに、ガイドホールと装薬孔の中心を 結ぶ線が互いにある角度を持つように ガイドホールを設けた場合の実験結果 を示したものである。

してしまうことがわかる。

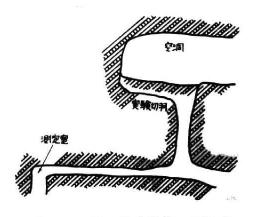
合に生ずるき裂の様相

6.4 スムース・プラスティングに関する現場実験

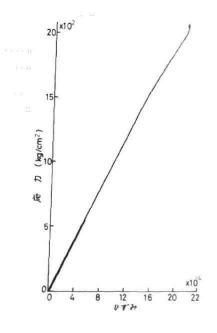
6.4.1 実験現場附近の状況と岩石の物理的性質

第5章および第6章の前節までに、スムース・プラスティングに関する基礎的な研究結果を示したが、これらの研究で得られた結果を確かめるために、スムース・プラスティングに関する現場実験を通常爆破と比較しつつ実施した。

実験は、1967年10月24日から11月2日までの10日間、三井金属鉱菜神岡鉱業所栃洞坑坑内の中段採掘切羽において行なわれた。実験現場附近の見取図は第6・18図に示すとおりであって、測定器室は実験切羽より約100m離れている。実験切羽の岩盤の様相は最初に爆破を実施



第6・18図 実験現場の見取図

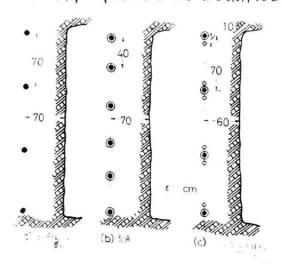


第6・19図 実験現場の岩石 の応カーひずみ線図

はほとんど認められず、また、圧縮破壊応力附近でもひずみはあまり大きくならず、この岩石が非常に弾性的な挙動を示すことがわかった。したがって、このような岩石で構成されている岩盛を弾性体と仮定して応力計算を行なっても、なんら不都合はないものと思われる。なお、岩石のヤンク率は9.9×10 ⁵ Kg/cm 、ポアソン比は0.25 、密度は3.18/cm 、圧縮強度はほぼ2×10 ⁸ Kg/cm 、引張強度は13.4 Kg/cmである。

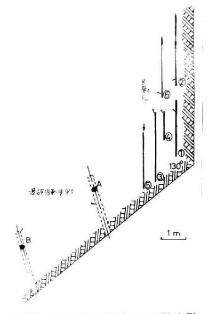
6.4.2 実験方法

実験は, 第6。20図(a),(b),(c)に示すような3条件について合計6回



第6・20図 爆破実験の条件

行なった。



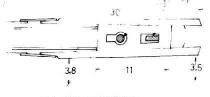
第6・21図 装薬孔と測定孔 の位置関係の図

であって,太い実線は爆薬の位置を示しており,それぞれの線に付した番号は爆破実験順序である。①,④,⑥の位置では第6・20図(a)に示した条件による爆破を実施し,②の位置では,(c)の条件による爆破を行なった。これらの爆破に起因する岩盤粒子の振動は,第6・21図に示した点A,Bに設置した加速度型振動計により測定し

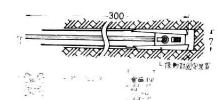
たが,振動計は爆破振動測定孔の軸方向,およびその軸を含む水平面内でその軸に直角の方向の振幅を受信できるように設置した。

なお、2本の爆破振動測定孔は直径7cm、孔長はほぼ9.5 mであって、4mの間隔で互いに平行に穿孔した。

爆破によって岩盤内に生ずる振動を測定するための加速度型振動計は,



(a) 原動計高児養置機工法

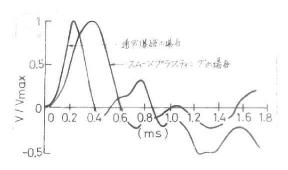


第6・22図 実験装置機器に関する説明図 (数字の単位は cm)

第6・22図に示すような方法で岩盤内に固定した。第6・22図(b)に示すように,振動計の出力端子には加速度に対応する電圧が生ずるが,圧電型加速度計はそのインピーダンスが高いため,振動計の近くにあるカソードフォロアによって,インピーダンスを下げたのち,シールド線を用いて伝送し,4成分データレコーダを用いて記録した。したがって,データレコーダには加速度に対応する電圧が記録されることになる。現場ではシンクロスコープを用いてプレイバックした。

6.4.3 実験結果

第6・23図は、スムース・プラステイングを行なった際に、爆源より 2.7 mの点に発生した変位加速度を積分して変位速度を求め、その結果を 示したものである。なお、比較のために、この図には通常爆破を行なった 際に、爆源から4.5 mの点に発生した変位速度の時間的変化状態も示した。 また、図の縦軸には、波形の対比を容易にするために、任意の時間におけ る変位速度をその最大値で除した値を示してある。図より明らかなように



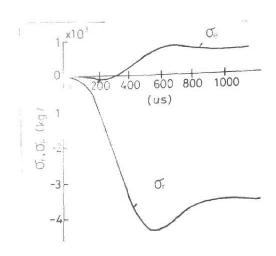
第6・23図 通常爆破とスムース・プラステイン グによる粒子の変位速度の時間的変化状態

デカップリング装薬で実施したスムース・プラステイングにおいては,変位速度が立ち上りより最大値に達し再び零になるまでの時間が通常爆破の場合のそれの約1.5倍というかなり大きな値を示している。また,デカップリング装薬をした場合の変位速度の最大値は,密装填で行なった通常爆破によるそれらのほぼ50%に減少している。

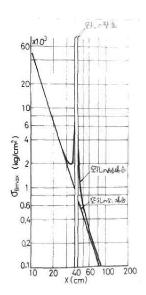
第 $6\cdot24$ 図は、上に示した岩盤粒子の変位速度などの実測結果を用いて爆源から40cmの点に生ずる応力 $\sigma_{\gamma},\sigma_{\theta}$ の時間的変化状態を計算し、その結果を示したものである。

このような応力状態が生ずる点にガイドホールが存在すると,装薬孔とガイドホールとを結ぶ線上に生ずる $\sigma_{m{\theta}}$ はどのように変化するかを示したのが第 6 。 2 5 図である。図よりこの解析結果においても第 6 。 1 4 図に示した模型実験の場合の応力状態の変化と同様の傾向を示しているが,ガイドホールが存在する場合の $\sigma_{m{\theta}}$ の最大値は存在しない場合の $\sigma_{m{\theta}}$ の最大値に比べて約 7 倍の大きさになっていることがわかる。このように大きな倍率になったのは,第 6 。 2 4 図に示した $\sigma_{m{\tau}}$ の最大値(絶対値)が $\sigma_{m{\theta}}$ の最大値(絶対値)に比べて 2 4 倍以上になっているためである。

さて,第6·26図(a),(b)は,密装塡による通常爆破を実施した際に生



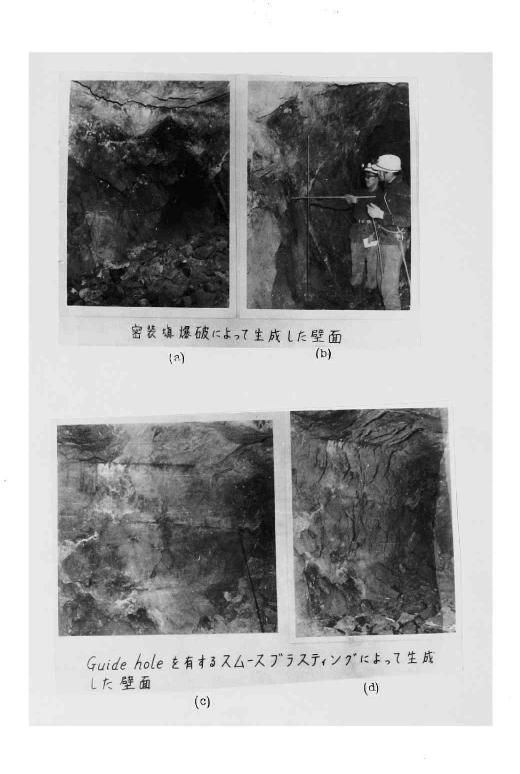
第6・24図 デカップリング装薬 (De = 2.2) の場合に ,爆源から40cm の点に生ずる応力の時間的変化 状態



第6・25図 空孔がX= 40cmの場合の Gy maxのX 軸方向 の変化

じた壁面の写真であって、装薬孔の跡が見つけられない程岩盤はひどく損傷しているのがわかる。

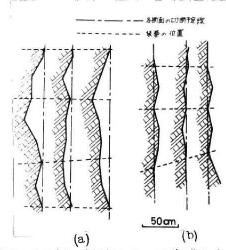
また、第6・26図(c)、(d)は、ガイドホールを有するスムース・プラステイングを実施した場合に生じた壁面の写真であり、壁面は大変滑らかであって、装薬孔やガイドホールの跡も、その存在位置が明瞭に観察できる。



第6・26図 爆破により生成した壁面の写真



第6・27図は,爆破によって生成した壁面について,切断予定面から の凹凸の状態を数個所の任意の断面において測定し,その結果を示したも のであって,第6・27図(a)は第6・26図(a),(b)に示した密装填による



第6・27図 爆破によって生成した壁面の状態

爆破の場合、第6・27図(b)は第6・26図(c)、(d)に示したガイドホールを有するスムース・プラステイングの場合に得られた結果を示している。図より明らかなように、ガイドホールを有するスムース・プラステイングの場合に生成した壁面の凹凸は、切断予定面より±7cm程度で、通常爆破および普通に行なわれているスムース・プラステイングによって生成した壁面の凹凸よりすぐれた壁面が生成したことがわかる。また、第6・27図(b)に示した壁面の特徴の一つは装薬孔との間が少しふくれていることであって、この現象は、第5章の第5・16図に示した断面の様相と一致している。このことから、第6・27図(b)にその結果を示したスムース・プラステイングでは、生成した壁面より損傷を与えてはいけない奥深い部分までき裂が生成していないと考えてもよいものと思われる。

6.5 結 言

本章においては、主としてガイドホールを有するスムース・プラステイングについて考察を行なった。まず、ガイドホールの存在によりガイドホールの方向以外の方向へのき裂の生成が抑制される現象については、ガイドホールの方向に早く生成したき裂から投射される応力解放彼の影響が大きいものと推定し、応力解放彼の性質について考察を行なった。

つぎに,得られた応力解放波の性質を考慮して,ガイドホールによるき裂の 抑制 被構について理論的,実験的に検討した。その結果,この抑制効果が装 楽孔とガイドホールとの間隔や,装薬条件などによって変化することを明か にした。

さらに、ガイドホールを有するスムース・ブラステイングについて現場実験を行ない、生成した壁面の切断予定面からの凹凸の状況を調べた結果スムース・ブラステイングにより生成した壁面の凹凸の最大値は±7cm程度であって、通常爆破や普通のスムース・ブラステイングの場合よりも良好な壁面が得られたことを述べた。また、得られた壁面の断面の様相は、第5・16図に示した断面のように、装薬孔と装薬孔との間がすこしふくれているような壁面であって、このことから、この場合の爆破では、損傷を与えたくない部分には大きなき裂はあまり生成していないものと思われることを指摘した。

参 考 文 献

- 1) チモシェンコ著:谷下・渡辺訳:工業振動学・東京図書1956,P. 275
- 2) 伊藤一郎·佐々宏一: 日本鉱業会誌 84巻 964号 (昭43) P. 1059

第 7 章 辱殊形状薬包によるき裂方向の制御

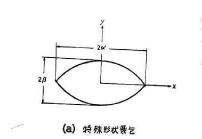
7.1 緒 言

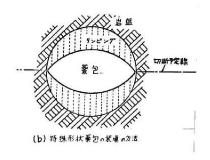
通常の内部装薬爆破の場合には,爆源を中心とする多くの半径方向のき裂が生成することはよく知られている事実であるが,この場合一般的には,半径方向のき裂がどの位置に発生するかについては予測できないことはすでに述べてきたとおりである。一方いままでに行なったスムース・プラステイングに関する研究を通じて,爆速が比較的速い爆棄,すなわち,それらの爆撃の爆轟にともなって生ずる波動によって震源近傍に破壊を生ずるような爆撃を使用する場合には、装薬孔に近接して空孔(ガイドホール)を穿孔しておくことにより,ある程度放射状き裂の発生方向を制御しうることを明らかにした。

そこで本章では、主として爆発生成ガスの準静的を圧力によって材料を被 振するような火薬類を用いる場合には、どのような方法によって爆源から発 生するき裂に方向性を持たせ得るかについて有限要素法を用いた静的な応力 解析による理論的検討かよび大規模なセメントモルタル・ブロックを用いて 実験的検討を行なった結果について述べる。さて、材料の破壊に対してガ ス圧が主役を演ずるような火薬類としては、燃速の遅いことが要求されるが 今回は、最近都市にかけるコンクリート構造物を破壊するための火薬類とし て開発されたコンクリート破砕薬を使用して爆破を行なう場合について検討 した。

7.2 特殊形状薬包

まず,装薬孔内壁に作用するガス圧により生ずる装薬孔近傍の破壊の様相 について考えてみることにする。いま無限媒質内に設けられた円柱状装薬孔 内に時間とともにゆるやかに増大する準静的な圧力が作用する場合を考えて みると、この圧力によって、装薬孔壁面に発生する接縁方向の圧力は、圧力値が材料の引張強度より低い場合には内圧と同じ大きさの引張応力となる。したがって、装薬孔の断面が完全に円形であり、かつ、材料が完全に均質であれば内圧の値が材料の引張強度と同じ大きさに達したときに装薬孔壁面から半径万向に多くのき裂が発生することになる。しかしながら、実際には、装薬孔の断面は完全な円形ではなく、材料も完全に均質ではないので、作用する圧力の値が材料の平均引張強度に近づくと装薬孔壁面上でもっとも弱い値所にまず半径方向のき裂が生成することになる。このことは、半径方向のき裂を発生させたい方向と装薬孔内壁との交点に引張応力の集中が生ずるよりにしておけば希望する方向へ半径方向のき裂を優先的に発生させるためには、その個所の曲率を大きくすればよく、逆に引張応力の値を軽減させたければ曲率を小さくすればよいであろうと考えられる。以上のような考えから希望する一直線上にき姿を発生させるためには、断面が第7・1図(a)に示す





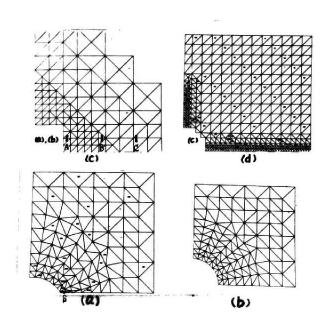
第7・1図 特殊形状薬包とそ の使用方法

ような形状の装薬孔を使用すればよいのではないかと考え、このような形状の断面をもつ装薬孔内に準静的な内圧が作用した場合に生ずる材料内の応力状態と、それにもとづく、き裂の進展状況などを、まず有限要素法を用いて検討した。なお、第7・1図(a)に示したような形状の装薬孔を穿孔することは困難であるから、実際の爆破作業においては、まず通常のさく岩機を用いて円形断面の装薬孔を穿孔し、その内部に第7・1図(a)に示すよう

な形状の断面をもつ薬包を,第7・1図(b)に示すよりに希望するき袈線の方向を考慮して挿入したのち,セメントモルタルを用いてタンピングを行なえば,所定の断面形状の装薬孔とみなすことができる。なか,コンクリート破砕薬を用いて材料を破壊する場合には,いずれの場合でもセメントモルタルを用いてタンピングを行ない,それが完全に固結してから,爆破を行なりことになっている。

7.3 応力解析条件および解析結果

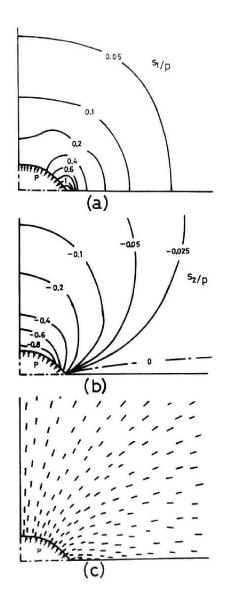
断面の形が,第7・1図(a)に示したような形状をもつ装案孔内に準静的な 圧力が作用した場合に,材料内に発生する応力状態とそれによって生成する き裂の様相とを有限要素法を用いて検討した。第7・2図(a)は,第7・1図 (a)に示した特殊形状断面の長軸の長さ2αと短軸の長さ2βとの比が2:1 の楕円状の断面をもつ薬包を円形の装薬孔内に装塡し,セメントモルタルで



第7・2図 静的応力解析に用いた模型

タンピンクを行なった場合を想定した模型の装薬孔近傍の要素分割状況を示した図であり,第7・2図(b)は,(a)の場合のき製方向制御の効果を明瞭にさせるために,今まで普通に用いられてきた円柱状の薬包を密装填した場合を想定した模型のそれである。実際に応力解析に採用した模型全体の要素分割状況は,第7・2図(a)あるいは(b)に示した部分が,第7・2図(c)の左下にはまり,さらにそれが第7・2図(d)の左下の部分に入った状態のものであって三形角要素の数は1074,節点の数は608である。採用した弾性定数の値は,後述する実験の結果と計算結果とを比較検討するために,実験で用いたセメントモルタルの弾性定数の値を用い,問題はすべて平面ひずみ問題として解析した。

さて, 第7·1図(a)に示した特殊形状の断面をもつ装薬孔内壁にPなる圧 力を加えた場合に、材料内に生ずる最大主応力8、(引張応力を正とし、符号 も考慮した最大主応力)の値が等しい点を結んだ等最大主応力線を示したの が第 7・ 3図(a)であり,最小主応力 S ,の値が等しい点を結んだ等最小主 応 力線を示したのが第 7· 3図(b)である。ただし,図にはS/PまたはS/P の値が示されており、この値が正のときは、引張応力であり、負のときは圧 縮応力である。 第7・3図(a)より明らかなように,α/β=2.0 の場合には, 装薬孔断面の長軸方向の壁面近傍に 8 √ P = 3.2 という大きな引張主応力が 生じることがわかる。また、S,/P=0.05の値を示す等主応力線をみてみ ると、その形はほぼ原点を中心とした同心円に近い曲線になっていて、これ は半径が (α+β) /2 の円形装薬孔にPなる圧力が作用した場合に示す応力 状態である。このことは、最大主応力S1の分布のみについてみれば、S1/ P=0.05を示す等主応力線以遠では,装薬孔の断面形状が楕円状であろうと 大差はなくなるととを示している。しかし、第7・3図(切に示すように、最 小主応力の分布状態は円柱状装薬孔の場合とは大変異なり、その差違は原点 から遠く離れた点においても明らかであって,長軸方向のS。の値は正,負 いずれの値をとるにしても零に近い値を示す。

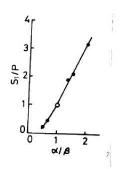


第7・3図 特殊形状薬包を使用した場合 の装薬孔周辺の応力状態

た \mathbf{S}_1 が作用する面の方向を示したのが第 $\mathbf{7}$ ・ $\mathbf{3}$ 図(c)であって,引張応力して作用する最大主応力が引張強度に達した場合に材料が破壊するとする

と,この方向に沿ってき裂が生成することになる。第7・3図から,圧力Pが零から徐々に大きくなってくると,岩石やセメントモルタルのように脆性度の大きな材料では,装薬孔壁面からのき裂は装薬孔断面の長軸を含む面に沿ってもっとも早く発生し始めることがわかる。

薬包の形が周囲の岩盛中に生ずる応力状態におよぼす影響について示したのが第7・4図である。縦軸には,第7・2図(a)に示した点Sに生ずる最大主応力を内壁に作用する圧力の大きさPで徐した値 S_1/P をとってあり、横



第7・4図 第7・2図(a) に示した点Sに生 ずるS₁ の大きさ がα/β の値によ ってどのように 化するかを示した

軸には、 α / β の値をとってある。図より明 らかなように、 α / β の値が大きくなるにし たがって、すなわち、薬包の形が切断予定線 方向に長くなるにしたがって、点 β に生ずる 引張応力の値は、直線的に増加することがわ かる。

なお, α / β = 1 の場合,すなわち,円形断面の装薬孔の場合には, β $_1$ / P の最大値は装薬孔壁面上ではすべて同じ大きさであって,理論的には 1 となる。

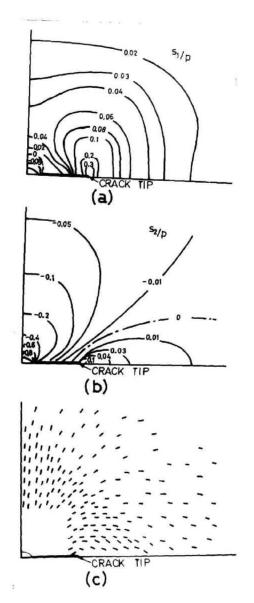
つぎに、このようにして圧力Pがある大きさに達し長軸方向にき裂が生成した場合には、材料内にはどのような応力状態が生ずるかについて解析した 結果を述べることにする。圧力Pの立ち上り時間(圧力が作用しはじめてか らその最高値に達するまでの時間)が遅く、波動による応力が無視できるよ うな場合でも、いったんき裂が生成しそれが時間とともに成長する場合には き裂の成長にともなう応力分布の変化は静的であるとはいい難いと思われるので、き裂の成長による応力変化を有限要素法で解析することには問題があるが、き裂の伝播速度が材料の縦波の伝播速度に比べて、非常に遅い場合には、静止しているき裂近傍の応力状態と大差がないことが、光弾性を用いた研究結果として報告されているので、1)ここでは一応有限要素法を用いて応力解析を行なった。

第7・5図(a),(b)および(c)は,特殊形状薬包を用いた場合に,き裂が長軸方向に壁面から4αの位置まで成長した時の等最大主応力線,等最小主応力線 および最大主応力が作用する面の方向を図示したものである。また,特殊形 状薬包を用いた場合と普通の円柱状薬包を用いた場合との差違を比較検討す るために,円柱状装薬孔の場合について装薬孔の半径の4倍の位置までき裂 が入った場合の等最大主応力線を示したのが第7・6図である。

第7・5図(a)および第7・6図より明らかなように、特殊形状薬包の場合も 円柱状薬包の場合も、き裂先端近傍における等最大主応力線の状態には大差 はなく、先端近傍では両者ともSェ/P=・0.4程度の大きさの引張応力が発生 している。しかしながら、き裂方向と直角な方向、すなわち、特殊形状薬包 の断面の短軸の方向では両者の応力状態は大きく異なっていて、円柱状薬包 の場合には図に示すようなき裂が存在していても、き裂方向と直角な方向の 心装薬孔壁面にはまだ大きな引張応力が生じているが、特殊形状薬包の場合 には、同じ位置での応力が圧縮応力となっている。

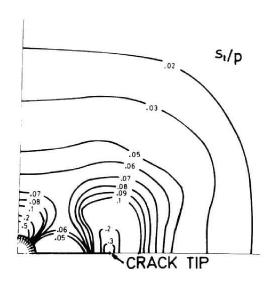
特殊形状薬包の場合には、切断予定線の方向と直角な方向の装薬孔壁面附近では、主応力は最大値も最小値もともに圧縮を示すことが特徴である。

また,第7・5図(a),(b),(c)に示したき裂先端部分の応力状態の傾向は,第7・3図に示した装薬孔壁面と長軸とが交わる部分近傍の応力状態の傾向とよく似ている。このことは,き裂が長軸方向に生ずる以前にあたかもき裂が存在しているかのような応力状態を示していることになり,スムース・プラステイングにとっては好ましい応力分布であるといえる。



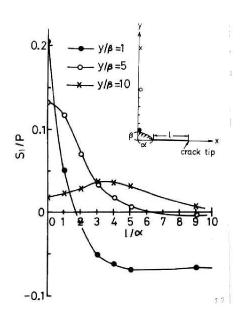
第7・5図 き裂の長さが4αの場合の 応力状態

とのように、長軸方向に、き裂が生成すれば、き裂先端に引張応力の集中が生ずるようになり、き裂先端が進行するとともに、との応力集中の部分も



第7・6図 円柱状装薬孔の場合に き裂の長さが半径の4倍の 時の応力状態

動するが,このき裂と直角な方向,すなわち,短軸方向に生ずる最大主応 s_1 がどのように変化するかを示したのが第7・7図である。緑軸には,軸上にあって,装薬の中心から β ,5 β ,10 β の位置にある点に生ずる s_1 値をPで徐した値をとり,横軸には,長軸方向の壁面から生成するき裂のさ ℓ をαで徐した値をとってある。図より明らかなように,短軸方向の装孔壁面近傍の点の s_1 の値は,長軸方向に,き裂が生成すると急激に減少, ℓ が1.7 α の時に引張応力から圧縮応力へと変化することがわかる。ころが,Yが10 β の点に生ずる s_1 の値は,一度増加し,ピークに選し後は減少する傾向を示している。これは,長軸方向に生成しているき裂の端に生ずる大きな引張応力の影響が,爆源から離れた点では遅れて現われくることを示している。そしてYが5 β の点に生ずる s_1 の値はこれらの間の変化の様相を示している。以上の解析結果より,長軸方向にすこして



第7・7図 短軸方向の各点に生ずる主応力8₁が長軸方向に生成したき裂の長さによって変化する様相を示した図

もき袈が生成すれば,装薬孔壁面上には引張応力は発生しなくなり,壁面上のすべての点で圧縮応力となることがわかる。このことは,特殊形状薬包を用いた場合には,まずその長軸方向にき裂が生成し,それ以外の方向には半径方向のき裂は生成しないということを示している。

なお、円柱状薬包の場合に、き裂方向と直角な方向の孔壁に発生する引張応力の大きさは、き裂が長くなっても大きな変化は示さず、き裂の長さが半径の4倍のときには、き裂が生成していない場合のそれの70%に、10倍のときも,20倍のときも66%に減少する程度で、これ以上変化はない。

以上に示したように、有限要素法による応力解析結果から、 $\alpha/\beta=2$ 程度

の楕円状の断面をもつ特殊形状楽包を用いれば、その長軸方向 の み に き裂を入れ うることが明らかとなったので、このことを実験的に確認するために特殊形状薬包を用いてセメントモルタルブロックを切断する実験を行なった。

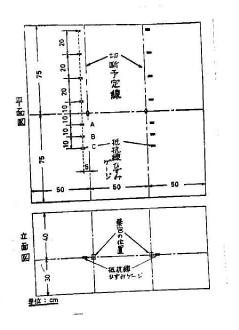
7.4 特殊形状薬包を用いてセメントモルタルプロックを切断する実験7.4.1 実 験 方 法

実験現場の概況とセメントモルタルプロックは,第7 - 8図に示すとおりであって,このプロックの大要は第7 - 9図に示すとおりである。プロック内には,コンクリート破砕薬の爆発によって,プロック内に生ずる切



第7・8図 実験現場の概観とセメ ントモルタルブロック

断予定線と直角な方向のひずみが側定できるように、切断予定線から5cm離れた線上に抵抗線ひずみゲージを埋め込んだ。また、このプロックを切断するために使用した特殊形状楽包は第7・10図に示すとおりであって断面の長軸と短軸との比は2:1で長軸の長さは4cmである。なお、薬長は薬量によって異なる。また、図に示すような特殊形状薬包内に、主としてガス圧によって材料を破壊するコンクリート破砕薬の一種であるCCRSを入れ、この薬包をセメントモルタルプロック内に密装塡した。密装塡の方法は、通常の方法でCCRSを用いる場合に行なわれているのと同一の方法であって、まず、CCRS 薬包を円形断面の装薬孔内に挿入し、ついで急



第7-9図 実験で使用したセメント モルタルブロックの説明図

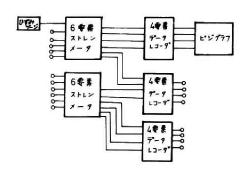
結剤で練りまぜたセメントを装薬孔内に流し込むという方法である。ただし、特殊形状薬包の場合にはその長軸の方向をブロックの切断予定線の方向と一致させておかなければならない。



第7・10図 実験で使用した特殊 形状薬包

使用したセメントモルタルのセメントと砂との比は1:2であって,そのャング率は 2.3×10^{5} Kg/cm,ポアソン比は0.10,密度は2.25 g/cm, 圧縮強度は 6.5×10^{2} Kg/cm,引張強度は4.7 Kg/cm,また,超音波法による縦波の伝播速度は 2.8×10^{8} m/8 であった。

第7・11図は測定装置の概念図であって,ひずみゲージで受信されたひずみに対応して,ストレンメータの出力端子に生ずる電圧はデータレコーダに記録され,ビジグラフによってプレイバックされた。



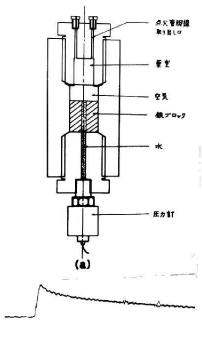
第7·11図 測定装置概念図

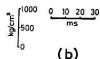
7.4.2 実 験 結 果

まず、今回の実験に使用したコンクリート破砕薬 CCRS を第 $7 \cdot 12$ 図(a) に示すような鋼鉄製の密閉容器内で燃焼させ、容器内壁に作用する圧力の時間的な変化状態を測定した。その結果の一例は第 $7 \cdot 12$ 図(b)に示すとおりであって、圧力が作用しはじめてからその最高値($800 \sim 1000$ $\sqrt{2}$ \sqrt{ch})に達するまでの時間はほぼ 4mS であった。この値は爆薬の爆轟圧の立ち上り時間に比べれば非常に長いといえる。

さて、実験の結果を大別すると、プロックを切断予定線方向に沿って切断 できた場合と、装薬孔近傍にき裂は生成したもののそのき裂は表面にまで 達しなかった場合とに分けることができる。また、それぞれの場合に得られ たひずみ記録から,き裂先端の進行速度は,切断できた場合には 5×10^2 $m/S\sim1\times10^3m/S$ 程度であり,切断できなかった場合には $5\times10m/S\sim8\times10m/S$ 程度であろうと推定できた。

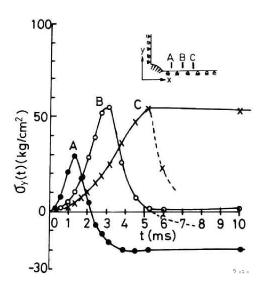
このように、切断できなかった場合のき裂の進行速度は、ブロック内での 縦波の伝播速度 2.8×10³ m/S に比べて非常に遅く、この場合には有限 要素法を用いた応力解析結果と実験結果とを対比しても大きな誤りはない ものと思われる。また、ブロックが大きく割れなかった場合には、ガスが あまり流出しないために装薬孔内壁に作用する圧力は第7・12図(りに示 した状態とほぼ同様の時間的な変化状態を示すものと思われる。





第7・12図 鋼製の密閉容器内で CCRS を燃焼させた場合 に容器内壁に作用する圧力 の時間的変化状態

C 化生じている応力状態を表わしている。第 $7 \cdot 13$ 図に示した実線は,き裂が点C の附近で進行を停止したと仮定した場合に得られた応力状態であって,き裂がそのまま進行を続ける場合には,応力の時間的な変化状態

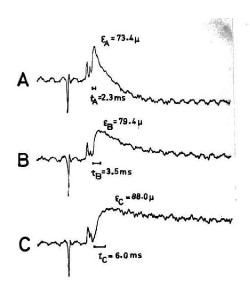


第7・13図 有限要素法による計算で 求めたき裂の進行にともなう点 A,B,Cの応力の時間的変化状態

は点線で示したようになる。図より明らかなように、き裂がその近傍を横切って進行する点Aおよび点Bにおいては、き裂の先端がその点に近づくと大きな引張応力を示し、さらに、き裂が発展すると応力値は減少している。

点Aにおいては、その応力状態にき裂の影響が大きく出ており、応力は引張から圧縮へと変化しているが、点Bにおいてはまだそれほどでもなく、 圧縮応力になるまでには至っていない。また、点Cにおいては、き裂の先端がその近傍で進行を停止しているため、大きな引張応力となっており、かつ、この点における応力の時間的変化状態は、第7・12図(b)に示した 圧力波形と比較的よく一致している。なお、き裂が点じ近傍で止まらないで、さらに進行する場合には、それぞれの点に生ずる応力は点線で示したように変化し、点Bでの応力も点Aにかけるそれと同様に圧縮応力に変化していく。

さて,第 $7 \cdot 14$ 図は,実験によって得られたひずみ記録の一例であるが,この記録は,78のCCRSを爆発させた場合に得られたものである。

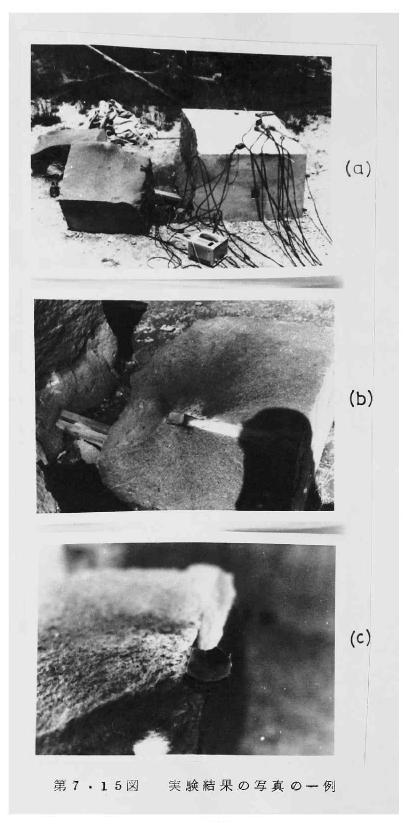


第7・14図 測点A,B,Cの点に 生ずるひずみ記録

この場合にはプロックは切断されなかったが、装薬孔近傍にはき裂が生成しており、しかもそのき裂は途中で止り表面に現われるほど成長しなかった。第7・14図に示したオシログラムA、B、Cは、それぞれ第7・9図に示した側点A、B、Cに埋め込んだひずみゲージによって得られたオシログラムである。ひずみ記録では零レベルから上が引張ひずみを、下が圧縮ひずみを表わす。なお、引張ひずみの最高値およびその値に達するまでの起爆後の時間は、オシログラムA、B、Cについてそれぞれ、

 ϵ_{A} =73.4 μ , ϵ_{B} =79.4 μ , ϵ_{O} =88.0 μ および t_{A} =2.3m8, t_{B} =8.5m8, t_{C} =6.0m8 という値になる。第7・13図および第7・14図を対比すれば明らかなように,両者の様相はかなりよく一致していた。とくに実験から得られた ϵ_{B} , ϵ_{C} > ϵ_{A} という関係と(t_{B} - t_{A}) < (t_{C} - t_{B}) という関係は,第7・13図に示した応力計算結果からも求めうる関係である。このように,今回の実験で実測したひずみ記録と有限要素法による解析結果とがほぼ一致しているということは,特殊形状薬包内の t_{C} t_{C}

第7.15図(a)は,特殊形状薬包を用いてブロックを切断した実験結果 の一例を示す写真であって、ブロックは切断予定線方向に沿って切断され ている。この場合に使用した CCRS の薬包は108である。切断された小 さい方のブロックは切断予定方向と直角な方向にさらに二つのブロックに 割れているが,切断予定方向と直角な方,すなわち,特殊形状薬包の短軸 方向に沿った割れ目は装薬孔壁面から発生したのではなく,切断されたブ ロックの中央がガス圧によって押されたためにブロックの側壁から装薬孔 の方へ向って生成したものである。このことは,第7・15図(ウ)に示すよ うに、切断予定方向に生じた破断面にはガスが進入した形跡があり、それ と直角方向に生じた破断面にはガスの進入した形跡はないということ,お よび,第7·15図(c)に示すように,特殊形状薬包の容器およびタンピン グに使用したセメントモルタルの短軸方向側の分が破断されずにそのまま 残っていることからも明らかである。以上に実験結果の一例を示したが, 9個のセメントモルタルブロックを用いて実施した多くの切断実験の結果 から,特殊形状薬包を用いることによって,その長軸方向以外の方向には 全くき裂を入れることなしに,長軸方向のみに長いき裂を入れうることを 実験的にも確認した。



=152-

7.5 結 言

本章においては、主として爆発生成ガスの圧力によって材料を破壊する火薬類を用いて内部装薬爆破を行なり場合に、装薬孔内壁から生成するき裂に方向性を持たせうるかどうかについて検討した。すなわち、薬包の断面が精円形をなす特殊形状薬包を円形断面の装薬孔内に装塡し、セメントモルタルでタンピングを行なったのちに起爆すれば、特殊形状薬包の断面の長軸方向以外の方向にはまったくき裂を入れることなしに、長軸方向のみに長いき裂を生成させうることを有限要素法による応力解析結果と特殊形状で薬包を用いて行ったセメントモルタルブロックの切断実験とから確認し、この種の特殊形状薬包を用いることによって有効なスムース・プラスティングを実施しりることを明らかにした。

参 考 文 献

1) A A Wells , D. Post : S. E. S. A Proceedings , vol. 16 No. 1, $(1958) \quad \text{P.} \ \, 69 \, \textcolor{red}{\sim} \, 92$

The second

第 8 章

プリスプリッティングにより生成したプリスプリットの効果

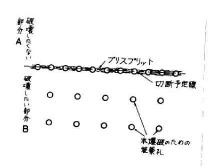
8.1 緒 言

以上は主としてスムース・プラスティングについて述べてきたが、大規模に実施された例のある制御爆破工法にブリスプリッティングがあることは緒論で述べた。プリスプリッティングは、まず、切断予定線に沿って孔間隔を密にして穿孔された装薬孔内に爆薬を軽装填し、これらを起爆することにより、切断予定線に沿ってき裂、すなわちプリスプリットを生ぜしめる。その後、本爆破を実施することにより、破壊したい部分を破壊し、本爆破によって生ずる波動の大きさや、き裂の数や大きさを、プリスプリットによって軽減し、切断予定線より奥にある岩盤に損傷をあまり与えないよりにする工法である。したがって、プリスプリッティングにおいて、どうして切断予定線に沿ってプリスプリットが生成するかという破壊機構は、スムース・プラスティングの場合の破壊機構とほとんど同じであると考えてよいであろう。

そこで、つぎに本章においては、プリスプリットが切断予定線上に生成したものとして、プリスプリットの存在が、本爆破にともなら波動の大きさや き裂の進展に与える影響について検討した。

82 プリスプリットが本爆破にともなり波動を軽減させる効果

ブリスプリッティングにおける本爆破は、第81図に示すように、プリスプリットの生成によって岩盤を破壊せずに残しておきたい部分Aと破壊したい部分Bとに分離された後に実施される。したがって、Bの部分で生じた爆破による波動がプリスブリットを横切って伝播してAの部分に達したときには、その大きさや波形に変化が生ずるが、どのように変化するかという理論的考察は今までにはあまりなされていないようである。その最大の理由とし



第8・1図 プリスプリッティングの 概念図

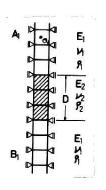
て、プリスブリットであるき裂をどのように表現して理論解析に組入れるかという問題が、困難な問題として残されていたからである。

岩盤内に生じたき裂を表現する方法には種々の方法が考えられるであるうが、ここではとりあえず以下に述べる三つの表現方法によりき裂を表現し、第3章32節で述べたTensor Code を少し修正した動的

応力の数値解析方法を用いてき裂の存在する岩盤内の応力状態について検討 し、それらのき裂が波動の伝播にどのような変化を与えるかを考察した。

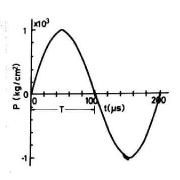
8.2.1. き裂が存在する岩盤の弾性定数を変化させることにより、き裂を表現する方法

検討した第一の方法は、第82図に示したような 模型で表現する方法である。すなわち、き裂が存在 しない部分の岩盤のヤング率を E_1 、ボアソン比 E_2 、 密度を ρ_1 とし、き裂が存在する長さ D の部分の岩盤 のそれらをそれぞれ、 E_2 、 ν_2 、 ρ_2 として、 E_2 < E_1 、 ν_2 > ν_1 、 ρ_2 < ρ_1 なる関係でき裂を表現するもので ある。数値解析に用いた条件は、四辺形要素の 一辺 の長さを 1.4 cm とし、図に示すように四辺形要素の 両端は波動の伝播方向にスライドとしたために、図 の横方向には無限に続いて岩盤が存在することにな る。また、伝播する波動は平面波であって、B の部 分の下端に加える圧力の時間的変化状態は第83図



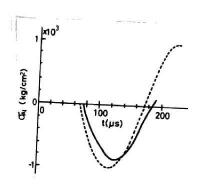
第 8・・2 図 ブリスブリットを含む岩盤 を弾性定数の異なる弾性体 とみなしてプリスブリット を表現する方法の模型

に示すようであって、一周期が 200μ s の正弦波で、最大値は1000 %である。 E_1 を 5.3×10^5 %、 μ を0.25、 ρ_1 を 2.5 %/cm とし、 E_2 を 5.3×10^4 %、 ν_2 を 0.4、 ρ_2 を 1.2 %/cm とした。したがって、き裂が存在しない部分の岩盤 B の縦波の伝播速度 C_{L_1} は 5×10^3 m/s、波長 λ_1 は $\lambda_1 = C_{L_1} \times T$ で示され、長さは50 cm、き裂が存在する部分の縦波の伝播速度 C_{L_2} は 3.05×10^3 m/s、波長 λ_2 は約 31 cm となる。



第8・3図 模型の下端に作用する圧 力の時間的変化状態

以上の条件のもとで、き裂の存在する部分の四辺形、要素の数を 3 個、すなわち、D の長さを 4.2 cm として、第 8.2 図に a_1 で示した点に波動の伝播方向に生ずる応力 a_2 の時間的変化状態を求めて示したのが第 8.4 図である。図には比較のために、き裂が存在しないと仮定した場合、すなわち a_2 a_3 a_4 a_4 a_5 a_4 の場合に点 a_4 に生ずる応力の時間的変化状態を点線で示し

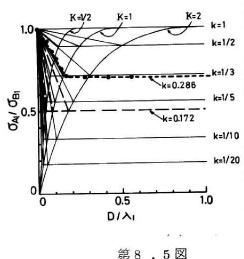


第8・4図 点 a nに生ずる応力の時間 的変化状態

てある。なお、平面波が伝播する場合は、応力 σ と変位速度 v との間には σ = ρ Cv なる関係が 存在するため、第8.4 図では応力と、変位速度 との波形にはそれぞれ比例関係があることに注意する必要がある。図より明らかなように、上記のような方法で表現したき裂、すなわちブリスプリットが存在する場合は、波動が点 a_1 に到達する時間は $D(1/C_{12}-1/C_{11})$ だけ遅くなり、応力の絶対値の最大値は減衰し、さらに波長が長くなるととがわかる。

つぎに、 A_1 の部分の一点に波動の伝播方向に生ずる応力の絶対値の最大値 σ_{A_1} をき裂がないと仮定した場合に B_1 の部分の一点に生ずる応力の絶対値の 最大値 σ_{A_1} で除した値 σ_{A_1} / σ_{B_1} を縦軸にとり、き裂の存在する岩盤の部分の長

さ D を B の 部分を伝播する波動の波長 λ , で除した値 D/λ 1 を横軸にとって、A1 の 部分に生ずる応力波の振幅がき裂幅の大きさの変化にともなってどのように変化するかを示したのが第 8.5 図である。黒丸が上記の計算条件のもとで実施した今回の数値解析方法で得られた結果を示す。 D の大きさが λ 1の大きさに比較して十分大きい場合は、音響インピーダンスの理論が適用できる



弾性定数を変化させて き裂を表現した場合の σ41/σm と D/λ1との関係

音響インピーダンスの理論が適用できるので、その方法で求めた σ_{A1}/σ_{B1} の値を点線で示しておいた。 Dの大きさが十分大きい場合は、数値計算による σ_{A1}/σ_{B1} の値と、音響インピーダンスの理論による σ_{A1}/σ_{B1} の値とは有効数字が三桁まで一致し、非常によくあっているものといえる。さて、数値計算の結果から明らかかなように、 σ_{A1}/σ_{B1} の値は、 D/λ_{1} の値が零から大きくなるにしたがって、ほぼ直線的に減少し、 $D/\lambda_{1}>0.17$ の範囲では、 σ_{A1}/σ_{B1} は 0.701 という一定の値を示すことがわかる。

なお、数値計算により求めた黒丸で示した値は、弾性定数が特定の値をとる場合であって、 $\ell=0.286$ K=1.17 の

場合である。ただし、k、Kはつぎの(8.1)式で得られる値である。 な = U (8.2)式

$$k = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\rho_2 C \iota_2}{\rho_1 C \iota_1} \qquad (8.1)$$

$$K = \frac{\rho_2}{\rho_1} \cdot \frac{\frac{1 - \nu_2}{(1 + \nu_2)(1 - 2\nu_2)}}{\frac{1 - \nu_1}{(1 + \nu_1)(1 - 2\nu_1)}}$$
 (8.2)

すなわち、 R は音響インピーダンス R₁, R₂の比であり、 K はャング率を 除いた弾性定数から求まる値である。第85図には,K=½, 1, 2のそれ ぞれの場合に k=1, %, %……と変化させ、Dの値が十分大きいとき理論 的に得られる σα1/σa1 と D/λ1との関係も示しておいた。このうち, たと えば破線で示した線を例にとって説明してみる。まず、音響インビーダンス の比慮の値が 0.172 の場合には、き裂の幅 D が十分大きいとき、 A1の部分に 生ずる応力 σ₄₁ の大きさは、B₁の部分に生ずる応力 σ₂₁の大きさの%になる。 また,Dの値が零の場合は当然 $\sigma_{A} = \sigma_{B}$ であり, σ_{A} / σ_{B} の値は σ_{A} / σ_{B} = 1 から σո/σո= 0.5 までは,数値解析の結果からほぼ直線的に小さくた るものとみなしてもよいであろう。ところが, ℓの値は,ャング率,ポアソ ン比および密度によって決定され、ゟが同じ値であっても,ャング率などの 値がまったく同じであるとは限らない。したがって、D/λιの値が零から順 次増加するにつれて σ_{ai} $/\sigma_{m}$ が順次減少し,0.5 の値に達して, この値が 変化しなくなるまでの経路は、破線でその例を示したように、数多くあると とになる。また,K=1の場合の破線をみてみると,Dの値が大きく, $\mathbb{D}/\lambda_1 \ge 0.09$ ならば $\sigma_{al}/\sigma_{bl} = 0.5$ であるが,き裂の幅が小さく,例えば $D/\lambda_1 = 0.05$ ならば、 $\sigma_{AI}/\sigma_{II} = 0.73$ となり、あまり

また、この図より逆に、 σ_{Al} 、 σ_{Bl} 、D、 λ_{1} の値を測定することにより、き裂を含む岩盤の弾性定数をある程度推定することができることもわかる。

σπは減衰しないことがわかる。

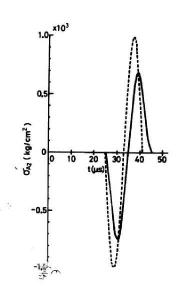
8.2.2 き裂が存在する岩盤には空孔があるものとして き裂を表現する方法

検討した第2の方法は、第8.6図に示したような模型でき裂の存在する岩盤を表現する方法である。すなわち、岩盤のヤング率を E_1 、ボアソン比を ν_1 、密度を ρ_1 とし、

A₂ E₁ V₁ P₁

第8 6 図 プリスプリットを含む岩盤を空孔列とみなしてプリスプリットを表現する方法の 模型

き裂が存在する部分には、一辺が a_1 の断面が正方形の角柱状の空孔をき裂に沿って設ける方法である。まず、 d_1 を 1.0 cm、空孔の間隔 d_2 を 1.0 cm、空孔の中心問距離 $a(=d_1+d_2)$ を 2.0 cm とし、 B_1 、 ν_1 、 ρ_1 の値は 8.2.1 項の数値解析に用いた値と同じ値を用い、岩盤内を伝播する応力波の波長 λ を種々変化させて、空孔の存在によって、第 8.6 図に示した A_2 の部分に生ずる応力の大きさがどのように変化するかを検討した。 B_2 の部分に加えた外力はその圧力最高値が 1×10^3 % の正弦波である。



第8・7図 点 a₂ に生ずる応力の時間的 変化状態

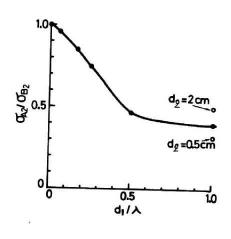
ても得られたが、第8.6図に示す空孔の配置では、点 a2 に波動が到達する時間は、空孔が存在している場合でも存在していない場合でも変化がないことが8.2.1項に述べた解析で得られ た 結果と異っている。

つぎに、 d_1 、 d_2 の値を1cmに保ち、波長 λ を種々変化させて解析を行なった結果を横軸に d_1/λ の値をとり、縦軸に A_2 の部分で空孔から十分離れた点に生ずる圧縮応力の絶対値の最大値 σ_{42} を、 B_2 の部分に生ずる圧縮応力

の絶対値の最大値 σ_{22} で除した値 σ_{42}/σ_{B2} をとって示したのが第 8.8 図である。図より明らかなよりに, d_1/λ の値が小さい場合,すなわち波長が長い場合には, σ_{42}/σ_{B2} の値は 1 に近く, σ_{42} はあまり減衰せず,波長が短くなるにしたがって, σ_{42} はほぼ直線的に減衰し, $d_1/\lambda > 0.5$ の範囲では σ_{42}/σ_{B2} の値はほぼ一定の値を示すようになり,波長が空孔の大きさに比較して短い場合には,それ以上減衰しないという限界が存在することがわかる。

第88図に示した波長の長短に ともなう σ₄₂の減衰傾向は, 第 85図に示した傾向とよく似て おり, 興味深いことである。

そこで、空孔が存在する岩盤の弾性定数 E2、ν2、ρ2 を求めてみよう。すなわち、第8.6 図に示したように、上記の解析では、き裂を含む岩盤を空孔と、ヤング率 E1、ボアソン比 ν1、密度ρ1である普通の岩盤とから成立しているものとしたが、いま、これらの空孔と普通の岩盤とからなる部分を合わせて、ヤング



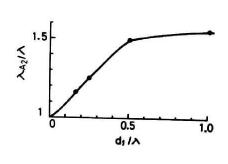
第8・8図

き裂を空孔列として表現する方法を採用した場合のき裂前後の応力値 4./ス との関係

率 E_2 , ポアソン比 ν_2 , 密度 ρ_2 , である一様な岩盤とみなすことにし、 E_2 ν_2 , ρ_2 の値を求めてみる。第85図,第88図を比較して,第88図に示した実線は,第85図における $\ell=36$, K=5 の定数で示される線とほぼ等しいことがわかる。また,模型より明らかなように, $\rho_2=36$ ρ_1 である。これらの数値より, $E_2=\frac{1}{320}$ ・ E_1 , $\nu_2=1.94$ ・ $\nu_1=0.486$ が得られ,さらに縦波の伝播速度 C_{12} はき裂がない部分の伝播速度 C_{11} の名であることがわかる。

第8.8 図には、空孔の大きさをそのままにして、 $d_1/\lambda=1$ の場合で空孔

の間隔 d_2 が 0.5 cm eqrap 2 cm の場合について σ_{A2}/σ_{B2} の値を白丸で示しておいた。それらの値は $d_2=0.5$ cm で $\sigma_{A2}/\sigma_{B2}=0.322$, $d_2=2$ cm で $\sigma_{A2}/\sigma_{B2}=0.502$ である。このことからもわかるように,間隔 d_2 を小さくするということは,き裂を含む岩盤の音響インピーダンスを小さくすることと等価であり,逆に, d_2 を大きくすることは,音響インピーダンスを大きくすることと等価であるといえる。

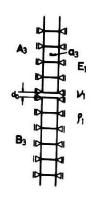


第8・9図 き裂を空孔列として表現した 場合に生ずる応力波の波長の 変化状態

第89図は、空孔の存在によって A_2 の 部分に伝播してくる応力波の波長が d_1 人の値によってどのように変化するかを示した図であって、横軸に d_1 人の値をとり、縦軸には A_2 の部分に伝播していく応力波の波長 λ_{42} を B_2 の部分を伝播する応力波の波長 λ で除した λ_{42} 人をとってある。第88図と第89図とを比較すれば、減衰が大きい場合には波長が長くなる程度も大きいことがわかる。

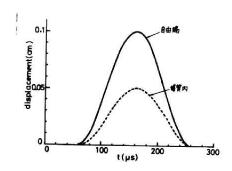
8.2.3 air gap としてき裂を表現する方法

き裂を表現する方法として検討した第3の方法は、第810図に示した模型のように、き裂が存在するところには、air gap が存在し、波動の伝播にともなって、この air gap が閉じたり開いたりして、 B_3 の部分から A_3 の部分へ波動が伝えられるものとしてき裂を表現する方法である。数値解析に用いた条件としては、 A_3 および B_3 の部分の弾性定数は同じ値であって、この値は82.1項で示した B_1 の部分のそれらと同じである。また、 B_3 の部分に加えた外力は第83図に示したものと同じであり、分割された四辺形要素の大きさも82.1項の場合と同じである。



第8 :10 図

ブリスプリットを空隙 とみなして表現する方 法の場合の模型

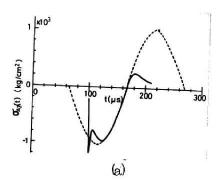


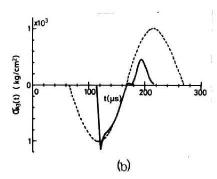
第8・11図

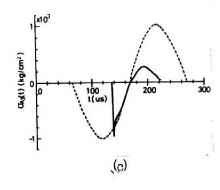
自由端および媒質内に生ずる変位の 時間的変化状態

さて、今回の場合には、air gap の幅 d。の値が 0.1cm より大きい場合には、波動は A_3 の部分の岩盤には伝揺しないが、0.1cm より小さい場合には、 B_3 の部分は A_3 の部分に衝突するために、波動の一部分は A_3 の部分に伝播する。そこで、d・の値が $0.025\,cm$ 、 $0.05\,cm$, $0.075\,cm$ の場合にはどのような応力波が A_3 の部分に伝播していくかを数値計算し、点 a_3 に波動の伝播方向に生ずる応力の時間的変化状態を求めてみた。それらの結果を示したのが第 8 12 図 (a), (b), (c) である。比較のために、d=0 の場合に点 a_3 に生ずる応力の時間的変化状態をそれぞれの図に点線で示した。

入射応力波は B₃ の部分の自由端に到達すると、この自由端は、A₃ の部 分の方に向って移動し始めると同時に、入射応力波は引張応力波となって岩







第8・12図 き裂を空隙として表現 した場合のき裂の存在 による応力状態の変化

盤 Baの中を戻っていくが、そのうちにBa の端面は A₃ の端面に衝突し、まだ反射し ていない入射応力波はそのまま A₃の部分へ 伝播するようになり、第812図に示すよう に, 正弦波の形をした応力波の前の部分が カットされたような状態で aa 点に生ずる応 力は時間的な変化を示すようになる。図よ り明らかなように、air gap の幅 d.が小 さいとカットされる部分も小さく、むが 0.05㎝の場合, すなわち, 第8.11 図に示 した岩盤内の点に生ずる変位の最大値と a. が等しい場合に、圧縮応力の半分がカット され、d.>0.05cm の場合には 圧縮応力の 半分以上がカットされ、最大値が減少する ことがわかる。また, air gap の所では 引張応力の伝達はなされないから, A₃ の部 分には大きな引張応力は生じないことにな る。

いま、B₃の部分を伝播する応力波の変位 速度の時間的変化状態を

$$v(t) = v_P \sin(2\pi f t) \cdots (8.3)$$

とする。ただし、 v_0 : 変位速度の最大値、 f: 周波数 であって、t=0で変位 u=0 という条件を考慮して(8.3)式を 積分すると

$$u(t) = \frac{v_{r}}{2 \pi f} \left\{ -\cos(2 \pi f t) + 1 \right\} \qquad \dots \dots (8.4)$$

を得る。したがって、B3中に生ずる変位の最大値 umは

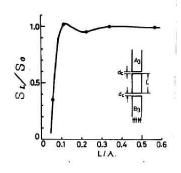
$$u_{\rm m} = \frac{v_{\rm P}}{\pi f} \qquad \cdots \cdots \cdots (8.5)$$

となる。第812図に示した結果を考慮に入れると、A3部分に伝播していく圧縮応力波の応力最高値あるいは変位速度の最高値を減少させるために必要なair gap の幅 Dcは

$$Dc > \frac{v_F}{\pi f} \qquad \cdots \cdots \cdots (8.6)$$

でなければならない。

以上は、air gap が1本の場合であって、切断予定線上にある装薬孔間 を結ぶようにして生成したブリスプリットが理想的に1本のき裂の場合を想 定したものであるが,現実のプリスプリットは多数の細いき裂で形成されて いるものと考えられる。そとでつぎに, air gap が2本の場合について検 討した。すなわち,airgapが平行に2本存在していても,その間隔が大 きく離れていれば、それぞれの air gap が独立して存在していることに なり、上述の理論を2回適用すればよい。しかしながら、2本の air gap の間隔が小さければ、それぞれのair gap は相互に影響し合うことになる。 そこで、dcが 0.025cmのair gap2 本を間隔Lだけあけておいた場合と、dc が 0.05cmの air gap が 1本のみ存在する場合とでは、Asの部分に伝播す る応力波による単位体積当りの力積がどのように異なるかを、間隔の長さL を種々変化させて計算を行なった。その結果を示したのが、第 8.13 図であ って、縦軸には、air gap の間隔がLの場合に A3の部分に生ずる単位 体積当りの力積 Szを air gap が1本の場合に A3の部分に生ずる単位 体積当りの力積 S。で除した値 S \checkmark /S。をとり、横軸には、間隔 L を B の部 分を伝播していく応力波の波長 λ で除した値 エ√λ をとってある。 図より



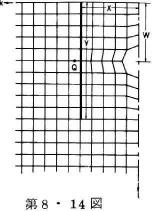
第8·13図

空隙が2本の場合と1本の 場合とについて求めたキ裂 部通過後の波動のもつ力積 以上、ブリスブリットによる波動の軽減効果について述べたが、821項822項で述べた二つのき裂の表現方法と823項で述べた表現方法とは大きな差がある。すなわち、前者の二つでは、周波数の大きい成分は周波数の小さい成分よりも減少しやすいことがわかるが、応力波が完全に伝達されないということはなく、どのような条件であっても応力波のうちの幾分かは伝達されることになる。それはブリスブリットを挾む二つの媒質が連続しているからである。一方後者では、波動の振幅が小さい場合、あるいは周波数が大きい場合にはまったく応力波が伝達されない場合がある。これはブリスブリットを挾む二つの媒質が不連続であるからである。また、Aの部分に伝達される応力波の波形についてみると、821項の方法では、Bの部分の波長に比較して少し波長が長くなる程度で、あまり波形の変化はみられない。822項で述べた方法では、第89図に示したように、波長は821項で述べた方法で得られる応力波に比較してかなり長くなり、823項で述べた方法では、第70回に表していなり長くなり、823項で述べた方法では、波形そのものに大きな変化が現われる。このように媒質に不連続な部分が増加すると、それだけ応力波形に変化が生じてくることがわかる。

83 プリスプリットが本爆破で生ずるき裂を抑制する効果

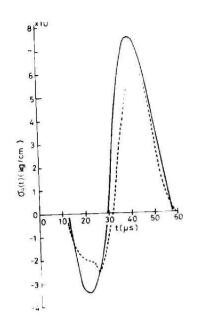
ブリスブリッティングを実施した後本爆破を実施した場合には、スムース・プラスティングを実施した後に生成した壁面と同様に、切断予定線に沿って滑らかな壁面が生成することはよく知られている事実である。ブリスブリッティングを用いた爆破の際に滑らかな壁面を得るためには、まずブリスブリットが切断予定線に沿って良好に生成される必要があるが、ブリスブリットの生成機構は、スムース・ブラスティングの破壊機構とよく似ているためここでは言及しない。つぎにブリスブリッティングを用いた爆破で滑らかな壁面を得るためには、本爆破によって生成するき裂がブリスブリットによって制止され、これより奥にはこれらのき裂が進展しないことが必要である。そのためには、ブリスブリットの幅や長さをどの程度にしなければならないかが問題になるが、今回は主としてブリスブリットの長さと、ブリスブリットの効果について検討した。

第8.14 図に示した模型を用いて ブリスブリットのき裂の抑制効果について検討した。 模型の大きさや採用した弾性定数は、第3章に示した一自由面爆破によって生成したき裂の様相と比較するために、一自由面爆破の際に採用したメタアクリル酸樹脂の弾性定数を用いた。最小抵抗線Wの長さを2cm、最小抵抗線Wの長さを2cm、最小抵抗線からブリスプリットまでの距離 LをL=Wとし、前節の8.2.3 項で示した方法でブリスプリットを表現し、ブリスブリットの幅を



ブリスブリットのき裂 抑制効果の検討に用い た模型の説明図

10 μとし、 プリスプリットの長さをYとし、Yは種々の値をとる。装薬孔に加える圧力は、第3章で述べたように、自由面もプリスプリットも存在しないと仮定した場合に、爆源から4cmの点に接線方向に生ずる応力が、第8 15 図に示すように、メタアクリル酸樹脂板を1号雷管で衝撃した場合の実



第 $8\cdot 15$ 図 爆源から4 cmの点に生ずる主応力 $\sigma_{\!A}$ σ 時間的変化状態

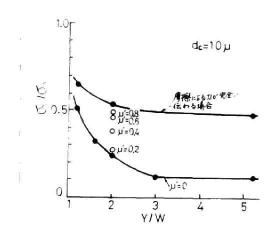


単なる一自由面爆破の 際に生ずるき裂の様相

測結果を(2.1)式に適用して求めた応力と一致するようにした。

さて、プリスプリットが存在しない場合、すなわち単なる一自由面爆破の場合には第816図に示すような様相をしたき裂が生成する。この図より、第814図に示した点 Q 近傍にはき裂が生成する危険性があることがわかる。したがって、プリスプリットが存在する場合に点 Qに生ずる引張応力の最大値が、プリスプリットが存在しない場合に比較してどのように変化するかを調べる必要がある。

さて、自由面からの長さがYのブリスブリットが存在する場合に点Qに生ずる引張応力の最大値 σ_r を、ブリスブリットが存在しない場合に同じ点に生ずる引張応力の最大値 σ_r で除した値 σ_r / σ_o を縦軸にとり、横軸にブリスブリットの自由面からの長さYと最小抵抗線の長さWとの比の値をとって、ブリ



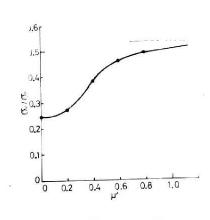
第8・17図

プリスプリットの長さによって点 Q に生ずる引 張応力がどのように変化するかを示した図

スプリットの長さが損傷を与えたくない部分にある点 Qに生ずる引張応力に およぼす影響について示したのが第8.17 図である。

プリスプリットの面が非常に滑らかならば、プリスプリットである air gap が閉じた後もプリスプリットの部分で摩擦は生じないであろう。 また、この面が十分に粗いならば、プリスプリットの部分に生ずるせん断応力は完全に伝達されることになる。そして現実には air gap を挾む媒質間の摩擦係数 μ' は $0.1 \sim 0.3$ 程度と考えられるため、せん断応力の一部分が点 Q 側に伝達されることになる。したがって、第8.17 図には、摩擦係数 μ' が零の場合とせん断応力が完全に伝わる場合とを黒丸で示してあり、Y=2 W の場合のみについて、 μ' が 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 のときの σ_r/σ_o の計算結果を白丸で示してある。図より明らかなように、プリスプリットの長さYが大きく

なるにしたがって、 σ_r/σ_o の値は減少していくが、 $Y \ge 3$ W では、 $\mu=0$ の場合も、せん断応力が完全に伝わる場合も、 σ_r/σ_o の値はそれぞれほぼ一定の値をとるようになり、これ以上ブリスブリットが長くなっても、点Qに生ずる引張応力は減少しないことがわかる。したがって、プリスブリットの長さ Y を 3 W 以上になるように設けても、ブリスブリットの効果には変化がないことになる。なお、この解析では、 α ir α の幅を応力波の波長に比較して非常に小さくして計算を行なったため、 α Q側に伝達される応力波の圧縮応力はほとんど軽減されていないが、引張応力は図に示したように減少する。

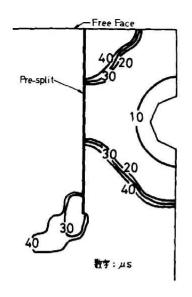


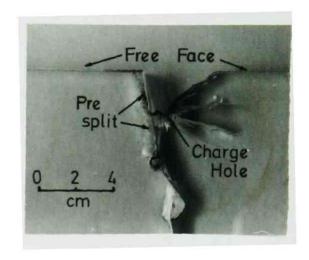
第 8 ・ 18 図 σ_{Y}/σ_{0} とまさつ係数 μ' との関係 (Y=2 Wの場合)

第8 18 図は、プリスプリットの長さ Yが2 Wの場合に、縦軸に σ_{1}/σ_{0} の値をとり横軸にプリスプリットを挟む媒質間の摩擦係数 μ' の値をとって、両者の関係を示した図である。図より明らかなように μ' が大きい場合の σ_{1}/σ_{0} の値が μ' が小さい場合に比較して大きく、プリスプリットが滑らかに生成したが否かもき裂抑制に大きな影響を与えることがわかる。また、摩擦係数 μ' の値を得の値が求められると摩擦係数 μ' の値を得

るととができる。

以上に示したように、プリスプリットによる波動の軽減効果があまりない場合でも、き裂の抑制効果は大きく、引張破壊を考慮に入れた数値計算結果でも、また小規模の爆破実験結果でもき裂の抑制効果を明瞭にみることができる。すなわち、第8.19 図は、引張破壊を考慮に入れた計算結果から、プリスプリッティングの場合のき裂の成長過程を示したものであって、プリス





第8.19図

プリスプリッティングの場 合のき裂の成長過程のシミ ュレーション

第8・20 図 ブリスブリッティングの 小規模爆破試験によって 生成したき裂の様相

ブリットを挾む媒質間の摩擦係数 μが零の場合について示したものである。 図より明らかなように、ブリスブリットと装薬孔間の媒質は t=20 μs でほとんど破壊を終了しており、 第8 14 図に示した点 Qには破壊は生じていず、ブリスブリットのき裂抑制効果が大きいことがわかる。ただし、ブリスブリットの先端から、 t=25 μs 以後にき裂が生成し始めており、ブリスブリット先端に生ずる応力集中の大きさに注意しなければならないことが指摘できる。 また、第8 20 図は、 数値計算を実施した場合とほぼ同一の条件で、メタアクリル酸樹脂板を使用して実施した爆破実験の結果を示した写真である。 爆破後、ブリスブリットの部分の面を観察した結果、面は非常に滑らかであることがわかった。 図より明らかなように、ブリスブリットを横切った大きなき裂は生成しないことがわかり、 第8 16 図に示した ブリスブリットが存在しない場合の実験結果と比較すれば、プリスブリットによるき裂の抑制効

果が大きいことが明らかである。

8.4 結 言

本章においては、ブリスプリッティングにおけるプリスプリットが本爆破によって生ずる波動やき裂をどの程度軽減し、抑制するかについて、主として解析的な研究を行なった。

得られた結果を要約すれば, つぎのとおりである。

- (1) 波動の軽減, き裂抑制効果に関する定量的な数値は, 第8.5 図, 第8.8 図, 第8.12 図, 第8.13 図, 第8.17 図 および(8.6)式に示した。
- (2) き裂を表現する方法として、弾性率を変化させる方法と多孔質媒質とする方法とはよく似た結果を示し、巨視的にみれば両者は等価であるとみなせる。
- (3) 媒質内に不連続部分が多くなれば、それだけ伝播する応力波の波形に大きな変化がみられる。
- (4) 波動軽減の効果が少ないプリスプリットでも、き裂の抑制効果は大きい。

第 9 章

結 論

本研究においては、まず、無限媒質内に存在する装薬孔内で装薬が爆轟し た場合に、媒質内に投射される応力波の伝播にともなって生じる放射状のき 裂の生成機構について明らかにするとともに,一自由面爆破の際に媒質内に 生ずる動的な応力状態を求め、さらにき裂およびクレータの成長過程を数値 計算でシミュレートし,き裂およびクレータの生成機構について検討し,つ ぎに、パルス状の応力波の伝播にともなって円柱状の空孔の周囲に生ずる応 力状態を解明した。さらに、これらの研究の結果を踏まえて、制御爆破工法 の一種であるスムース・ブラスティングの場合の破壊機構を明らかにすると ともに最適爆破条件について検討し、ついで、スムース・ブラスティングに おけるガイドホールの効果について検討し、さらに、特殊形状薬包を用いて 爆破を実施すれば、装薬孔近傍に生ずるき裂を制御できることを明らかにし、 さらにすすんで、破壊機構がスムース・プラスティンクの破壊機構とほぼ同 じであるとみなされるブリスプリッティングの場合に生ずるブリスプリット, すなわち、き裂が、本爆破にともなって生じる波動やき裂を抑制する効果に ついて検討し,合理的な制御爆破工法を実施するための資料を得るとともに, これらの結果を通じて,制御爆破の破壊機構を明らかにするよう努めた。

以下に、本研究で得られた主な成果を結論的に要約して示すことにする。

- (1) 爆源から投射される応力波の伝播にともない、放射状に生成するき裂は 爆源から連続的に生成するのではなく、まず、応力波の伝播にともなって き裂の核が多く生成し、これらの核から同心円状にき裂が成長してゆき、 これらの同心円状のき裂がつながり合って一本の大きなき裂になる。した がって、同心円状に成長するき裂がつながり合った点の軌跡は放物線状の 模様を呈するようになる。
- (2) メタアクリル酸樹脂板を1号電気雷管で衝撃した場合に生ずる破断面上

に生成するき裂の核の分布密度の最大値は、装薬孔壁面から約 $1\,cm$ の点でほぼ 6.6×10^3 個/cmである。爆源の極く近傍では、爆轟にともなり断熱圧縮のために媒質の温度は上昇し、核の分布密度はほぼ 6.6×10^2 個/cm と小さい値を示す。

- (3) 最小抵抗線の長さがWの一自由面爆破の場合に、波長が約75Wの 応力波の伝播にともなって、自由面と最小抵抗線の交点近傍に生ずる引張応力の最大値は、自由面がないと仮定した場合に同じ点に生ずる引張応力の最大値の約2倍となる。さらに、一自由面爆破の場合に波長の長い応力波によって生ずる応力状態の特徴として、自由面上で、最小抵抗線からの距離をXとすると、X<Wの範囲内に生ずる引張応力の値は、自由面がないと仮定した場合に比べて小さくなるが、引張りとして作用する時間は長くなり、さらにX>Wの範囲では引張応力の値な小さくなるとともに引張りとして作用する時間も短くなり振動性を帯びてくる、などのことがあげられる。
- (4) 一自由面爆破に関して、引張破壊を考慮に入れた応力解析を行なってき 裂の成長過程をシミュレートした結果と実験によって得られたき裂の様相 およびクレータの形と比較検討した結果、両者はかなりよく一致することがわかった。シミュレーションの結果は、爆源から放射状に生成するき裂は、まず、最小抵抗線近傍に生じ、すべての方向に て (Wの範囲内で引張 応力によるき裂が生成するとろには、自由面近傍の X (Wの範囲での破壊 はすでに終了しており、それ以後は、爆源から自由面に平行な方向および 最小抵抗線と逆の方向にき裂は大きく成長し、ガス圧の作用の仕方、ある いはどのき裂にガスが進入するかによって、自由面に平行な方向に進展したき裂は自由面に達して大きなクレータを形成する場合も考えられることが明らかとなった。
- (5) 破断面上に生ずるリップルマークの生成機構についてシミュレーション

- の結果から検討し、リップルマークは、き裂の成長する速度が停止しているかまたはある速度で成長している状態からさらに大きな速度で成長する 状態に移行する点に生成することを示した。
- (6) 無限媒質内に円柱状または断面が正方形の角柱状の空孔が存在し、ベルス状の応力波がその媒質を伝播する場合について、空孔の周囲に生ずる応力状態を求めた。その結果、応力波の波長 λ と円柱状の空孔の直径 α との比 λ / α の値が $2\sim3$ の近傍で応力波の挙動は大きく異なり、この値より λ / α が小さいときは、波動は円柱状空孔壁面で壁面があたかも平面であるかのように反射し、 λ / α が $2\sim3$ より大きいときは、波動による動的な応力状態でも静的な応力状態に近似するようになることを示した。
- (7) 国鉄湖西線長等山トンネル掘進爆破が疎水トンネルにおよぼす影響を調べた振動測定結果と数値解析結果とが比較的よく一致することを示し、その結果、爆破振動によって疎水トンネルの周囲に生ずる応力状態は数値解析で得られた応力状態とほぼ同一であろうと推定した。
- (8) スムース・プラスティングにおける破壊機構は、使用する雷管の点爆時間のばらつきによって、2,3の機構が考えられる。まず、隣り合った装薬孔に装薬された雷管の点爆時間のばらつきが大きい場合は、ある装薬が爆轟しても、隣接した装薬はまだ爆轟していない。したがって、隣接した装薬孔は空孔として作用する。この場合には、当然爆轟した装薬孔周辺には放射状のき裂が生成し、またこの放射状のき裂とは別個に空孔として作用していた隣接の装薬孔壁面から切断予定線に沿ってき裂が生成し、その後空孔として作用していたこの装薬孔内の装薬が爆轟することにより、別個に生成していたき裂が切断予定線に沿って助長されて滑らかな壁面を生成する。

切断予定線に沿って設けられた装薬孔の数が多ければ多い程, 隣接した 装薬が同時に爆轟する割合は大きくなる。したがって, この場合には, 隣 接した装薬孔から投射された応力波の干渉が生じ, 応力波の干渉によって 切断予定線に沿ってき裂が生成し滑らかな壁面が形成される。

点爆時間のばらつきがあまり大きくはないが、同時に点爆はしないという場合には、上記の二つの破壊機構が共存するような破壊機構を示すようになる。

- (9) 良好なスムース・ブラスティングを実施するためには、装薬孔間隔が小さい方が望ましく、装薬孔間隔が最小抵抗線の長さの1.6 倍より大きい場合には、空孔として作用する隣接した装薬孔壁面と切断予定線との交点に最大の引張応力が生ずるのではなく、装薬孔壁面と切断予定線と直交する最小抵抗線との交点に最大の引張応力が生ずる。したがって、空孔として作用する装薬孔内壁から切断予定線に沿ってき裂が生成しない場合でも、切断予定線と直交する方向にき裂が生成する場合が生じ、スムース・プラスティングにとっては好ましくないことになる。
- (10) 良好なスムース・プラスティングを実施するためには応力波の干渉による効果を利用するのが望ましい。そのためには、点火方法は斉発がよく、 点爆時間のばらつきの少ない精度のよい電気雷管の使用が望まれる。
- (1) 爆薬を軽装塡すると、装薬孔近傍の破砕圏を小さくすることができるために、より滑らかな壁面を得ることができるが、その結果生ずる破砕片が 大きくなる可能性があることを、シミュレーションの結果から示した。
- (2) 良好なスムース・プラスティングにより新しく生成するであろう壁面の 形の一般的な特徴は、装薬孔間にある岩盤が切断予定面よりも少しふくれ ているような形を示すことである。
- (13) ガイドホールを有するスムース・プラスティンクにおいては、まず、接線方向に生ずる引張応力 σ_{θ} にりガイドホールの方向にき裂が生成し始め、このき裂面から応力解放波が投射され、ガイドホールの方向以外の方向にある点に生ずる σ_{θ} が岩盤の引張強度に達するまでに応力解放波が到達すると、それ以上引張応力は大きくなり得ず、き裂の生成が抑制されることを理論的、実験的に示した。

- (14) 応力解放波の伝播速度は縦波の伝播速度に等しい。
- (15) 最小抵抗線の長さが57cm,装薬孔間隔が約75cm,ガイドホールと装薬 孔間隔が10cm,装薬孔の長さ3.5 m 装薬孔の数は4本,デカップリング 係数は2.0 という条件で、スムース・プラスティングに関する現場実験 を行なった結果,生成した壁面の切断予定面からの凹凸の最大値は±7cm 程度であり、良好な壁面が得られた。
- (6) 主として爆発生成ガスの圧力によって材料を破壊する火薬類を用いて内部装薬爆破を行なり場合に、装薬孔内壁から生成するき裂に方向性を持たせうるかどうかについて検討し、薬包の断面形状が、長軸と短軸との比が2対1程度の楕円形であるならば、長軸方向のみき裂を生成させることができ、有効なスムース・プラスティングを実施しうることを示した。
- (f) 装薬孔内壁に作用する圧力の時間的変化が非常にゆるやかであり、かつ、 生成するき裂の先端の進行速度が縦波の伝播速度に比較して遅い場合には、 き裂の生成を考慮に入れた応力解析は、いくつかの静的な問題として取り 扱うことができる。
- (18) プリスプリットやき裂が存在する岩盤を弾性定数が異なった弾性体とみなした場合に、プリスプリットやき裂の存在によって爆破による波動がどの程度減少するかを定量的に求め、その結果を第8.5 図に示した。
- (19) ブリスプリットやき裂が存在する岩盤を断面が正方形の空孔列が存在するものとみなした場合に、プリスプリットやき裂の存在によって爆破による波動がどの程度減少するかを定量的に求め、その結果を第8.8 図に示した。

この場合には、ブリスブリットやき裂を通過した後の応力波の波長は長くなり、かつ波長が長くなる程度は応力波のもとの波長によっても異なってくる。その結果を第89図に示した。

(20) プリスプリットやき裂が存在する部分を air gap が存在するとみな した場合、すなわち、応力波がこの air gap を伝播していくときに、 条件によっては生ずる弾性体の衝突を考慮に入れた場合にプリスプリットやき裂、すなわち air gap の存在によって爆破による波動がどの程度に減少するかを検討した結果、伝播する波動を正弦波と仮定し、これによって生ずる変位速度のピーク値を ∇ r、周波数をfで表わした場合に、変位速度のピーク値が減少するために必要な air gap の幅 Dc は

$$D_c > \frac{\nabla_F}{\pi f}$$

で表わされることを示した。

- 知 幅の大きい air gap が1本存在するよりも、幅の小さい air gap が数多く存在する方が、gap を通って伝達されていく応力波による力積 は減少する。
- (2) (18)で示した方法によってき裂を含む岩盤を表現した場合と、(19)で示した方法によってき裂を含む岩盤を表現した場合は、プリスプリットによる波動の軽減効果に関して得られる解析結果は、巨視的にみてほぼ同じとみなしうる。
- (2) 爆破による波動が軽減されないような小さなブリスプリットが存在する場合でも、本爆破にともなうき裂の抑制効果は大きい。この結果を第8.17 図に示した。
- (24) プリスプリットによるき裂の抑制効果は、プリスプリットの部分の岩盤 の摩擦係数によっても大きな変化を示す。この結果を第8.18図に示した。

謝辞

本研究に行なりに当り、終始温情ある御指導と御鞭撻を賜わった恩師、京 都大学教授伊藤一郎博士に心からの感謝をささげ、深く御礼申し上げます。

また、本研究に関連した多くの基礎的な事柄の御教示を賜わりました資源 工学教室の諸先生方に厚く御礼申し上げるとともに、直接実験など援助して いただいた開発工学研究室の諸先生方および学生諸氏に深く感謝する次第で ある。

また、本研究のための実験場所を提供していただいた三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所および旭化成工業株式会社管管工場に対し、また実験に使用した電気雷管を提供していただいた日本化薬株式会社姫路工場に対し、さらにまた電子顕微鏡による破断面の撮影をしていただいた日本電子株式会社に対し深く感謝する次第である。

.

9

(862)

